





دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشکده فیزیک

پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک

گرایش حالت جامد

بررسی خواص تراابری الکترونها در ساختار نیمرسانای $InGaN$ در حد میدان های الکتریکی ضعیف

اساتید راهنما :

۱-جناب آقای دکتر هادی عربشاهی

۲-جناب آقای دکتر محمد ابراهیم قاضی

دانشجو :

علی سمامی

شهریور ۸۳

دانشکده فیزیک
دانشگاه صنعتی شاهرود

تقدیم به :

فرزنده محمد مهدی

۹

خوشید زندگیم همسرخ که صبر از او صبوری آموخت

به نام یک‌انه معبد حیتی

سپاس و ستایش فدای را که توفیق تمثیل بعد از چندین سال که وقفه در تمثیلاتم ایجاد شده بود دوباره به من عطا فرمود. برخود لازه می‌دانم از زممات کلیه اساتید محترم گروه فیزیک که در مراحل مختلف تمثیل افتخار شاگردی ایشان را داشته‌ام تشکر و قدردانی کنم. به‌خصوص از زممات و راهنمایی‌های بی‌دریغ استاد ارجمند جناب آقای دکتر هادی عربشاهی که در انجام مراحل مختلف این طرح مرا یاری نمودند سپاس‌گزارم.

همچنین مراتب سپاس و تشکر خود را از جناب آقای دکتر محمد ابراهیم قاضی به خاطر راهنمایی‌های ایشان به عنوان استاد راهنمای دوه طرح ابراز می‌دارم. از جناب آقای دکتر قربانی و جناب آقای دکتر عشقی که زحمت مطالعه پایان‌نامه و حضور در جلسه دفاع را متحمل شدند تشکر و سپاس‌گزاری می‌کنم. همچنین از پدر و مادر بزرگوارم که در طول تمثیلات دعاها ایشان همواره برقه راهم بوده قلب اقدارانی می‌کنم، و از جناب آقای نادر سماعی برادر گرامیم که در امر آموزش قسمت‌های مختلف کامپیوتر مرا یاری نمودند صمیمانه تشکر می‌کنم.

علی سماعی

چکیده

خواص تراپری الکترون ها در ترکیبات دو و سه تایی مواد نیمرساناً در حد میدان های الکتریکی پایین اولین بار توسط رود (Rode) با حل معادله بولتزمن به روش برگشت پذیری انجام پذیرفت . هر چند بعدها روش های دیگری نظیر روش مونتکارلو (Monte Carlo) نیز مطرح گردید . در مطالعه خواص تراپری الکترون در حد میدان های الکتریکی پایین عموماً حرکت پذیری الکترون بر حسب تابعی از دما و چگالی اتم های ناخالصی تعیین می شود . چنانچه می دانیم حرکت پذیری مهمترین عامل الکتریکی یک ماده نیمرسانا است و با تعیین آن می توان به خواص الکتریکی ماده و کاربردهای آن در طراحی و ساخت قطعات نیمرسانا پی برد . موضوع این پژوهه نیز تعیین پارامتر الکتریکی حرکت پذیری (Γ) الکترون ها در ماده نیمرسانای $In_{1/2}Ga_{1/2}$ بر حسب تابعی از دما و چگالی اتم های ناخالصی است . این اندازه گیری به روش حل معادله بولتزمن از طریق برگشت پذیری با طراحی یک کد کامپیوترا انجام گرفته است . به منظور مقایسه خواص تراپری این ماده ها جا لازم باشد ، خصوصیات تراپری محاسبه شده این ماده با دیگر مواد نیمرسانای مشابه اش نظیر InN و GaN مقایسه شده است . از آنجا که در تعیین پارامترهای الکتریکی هر ماده بلورین ، ساختار بلوری ، ساختار نواری و عوامل پراکنده ای الکترونها مهمترین نقش را دارند ، لذا در این پژوهه نیز مطالعه ای مروری بر خواص ساختار بلوری ، نواری و عوامل پراکنده ای موثر در این ماده انجام شده است .

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	مقدمه
فصل اول - خواص عمومی جامدات	
۱۰	۱-۱- ساختار بلوری
۱۵	۱-۲- مدل الکترون آزاد
۱۸	۱-۳- شکست مدل الکترون آزاد
۱۹	۱-۴- ساختار نواری در جامدات
۲۰	۱-۵- طیف انرژی در اتمها و مولکولها
۲۳	۱-۶- تابع بلوخ
۲۵	۱-۷- نوارهای انرژی
۲۹	۱-۸- رابطه میان انرژی و بردار موج
۳۰	۱-۹- نظریه نواری در سه بعد ، مناطق بربلوبن
۳۱	۱-۱۰- مشاهده تجربی نوارهای انرژی
۳۲	۱-۱۱- روش های محاسبه نوارهای انرژی

فصل ۲ - حرکت الکترون درون نیمرسانا و مکانیسم های پراکندگی

۴۰ ۲-۱- نظریه مقدماتی رسانندگی
۴۸ ۲-۲- مکانیسم های پراکندگی
۵۰ ۲-۳- پراکندگی الکترونی ناشی از ارتعاشات شبکه
۵۲ ۲-۳-۱- پراکندگی الکترونی در اثر فونون های آکوستیکی
۵۷ ۲-۳-۲- پراکندگی الکترونی در اثر فونون های اپتیکی
۶۰ ۲-۳-۳- پراکندگی الکترونی از حضور اتم های ناخالصی

فصل ۳ - معادله تراابری بولتزمن

۶۴	معادله تراابری بولتزمن
----	------------------------

فصل ۴ - بررسی ساختار بلوری و نواری InGaN و نتایج و کارهای انجام شده

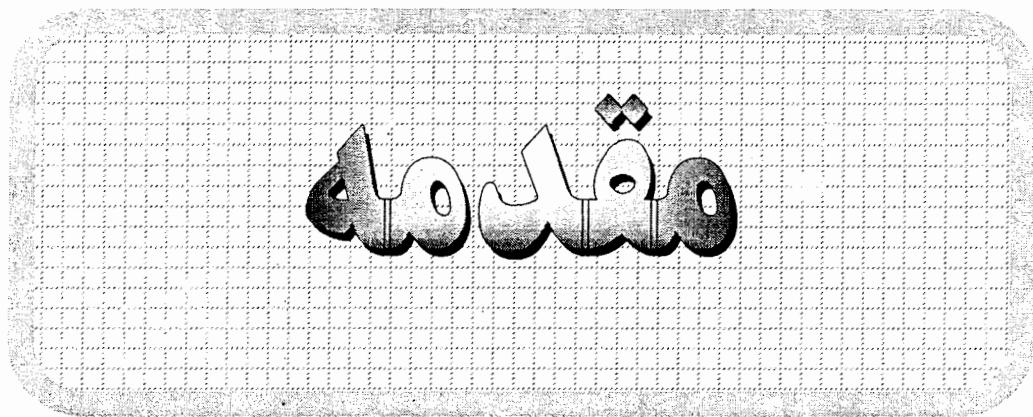
۷۲ ۴-۱- مقدمه
۷۴ ۴-۲- ساختار بلوری ترکیبات نیمرسانای $In_{x/2}Ga_{1-x/2}N$ و GaN
۷۹ ۴-۳- ساختار نواری ترکیبات نیمرسانای $In_{x/2}Ga_{1-x/2}N$ و InN
۸۳ ۴-۴- محاسبه آهنگ پراکندگی در ترکیب نیمرسانای $In_{x/2}Ga_{1-x/2}N$
۹۰ ۴-۵- محاسبه تحرک پذیری در حد میدان الکتریکی ضعیف
۱۰۰ ۴-۶- کارهای آیند

منابع

ضمائمه

صفحة ١

مقدمة



مقدمه

منشأ نیمرساناها به زمان فارادی^(۱) و بکرل^(۲) بر می گردد . در سال ۱۸۳۳ ، فارادی کشف کرد که سولفیت نقره دارای یک ضریب گرمایی منفی است و در سال ۱۸۳۹ بکرل روی خواص الکتروولیتهای مختلف مطالعه کرد . در ۱۹۴۸ بارتین^(۳) و باردین^(۴) در آزمایشگاه « بل » ایالات متحده ، اولین ترانزیستور تماسی را که از ژرمانیوم ساخته شده بود ، ساختند و فقط چند ماه بعد شوکلی^(۵) ترانزیستور اتصالی را ساخت که خیلی زود جای ترانزیستورهای « نقطه تماس » را گرفت و بعد از پیشرفت‌های وسیع ، از آن قطعه‌ای ساخته شد که امروزه آن را به عنوان ترانزیستورهای دو قطبی می‌شناسیم .

به دنبال پیشرفت‌هایی که در سال ۱۹۴۰ حاصل آمد ، بر اهمیت نیمرساناها افزوده شد و اکنون به عنوان پایه الکترونیک جدید ، حوزه استفاده وسیعی دارند . بیشتر نیمرساناهای که در دسترس ما هستند ، از ترکیبات مواد نیمرسانا ساخته شده اند . اغلب قطعات نیمرسانا که در مدارهای الکترونیکی وجود دارند عبارتند از : دیود ، ترانزیستورهای اثر میدان ، ترانزیستورهای دوقطبی ، ریزموجهای نوری . سیلیکون Si معروف‌ترین ماده نیمرسانایی است که در ساخت هر نوع قطعه نیمرسانایی در مدارهای الکترونیکی استفاده می‌شود . اگر چه دیگر آلیاژهای دو عنصری ، مخصوصاً آنهایی که از عناصر گروه III و V جدول تناوبی تشکیل شده اند ، برای موارد بسیار ویژه استفاده می‌شوند . همچنین علاوه بر ترکیبات دوتایی ، ترکیبات سه‌تایی و چهارتایی از مواد نیمرسانا نیز وجود دارند و می‌توان آنها را برای بازده بهتر در بعضی از موارد

1-Faraday

2-Becquerel

3-Brattain

4-Bardeen

5-Schooley

خاص استفاده کرد . اخیراً از آلیاژ ژرمانیوم SiGe برای ساخت قطعات نیمرسانایی همانند انواع ترانزیستورهای اثر میدان که در آنها تولید الکترونهای با سرعت بالا اهمیت دارد ، استفاده می شود . امروزه بجای SiGe از ترکیبات جدید نیترات دار AlN ، GaN و InN نیز برای ساخت قطعات نیمرسانایی که در آنها سرعت تراابری الکترون در حد میدان های الکتریکی شدید بسیار بالاست ، استفاده می شود . گروه مواد نیترات دار مجموعه ترکیبات نیمرسانایی موثر و سودمندی را تشکیل می دهند . زیرا آنها با آلیاژهای AlGaN ، InGaN و AlInN نیمرساناهای را با گاف انرژی مستقیم از 1.9eV (InN) تا 6.2eV (AlN) ، پدید می آورند . پتانسیل بالای این مجموعه عناصر در توان بالا ، درجه حرارت بالا ، فرکانس بالا و گسیل زیاد (نور - انرژی) اکنون به عنوان پیشرفته عظیم در زمینه تکنولوژی مواد محسوب می شود . دیودهای نوری (LED)^(۱) که بر پایه مواد نیمرسانای نیترات دار ساخته شده اند توانایی تشعشع همه رنگها را دارند ، زیرا تشعشع سه رنگ اصلی قرمز ، سبز و آبی ، توسط آنها امکان پذیر است . علاوه بر آن گسیل امواج نوری ، با طول موجهای کوتاه ، نشان می دهد که دیودهای لیزری ساخته شده از این مواد ، تمرکز رنگی بیشتری دارند و در نتیجه می توانند توانایی ذخیره سازی را افزایش دهند . بطور مثال در دیسکهای مختلط دیجیتالی (DVD) زمانی که لیزرهای آبی GaN مورد استفاده قرار می گیرند در هر دیسک چگالی ذخیره سازی از یک گیگا بايت به 40 گیگا بايت افزایش پیدا می کند . این ترکیبات نیمرسانا همچنین کاندیداهای خوبی برای استفاده در گیرنده های ماوراء بنفس هستند و موارد استفاده فراوانی ۰ تحقیقات خورشیدی و نظارت بر فرآیند احتراق دارند .

سرعت سوق بالای ترکیبات نیترات دار نظیر AlN ، GaN و InN و دیگر ترکیبات ساخته شده از آنها نظیر AlGaN و همچنین حساس نبودن پارامترهای الکتریکی این

ترکیبات به دما ، باعث شده است که امروزه از این مواد در ساخت قطعات الکترونیکی توان بالا و جریان های زیاد استفاده شود .

با این حال مشکلات پیچیده متعددی در رشد بلور این مواد وجود دارند که مهمترین آنها فقدان مواد مناسب برای ساختار زیر لایه هاست . مشکلات دیگری نیز در زمینه ترکیب این مواد وجود دارد . سختی ترکیب کردن GaN و نمونه های پتاسیم و کمبود اسید مناسب برای این مواد از این جمله اند . با این حال پیشرفت های چشمگیری در چند سال اخیر در کیفیت مواد حاصل شده است . بهینه سازی لایه های مقاوم در صفحات یاقوتی و اخیراً در دسترس قرار گرفتن لایه های سیلیکون و یا کربن به مواد تشکیل دهنده اجراه می دهد که بوسیله روش های مختلف رشد بلور از حالت مذاب و یا حالت تبخیر بتوان این مواد را تشکیل داد . همچنین با ترکیب ناخالصی های گیرنده و یا دهنده می توان GaN را به عنوان معرف همه ترکیبات غنی شده با چگالی ناخالصی در حد $3 \times 10^{-24} m^3$ قرار داد . بهبود در کیفیت رشد و مراحل ساخت مواد ، محققان را بر آن داشت تا به خاطر تجاری کردن و استفاده بهینه از GaN تحقیقات را توسعه منابع انرژی نوری انجام دهند . اولین دیود نوری ساخته شده از GaN در اوایل سال ۱۹۷۰ توسط پانکوف^(۱) ساخته شد . به علت وجود ناخالصی فسفر در ترکیبات رشد داده شده عموماً دیود های نوری ساخته شده از نوع $n-p$ بودند که حتی نسبت به قطعات فلز - نیمرساناً غیر متعارف تر بودند . پیشرفت هایی که در همه جهات در تکنولوژی GaN بدست آمد ، سرانجام امکان ساخت انواع قطعات ساخته شده از این مواد را در ترانزیستور های اثر میدان بوجود آورد .

توسعه و پیشرفت GaN بر پایه عملکرد قطعات انتقال دهنده بنا شده است که در همان ابتدای راه به خاطر کیفیت پایین رشد بلور این مواد دچار محدودیت بشد .

در تعیین خواص الکتریکی ترکیبات دوتایی و سه تایی نیترات دار عموماً از روش های تئوری و شبیه سازی استفاده می شود و این بدان جهت است که عموماً این ترکیبات دارای گاف انرژی بالایی بوده و تراپری الکترون در آنها به میدان های الکتریکی بسیار شدید نیاز دارد . امکان بررسی رفتار تراپری الکترونها در این مواد از طریق نظری باعث پیشرفت مطالعه خواص این مواد شده است ، بخصوص اینکه اینگونه مطالعات در زمان کمتر و با امکانات وسیعتری قابل بررسی است .

اندازه سرعت سوق الکترون در حد میدان های الکتریکی پایین و بالا در انتخاب یک ماده نیمرسانا در ساخت قطعات الکترونیکی بسیار مهم است . در مورد ترکیبات نیترات دار اولین بار لیتل جان^(۱) در سال ۱۹۷۶ با مطالعات نظری خود اندازه سرعت سوق الکترون را در ترکیب نیمرسانای GaN محاسبه نمود . محاسبات وی نشان داد که در ماده نیمرسانای GaN با چگالی ناخالصی $10^{22} m^{-3}$ و در حد میدان الکتریکی $2 \times 10^7 V/m$ ، سرعت سوق الکترونها به بزرگی $2 \times 10^5 m/s$ است ، که بطور قابل ملاحظه ای از سرعت سوق الکترونها در نیمرسانای Si یا GaAs بیشتر است . همچنین مطالعات وی نشان داد که سرعت سوق در GaN بر خلاف دیگر ترکیبات نیمرسانا نظیر Si یا GaAs به دما وابسته نبوده ، و در نتیجه این مواد در ساخت قطعات نیمرسانا دارای مزیت فراوانی می باشند .

خواص تراپری الکترون ها در ترکیبات دو و سه تایی نیمرساناهای نیترات دار در حد میدان های الکتریکی پایین اولین بار توسط رود^(۲) با حل معادله بولتزمن^(۳) به روش برگشت

1-Littlejohn

2-Rode

3-Boltzmann

پذیری انجام پذیرفت . هر چند که بعدها گاسیکل^(۱) با روش مونتوکارلو^(۲) خواص ترابری حامل ها را در این ترکیبات در حد میدان های الکتریکی پایین محاسبه نمود . در مطالعه خواص ترابری الکترون در حد میدان های الکتریکی پایین عموماً تحرک پذیری الکترون بر حسب تابعی از دما و چگالی الکترونها تعیین می شود . چنانکه می دانیم تحرک پذیری مهمترین عامل الکتریکی یک ماده نیمرساناست و با تعیین آن می توان به خواص الکتریکی ماده و کاربردهای آن در طراحی و ساخت قطعات نیمرسا پی برد . موضوع این تحقیق نیز تعیین پارامترهای الکتریکی نظیر تحرک پذیری μ الکترونها در ماده نیمرسانای $In_{0.8}Ga_{0.2}$ بر حسب تابعی از دما و چگالی الکترونها است . این اندازه گیری به روش حل معادله ترابری بولتزمن از طریق برگشت پذیر بوسیله یک برنامه کامپیوتری است . به منظور مقایسه خواص ترابری این ماده هر جا لازم باشد ، خصوصیات ترابری محاسبه شده این ماده با دیگر مواد نیمرسانای سازنده اش نظیر GaN و InN مقایسه شده است . از آنجا که در تعیین پارامترهای الکتریکی هر ماده بلورین ساختار بلوری ، ساختار نواری و عوامل پراکندگی الکترونها مهمترین نقش را دارند ، لذا در این پژوهه نیز ابتدا مطالعه ای مروری بر خواص ساختار بلوری ، نواری و عوامل پراکندگی موثر در این ماده شده است . بنابراین ادامه این پژوهه به روش زیر تقسیم بندی شده است .

در فصل اول بررسی اجمالی به خواص عمومی ترکیبات نیمرسانا ، از دیدگاه ساختار بلوری و ساختار نواری می پردازیم . با توجه به آنکه عموماً ترکیبات نیمرسانای دوتایی و سه تایی نیترات دار در ساختار وورتسایت^(۳) و یا زینک بلند^(۴) متبلور می شوند ، شناسایی و خواص بلوری این

1- Gaskill
2-Monte Carlo
3- Wurtzite
4- Zincblende

ساختار برای بررسی های آینده اهمیت فراوانی دارد. همچنین در این فصل اشاره ای به روش های مختلف تعیین ساختار نواری این ترکیبات می شود. نوع ساختار نواری این ترکیبات (مستقیم یا غیرمستقیم) و پارامترهای ساختار نواری این مواد از قبیل انحنای نوارهای رسانش و جرم موثر الکترون در دره های مختلف تأثیر بسیار فراوانی در تحرک پذیری الکترونها دارد.

همچنین چون مطالعه اصلی این تحقیق در حد میدان های الکتریکی پایین است، شکل پایین ترین نوار رسانش و بد موص دره مرکزی آن (دره Γ) و جرم موثر الکترون در آن تعیین کننده اصلی در سرعت سوق و تحرک پذیری الکترونها است، زیرا چنانکه می دانیم در حد میدان های الکتریکی پایین (10^5 V/m) تمامی الکترونها در دره مرکزی Γ بوده و لذا محاسبات انجام شده بر روی تعیین سرعت سوق و تحرک پذیری در همین دره است.

در فصل دوم، به مطالعات عوامل مختلف پراکندگی الکترونها تحت تأثیر میدان الکتریکی اعمالی می پردازیم. چنانکه می دانیم تحت تأثیر میدان الکتریکی اعمالی الکترونها با شتاب

$$a = \frac{eE}{m^*}$$

پراکندگی است. در این فصل آهنگ پراکندگی الکترونها را در حضور پراکندگی از عوامل مختلفی چون، فونون های آکوستیکی^(۱) و اپتیکی^(۲)، پیزوالکتریسیته^(۳) و اتم های ناخالصی بررسی می کنیم. عامل پراکندگی پیزوالکتریسیته بدین دلیل در محاسبات منظور می شود که چون عموماً ترکیبات نیمرسانای نیترات دار نظیر $\text{In}_{1/2}\text{Ga}_{1/8}$ در ساختار وورتسایت متبلور شده و این ساختار به دلیل عدم تقارن دارای خاصیت پیزوالکتریسیته است. در این فصل روابط مربوط به هر

1-Acoustic Phonons

2-Optical Phonons

3-Piezoelectric

به هر آهنگ پراکندگی محاسبه شده و به منظور بررسی بیشتر در مورد ماده GaN تغییرات این آهنگ های پراکندگی بر حسب انرژی ترسیم شده است . در فصل نتایج نمودارهای مشابهی برای

ترکیب نیمرسانی سه تایی $In_{x/2} Ga_{y/8} N_{z/8}$ بررسی خواهد شد .

در فصل سوم به توضیح و تبیین معادله بولتزمن می پردازیم . حل و بحث این معادله در حد میدان های الکتریکی پایین و شرایط ایستا به روش عددی برگشت پذیر مورد بررسی قرار گرفته و نشان خواهیم داد که چگونه می توان از حل این معادله نهایتاً پارامتر الکتریکی تحرک پذیری را محاسبه کرد .

نهایتاً در فصل چهارم به نتایج به دست آمده از حل و بحث معادله بولتزمن برای تعیین

خواص الکتریکی ترکیب سه تایی $In_{x/2} Ga_{y/8} N_{z/8}$ می پردازیم .

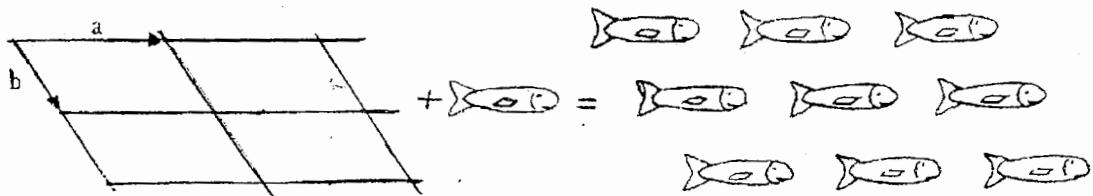
فصل اول

خواص عمومی جامدات

۱-۱- ساختار بلوری

با دیدن شکل خارجی جامدات و نظم موجود می توان به این نتیجه رسید که این نظم خارجی ناشی از نظم در آرایش اتم های تشکیل دهنده آنها است. بعبارت دیگر اجسام بلوری باید یک آرایه سه بعدی از اتمها باشند. با کشف پرتو X^(۱) و بررسی آثار تداخلی پرتوهای رونتگنی^(۲)، نخستین مشاهدات تجربی پراش پرتو X توسط بلورها انجام پذیرفت. آزمایشات پراش پرتو X از بلورهای مختلف بطور قطعی ثابت کرد که بلورها آرایه ای سه بعدی از اتمها هستند.

بلور ایده آل از تکرار بی پایان واحدهای ساختاری همانند در فضا بوجود می آید. این واحد ساختاری در بلورهای ساده یک اتم است و در بلورهای پیچیده تر شامل چندین اتم و مولکول می باشد. ساختار بلوری بر حسب شبکه ای از نقاط که در هر نقطه آن گروهی از اتمها نشسته اند توصیف می شود. بطوریکه ساختار بلورین را می توان متشکل از مجموع شبکه بعلاوه پایه در نظر گرفت (شکل ۱-۱) که در آن شبکه یک آرایش منظم و دوره ای از نقاط در فضاست و پایه یک اتم یا مجموعه ای اتمها است که با قرار گرفتن آن در هر نقطه ای از شبکه ساختار بلور را تشکیل می دهد. پایه ها در ترکیب آرایش و سمتگیری اتمها کاملاً یکسانند.

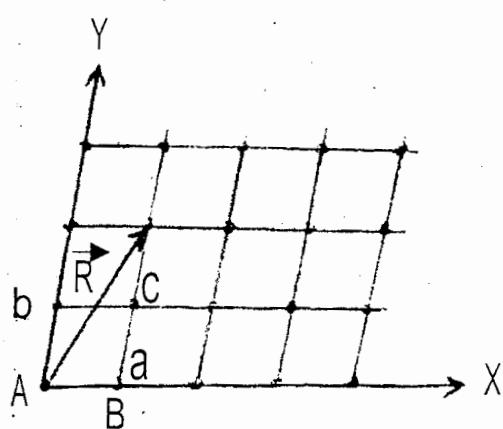


پایه + شبکه = ساختار بلور

شکل ۱-۱ - ساختار بلور از نظر قرار گرفتن پایه ای از اتم های مشابه در محل نقاط شبکه تشکیل می شود [۱].

آرایش منظم اتمنها در ماده وجه تمایز بلور با ماده آمورف است. اما بسیاری از دانشمندان بویژه فیزیکدانها مایلند جزئیات آرایش اتمی را نادیده بگیرند و حجم کوچکی از بلور را به صورت آرایه ساده مکعبی نمایش می دهند.

در یک بلور، اتمها به صورت منظم و تناوبی قرار می گیرند شکل (۱-۲) بطوریکه در یک بلور کامل این خاصیت تناوبی بودن در سه امتداد محورهای x ، y و z از $-\infty$ تا $+\infty$ حفظ می شود.



شکل ۱-۲ - یک شبکه جامد دو بعدی در یک بلور دو بعدی، فاصله بین هر دو اتم مجاور در امتداد محور X ها برابر a و در امتداد محور Y ها برابر b است.

از تناوبی بودن شبکه بلوری می‌توان نتیجه گرفت که اتمهای A , B , C معادل هم هستند. در نتیجه می‌توان گفت بلور تقارن انتقالی دارد، یعنی بلور تحت هر برداری مانند R قبل و بعد از انتقال دقیقاً یکسان است.

برای بلورهای سه بعدی، بردار انتقال شبکه سه بعدی با رابطه $\vec{R} = n_1 \vec{a} + n_2 \vec{b} + n_3 \vec{c}$ بیان می‌شود که در آن سه بردار $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ در یک صفحه نیستند و نقطه‌ای از شبکه را به نقاط همسایه اولش وصل می‌کنند.

سطح متوازی السطوحی که اضلاعش بردارهای $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ (که در یک جهت نبوده) و بردارهای پایه نامیده می‌شوند) باشد، سلول واحد^(۱) نامیده می‌شود. بنا بر این یک شبکه را می‌توان به عنوان ترکیبی از تعداد بسیاری از سلولهای واحد در نظر گرفت که پہلو به پہلو کنار هم چیده شده‌اند. در بلور شناسی خواص هندسی بلور بیش از خواص یک بلور اهمیت دارد.

بنابراین می‌توان اتم‌ها را با نقاط هندسی معادل جایگزین کرد. بدین ترتیب نقشی بدست می‌آید که دارای خواص هندسی بلور است ولی محتوای فیزیکی ندارد. این نقش هندسی را شبکه بلوری می‌نامند. شبکه‌های بلوری را می‌توان در حالت کلی به دو گونه شبکه براوه و شبکه غیربراوه تقسیم بندی نمود، بطوريکه در یک شبکه براوه^(۲) تمام نقاط شبکه معادل یکدیگرند و چنین شبکه‌ای است که می‌تواند خواص جامدات بلورین را توصیف کند.

این شبکه در سال ۱۸۴۸ میلادی توسط شخصی بنام براوه (A-Bravais) پیشنهاد شده است که اختلاف آنها در زاویه بین سه امتداد حرکت بردارهای $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ و اندازه این بردارهاست. شبکه غیربراوه را می‌توان ترکیبی از دو یا چند شبکه براوه دانست که در هم فرو رفته‌اند و جهتشان

نسبت به یکدیگر ثابت است. چهارده شبکه براوه به هفت سیستم بلوری گروه بنده می شوند.

این سیستم ها عبارتند از :

سه میلی (Cubic) ، شش گوشه (Hexagonal) ، مکعبی (Triclinic) ،
چهار گوشه (Monoclinic) ، راست گوشه (Ortorombic) ، تک میلی (Tetragonal)
و سه گوشی (Trigonal) . مشخصات ساختاری و هندسی این سیستم های بلوری در هر کتاب
بلورشناسی و یا حالت جامد پایه ذکر شده است.

چنانکه می دانیم جامدات ساختار پایداری دارند ، مثلاً یک بلور Ge از مجموعه ای از
اتم های Ge پایدارتر است. این موضوع بیانگر این مطلب است که وقتی اتمهای Ge به هم
نزدیک شوند ، یکدیگر را جذب می کنند. یعنی یک نیروی جاذبه بین اتمی وجود دارد که اتمها را
کنار هم نگه می دارد.

نیروی بین اتمی ترکیبی از دو نیروی جاذبه و دافعه اتمی است (پتانسیل لنارد جونز)^(۱) ،
نیروی جاذبه در فواصل بزرگ نیروی غالب است و نیروی دافعه در فواصل کوچک اثر می کند.
وجود نیروی جاذبه بین اتمی ناشی از پیوند اتمها در جامدات است. این نیروها ، پیوندهای بین
اتمی در جامدات را تشکیل می دهند که مسئول پایداری بلورها می باشند. بسته به منشا نیروهای
پیوندی ، چندین نوع پیوند وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از : پیوند یونی ، پیوند کووالان و
پیوند فلزی .

اطلاعات بسیاری که از بررسی ساختار بلورهای حقیقی بدست آمده است ، نشان می دهد
که ساختار درونی بلورها ، به ساختار یک بلور ایده آل شباهت ندارد. آنچه درباره شبکه بلور و
آرایش اتمها گفته شد ، تنها در صورتی صادق است که اتمها دقیقاً در مکانهای صحیح خود در بلور

قرار داشته باشند. اما بلورهای حقیقی دارای ساختار موزاییکی هستند و از قطعات منظمی تشکیل

شده اند که تقریباً موازی هم می باشند. ابعاد این قطعات بین 10^{-8} تا 10^{-6} متر تغییر می کند

و زاویه بین آنها نیز از چند ثانیه تا ده ها دقیقه متغیر بوده، و بین آنها لایه ای انتقالی وجود دارد.

از این رو شبکه تغییر شکل پیدا کرده و در نتیجه ناراستیهای^(۱) در شبکه بوجود می آید.

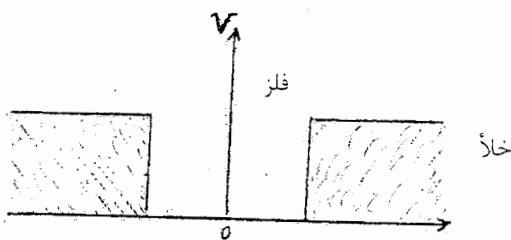
شاید تصور شود که حضور ناراستی ها تأثیر زیادی بر خواص ساختاری و الکتریکی ماده ندارد. اما روش نشده است که وجود برخی ناراستی ها در شبکه، تأثیر اساسی در بسیاری از خواص مهم جامدات از قبیل مقاومت الکتریکی و استحکام مکانیکی دارد.

در بلور دو نوع ناراستی هندسی عمدت یافت می شود. در یکی از آنها، ناراستی بسیار جایگزینه و دارای ابعاد اتمی است، اینها را ناراستی های نقطه ای می گویند که واضح‌ترین مثال آن حضور اتم های ناخالصی است. ناراستی های دیگری نیز یافت می شوند که مهم‌ترین آنها در رفتگی^(۲) است. علاوه بر ناراستی های استاتیکی، ارتعاشهای گرمایی نیز کامل بودن آرایش شبکه را بر هم می زند، که البته در دماهای بالا اهمیت دارند. حضور ناراستیهای بی نظمی بلور را افزایش می دهد (یعنی آنتروپی را زیاد می کند). به هر حال برای آنکه بتوان حرکت الکترونها را در بلور بررسی نمود نیاز به شناسایی ساختار اتمی بلورها داریم. روش های متعدد و فراوانی برای بررسی ساختار اتمی بلورها وجود دارد که ساده ترین آنها مدل کلاسیکی الکترون آزاد است.

۱-۲ - مدل الکترون آزاد^(۱)

بیشتر خواص فیزیکی فلزات مشترک است ، مانند مقاومت فیزیکی زیاد ، چگالی زیاد ، رسانایی الکتریکی و حرارتی خوب و بازتاب زیاد اپتیکی . تمام این خواص را می توان با فرض اینکه فلزات شامل تعداد زیادی الکترون تقریباً آزاد بوده که می توانند آزادانه در داخل بلور حرکت کنند ، درک کرد .

وقتی اتمهای آزاد گرد هم می آیند و باعث شکل گیری یک فلز می شوند ، الکترونهای ظرفیت اتمها به الکترونها رسانش تبدیل می شوند و حالتها آنها کاملاً تغییر می کند . در حالیکه الکترونهای داخلی جایگزیده باقی می مانند و مشخصه آنها اساساً بدون تغییر می ماند . درست همانگونه که الکترونهای ظرفیت مسئول خواص شیمیایی هستند ، الکترونها رسانش نیز مسئول اکثر خواص فلزاتند . در تقریب الکترون آزاد از نیروهای بین الکترونها رسانش و مغزهای یونی چشم پوشی می شود . در اینجا فرض می شود که الکترونها رسانش کاملاً آزادند و فقط یک پتانسیل در سطح نمونه بر آنها اعمال می شود (شکل ۳ - ۱) . در این تقریب از این واقعیت که یک اتم با از دست دادن یک الکترون به صورت یک یون مثبت باقی می ماند ، چشم پوشی می شود (این ایده اصلی در مدل الکترون در جعبه است) . در نتیجه اعمال پتانسیل فوق الذکر ، الکترونها در داخل نمونه محبوس می شوند .



شکل ۱-۳ - پتانسیل در مدل الکترون آزاد

بر طبق این مدل ، بجز بازتابهای نادری که الکترونها از سطح نمونه می کنند ، الکترونها رسانش ، بدون هیچ برخوردی در داخل نمونه حرکت می کنند . این رفتار خیلی شبیه رفتار یک گاز ایده آل است . ولذا به همین دلیل این مدل به مدل گاز الکترون آزاد نیز مشهور است . میتوان از حل معادله موج شرودینگر برای این مدل (که همان ذره در جعبه است) انرژیهای ممکن E را برای الکترون محبوس در جعبه ، که در اینجا همان بلور است ، محاسبه نمود . معادله شرودینگر در فضای سه بعدی عبارتست از :

$$\frac{-\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} \right) = E\psi \quad 1-1$$

که در آن ψ تابع موج الکترون آزاد است . از حل این معادله انرژی الکترون در بلور بصورت بدست می آید که در آن k بردار موج الکترون و m جرم آن است .

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

تعداد الکترونها رسانش را می توان با توجه به ظرفیت و چگالی فلز محاسبه کرد . چگالی الکترونی یعنی تعداد الکترونها در واحد حجم از رابطه زیر بدست می آید :

$$N = Z_v \frac{\rho_m N_A}{M'} \quad 1-2$$

که در این رابطه ρ_m چگالی ماده ، M' وزن اتمی ، N_A عدد آووگادرو و Z_v ظرفیت اتمی است .

طبق این مدل ، جریان الکتریکی در اثر حرکت الکترونها رسانش در بلور بوجود می آید و یون ها به دلیل جرم زیاد هیچگونه تحرکی از خود نشان نمی دهند . لذا این مدل منجر به قانون معروف اهم ، $V=RI$ می شود که در آن مقاومت الکتریکی شبکه بلوری است .

با استفاده از این مدل می توان پیش بینی کرد که مقاومت الکتریکی فلزات مت Shank از دو جمله است که یکی به دما بستگی داشته و دیگری مستقل از آن است . وجود چنین وابستگی های به دلیل حضور نواقص و ناراستیهای بلوری است . ماتیسنه^(۱) نشان داد که جمله مستقل از دما به دلیل حضور اتم های ناخالص در شبکه بلوری است که بعثت پراکندگی الکترونها می شود و جمله وابسته به دما به دلیل پراکندگی الکترونها از فونون ها^(۲) (ارتعاشات شبکه) است .

با استفاده از مدل الکترون آزاد می توان برخی از خصوصیات فلزات را توجیه کرد . از جمله آنها ، ظرفیت گرمایی ، رسانایی حرارتی ، تشدید سیکلوترونی ، انرژی فرمی ، گسیل گرما یونی و ... است . همچنین خواص اپتیکی (جذب و بازتابش بلور) فلزات را می توان توسط این مدل به خوبی توضیح داد .

۱-۳ - شکست مدل الکترون آزاد

مدل الکترون آزاد فقط یک مدل تقریبی بوده و دارای محدودیت هایی است. مهمترین نارسایی های مدل الکترون آزاد را می توان به صورت زیر بیان کرد :

الف- این مدل پیشنهاد می کند رسانندگی الکتریکی مواد بلورین به چگالی الکترونی آنها وابسته است ، ولی تجربه نشان می دهد که فلزات دو ظرفیتی و سه ظرفیتی بطور قابل ملاحظه ای از فلزات یک ظرفیتی رسانایی کمتری دارند ، هر چند فلزات دو یا سه ظرفیتی چگالی الکترونی بیشتری دارند .

ب- مدل الکترون آزاد همیشه یک ضریب هال منفی را پیش بینی می کند ، در حالی که ثابت هال بعضی از فلزات مانند Cd ، Zn و Be مثبت است .

ج- این مدل نمی تواند تمایز بین فلزات ، نیمه فلزات ، نیمرسانایها^(۱) و عایقها را توجیه کند.

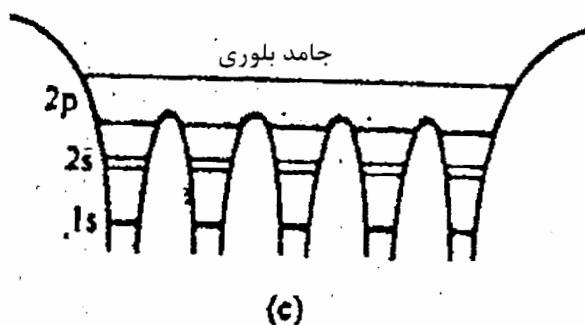
د- اندازه گیری سطح فرمی^(۲) بر این نکته دلالت دارد که شکل این سطح اغلب غیرکروی است ، که این مطلب با مدل الکترون آزاد که یک سطح فرمی کروی را پیش بینی می کند ، تناقض دارد .

ه- رابطه الکترونها رسانش در فلزات با الکترونها ظرفیت اتمهای آزاد ، توسط مدل الکترون آزاد توضیح داده نمی شود .

این مشکلات و برخی مسائل دیگر ، نیاز به یک تئوری جامع تر را مطرح می کند که در زیر به آنها می پردازیم .

۱-۵- طیف انرژی در اتمها و مولکولها

برای توصیف کلی طیف انرژی الکترون درون یک جامد بلوری، بهتر است بحث را با بررسی طیف یک اتم آغاز کنیم و بینیم وقتی این اتمها گرد هم می‌آیند تا یک جسم جامد را تشکیل دهند، چگونه این طیف تغییر می‌کند و شکل طیف انرژی چگونه است. چنانکه می‌دانیم هر کدام از ترازهای اتمی به N زیر تراز نزدیک به هم شکافته می‌شود که N تعداد اتمهای موجود در جامد است. از آنجا که N خیلی بزرگ است زیر لایه‌ها آنچنان به هم نزدیک‌شوند که به هم می‌پیوندند و یک نوار انرژی را تشکیل می‌دهند. بدین ترتیب همانگونه که در شکل ۱-۵ نشان داده شده است، ترازهای $1s, 2s, 2p$ را به ترتیب نوارهای $1s, 2s, 2p$ تشکیل می‌دهند.



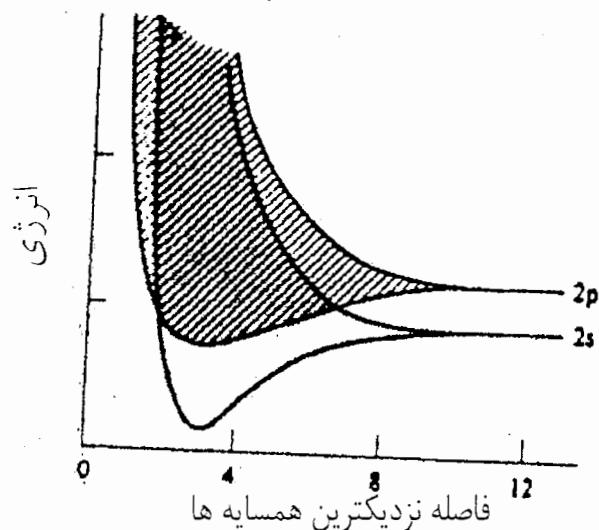
شکل ۱-۵- ترازهای $1s, 2s, 2p$ که به ترتیب نوارهای $1s, 2s, 2p$ را تشکیل می‌دهند. [۳]

برای اینکه نشان دهیم زیر لایه‌ها در یک نوار چقدر به هم نزدیک‌شوند، مثال عددی زیر را در نظر می‌گیریم. فرض کنید پهناوری نواری نوعی eV باشد، در اینصورت بازه انرژی بین دو تراز مجاور از مرتبه $eV = 5 \times 10^{-23}$ خواهد بود [۳] و از آنجا که این مقدار بینهایت کوچک است،

زیر لایه ها از یکدیگر قابل تشخیص نیستند و می توانیم توزیع آنها را به صورت نوارهای انرژی پیوسته در نظر بگیریم.

در مجموع می توان گفت طیف یک جسم جامد، ترکیبی از نوارهای انرژی است. نواحی میانی که این نوارها را از هم جدا می کند، گافهای انرژی^(۱) یا نواحی ممنوع انرژی هستند که الکترونها نمی توانند آنها را اشغال کنند. بر عکس چنین وضعیتی، حالت مربوط به یک اتم یا مولکول است که انرژی های مجاز، مجموعه ای از ترازهای گستته را تشکیل می دهند. قرار گرفتن این ترازهای انرژی در نوارهای انرژی، یکی از خواص اساسی و مهم یک جسم جامد است. پهنهای این نوارها متغیر است ولی در حالت کلی هر چه انرژی نیوار بیشتر باشد، پهنهای آن نیز بیشتر است. زیرا یک حالت انرژی زیاد، متناظر با یک شعاع اتمی زیاد و بنابراین پریشیدگی زیاد است که منجر به پهن شدن تراز انرژی می گردد. متقابلاً حالت های انرژی پایین متناظر با مدارهای کاملاً مقید می باشند که از پریشیدگی خیلی کم متأثر می شوند.

در شکل ۱-۶ نوارهای انرژی ۲p، ۲s برای لیتیوم فلزی نشان داده شده است، چنانکه ملاحظه می شود پهن شدگی نوارها به صورت تابعی از ثابت شبکه رسم شده است. همانطور که انتظار داریم، با کاهش ثابت شبکه پهنهای نوار افزایش می یابد، زیرا هر چه فواصل بین اتمی کوچکتر باشد، پریشیدگی بیشتر است.



شکل ۱-۶- پهن شدگی ترازهای $2s$ ، $2p$ درون نوارهای انرژی در یک بلور لیتیوم (a_0 شعاع بوهر یعنی

$$[3] \text{ } ۰/۵۳ \text{ } \text{Å}^{\circ}$$

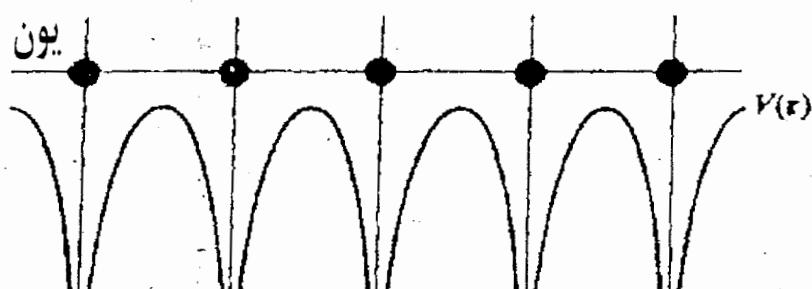
بر خلاف اوربیتالهای اتمی که در اطراف اتم خاصی جایگزیده اند و با دور شدن از اتمها بطور نمایی کاهش می یابند ، اوربیتالهای بلوری (یعنی توابع موجی که حالت‌های الکترونی را در نوارهای تووصیف می کنند) ، در تمام جامد گسترش دارند . بر این اساس از توابع موج جامدات به عنوان اوربیتالهای جایگزیده نشده یاد می کنیم . این اوربیتالها در واقع امواج الکترونی رونده در جامدات را تووصیف می کنند . مفهوم جایگزیده نشدن ، یک مفهوم اساسی است ، این مفهوم ، مسئول تمام پدیده های ترابری الکترونی در جامدات مانند رسانایی الکتریکی و گرمایی است .

۱-۶ - تابع بلوخ ^(۱)

رفتار الکترون در یک جامد بلوری با معادله شرودینگر، مطالعه می‌شود. این معادله را می‌توان به صورت زیر در نظر گرفت:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(r) \right] \Psi(r) = E\Psi(r) \quad 1-3$$

که در آن $V(r)$ پتانسیل بلور است که توسط الکترون دیده می‌شود، $\Psi(r)$ و E به ترتیب تابع حالت و انرژی این الکترونند. پتانسیل $V(r)$ شامل بر هم کنش الکترون با تمام اتمها در جسم جامد و همینطور بر هم کنش بین الکترونهای دیگر است، که به دلیل تناوبی بودن شبکه بلوری خود دارای خاصیت تناوبی است. این پتانسیل متناوب در شکل ۷-۱ نشان داده شده است.



شکل ۷-۱ - پتانسیل تناوبی موجود در شبکه بلوری [۴]

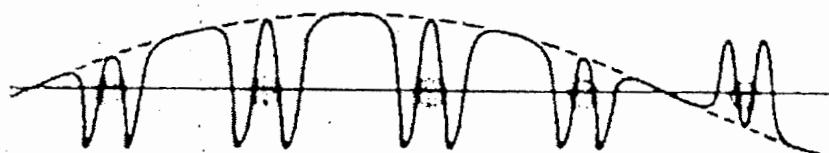
بر طبق قضیه بلوخ، حل معادله شرودینگر برای یک پتانسیل متناوب $V(r)$ به صورت زیر است:

$$\Psi_k(r) = e^{ikr} U_k(r) \quad 1-4$$

که در آن تابع $U_k(r)$ همان تقارن انتقالی شبکه را دارد. یعنی می‌توان نوشت:

$$U_k(r+R) = U_k \quad 1-5$$

تابع $U_k(r)$ به تابع بلوخ معروف است. این تابع به شکل یک موج تخت رونده است و این نکته دلالت بر این دارد که الکترون در بلور مانند یک ذره آزاد منتشر می‌شود. اثر تابع $U_k(r)$ مدوله کردن^(۱) این موج است. (شکل ۸ - ۱)



شکل ۸-۱- نمایشی از موج یا تابع بلوخ [۱]

چون الکترون مانند یک موج با بردار k در داخل شبکه بلوری رفتار می‌کند لذا می‌توان به

$$\text{آن طول موج دوبربوی}^{(۲)} = \frac{2\pi}{k} \quad \text{نسبت داد و بنابراین اندازه حرکت آن} \quad P = \hbar k$$

همچنین تابع $\Psi_k(r)$ ، یک اوربیتال بلوری است و در اطراف اتم خاصی جایگزیده نشده است،

لذا می‌توان نتیجه گرفت که الکترون متعلق به همه بلور است. این مطلب با این خاصیت که

الکترون را به صورت یک موج رونده، توصیف کردیم سازگار است.

1-modulation

2-Dobroy wave Length

۱-۷ - نوارهای انرژی^(۱)

از حل معادله شرودینگر می‌توان طیف انرژی‌های ممکنه را در ساختار بلوری بدست آورد.

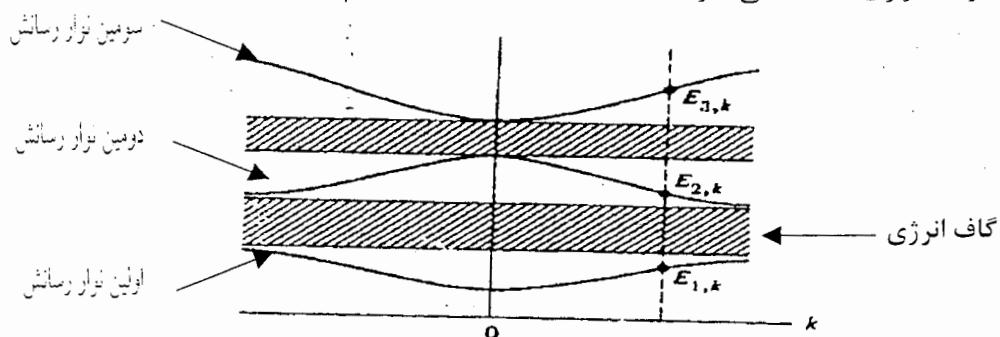
معادله شرودینگر را با جایگزینی $e^{ikr} \Psi_k(r)$ از رابطه بلوخ و حذف e^{ikr} ، پس از انجام عملیات لازم

می‌توان به شکل زیر بازنویسی کرد:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} (\nabla + ik)^2 + V(r) \right] U_k(r) = E_k U_k(r) \quad ۱-۶$$

این معادله یک معادله ویژه مقداری است. در اینجا هم ویژه تابع و هم ویژه مقدار به k یعنی بردار موج الکترون در شبکه بلوری وابسته است. یک معادله ویژه مقداری، به چندین حل منجر می‌شود بطوریکه برای هر مقدار k چندین جواب بدست می‌آید که مجموعه ای از انرژی‌های گسسته را تشکیل می‌دهند. چون این انرژی‌ها به k وابسته است، با تغییر k به صورت پیوسته تغییر می‌کنند. همانطور که در شکل ۱-۹ نشان داده شده است هر تراز به یک نوار انرژی منجر می‌شود. بنابراین انرژی ویژه مقدار را به صورت $E_n(k)$ نویسیم، که در آن

اندیس n ضریب نواری نامیده می‌شود.



شکل ۱-۹ - گافها و نوارهای انرژی [۱۴]

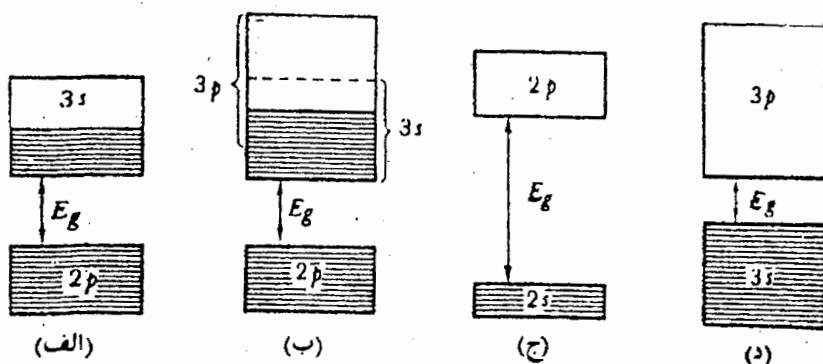
عموماً تعداد نوارها زیاد و بینهایت است ، و فقط پایینترین نوارها توسط الکترونها اشغال می شوند . هر نوار یک ناحیه انرژی معین را می پوشاند که وقتی در فضای k رسم شود ، از پایینترین تا بالاترین مقادیر انرژی را در بر می گیرد . بازه هایی از انرژی که نوارهای انرژی را از هم جدا کرده اند ، گافهای انرژی نامیده می شود ، که نواحی انرژی ممنوعه می باشند ، یعنی در این مکان ها الکترون نمی تواند حضور داشته باشد .

از آنجا که k یک کمیت برداری است ، شکل ۹ - ۱ ترسیمی از نوارهای انرژی در یک جهت بخصوص از فضای k را نشان می دهد . اگر این نوارها در جهات گوناگون k رسم شوند در حالت کلی شکل آنها تغییر خواهد کرد . بنابراین برای نمایش کامل نوارها لازم است نوارهای انرژی را در تمامی فضای k تعیین نماییم . بین نوارهای انرژی که از این تجزیه و تحلیل بدست می آید و ترازهای اتمی که از آنها ناشی می شود ، یک تناظر یک به یک برقرار است .

هر نوار انرژی تعداد محدودی تراز انرژی دارد . طبق اصل طرد پانولی ، هر تراز انرژی نمی تواند بیش از دو الکترون داشته باشد . با توجه به تعداد محدود الکترونها در یک جامد ، فقط نوارهای با انرژی کمتر ممکن است پر شوند . بر حسب کیفیت اشغال نوارها توسط الکترونها ، در دمای صفر کلوین کلیه جامدات را می توان به دو گروه بزرگ طبقه بندی کرد . گروه اول شامل اجسامی است که بالاتر از نوار کاملاً پر آنها ، نواری وجود داشته باشند که به طور جزئی پر است (شکل ۱۰ - ۱ الف) . این نوارهای غیر پر از آن دسته ترازهای اتمی تشکیل شده است که خودشان تکمیل نیستند (فلزات قلیایی) . همچنین یک نوار غیر پر ممکن است از یک نوار کاملاً پر و یک نوار خالی یا یک نوار غیر کامل هم تشکیل شود . (مانند برلیوم و فلزات قلیایی خاکی ، (شکل ۱۰ - ۱ - ب) . فلزات دارای نوارهایی هستند که بطور جزئی پر شده اند .

گروه دو شامل اجسامی است که در بالای نوار کاملاً پر آنها نوارهای کاملاً خالی وجود داشته باشد. (شکل ۱۰ - ۱ - ج و د) نمونه چنین اجسامی عناصر گروه چهار جدول تناوبی مانند کربن به صورت الماس، سیلیسیوم، ژرمانیوم و قلع خاکستری که ساختار الماسی را دارند، می‌باشد. این گروه همچنین بعضی از ترکیبات شیمیایی اکسیدهای فلزی، نیترات‌ها، کربورها و ترکیبات هالوژنه فلزات قلیایی و غیره را در بر می‌گیرد.

طبق نظریه نواری، الکترون‌های خارجی ترین نوار انرژی عملأً آزادی بیشتری در حرکت دارند و فرقی نمی‌کند که جسم جامد، فلز یا عایق باشد. حرکت الکترون از یک اتم به اتم دیگر بر حسب پدیده تونل زنی^(۱) انجام می‌شود. علی‌رغم این واقعیت اختلافی در حدود چندین مرتبه نمایی بین خواص الکتریکی آنها وجود دارد، بخصوص در خواص رسانایی الکتریکی اجسامی از این دو نوع تفاوت بزرگی مشاهده می‌شود.



شکل ۱۰ - ۱ - اشغال نوارها توسط الکترونها
الف و ب - نوار غیر پر در بالای نوار پر، ج و د - نوار تهی در بالای نوار پر [۳]

در فلزات رسانندگی عموماً از مرتبه $\sigma = 10^7 (\Omega - m)^{-1}$ و در بهترین نارساناهای رسانندگی عموماً کوچکتر از حد $\sigma = 10^{11} (\Omega - m)^{-1}$ است. برای درک بیشتر مکانیسم هدایت الکتریکی جامدات به بررسی رفتار الکترونها تحت تأثیر یک میدان خارجی در نوارهای انرژی پر و نیمه پر می‌پردازیم.

فرض کنیم میدان الکتریکی خارجی E را بر بلواری اعمال کنیم. این میدان هر الکtron را تحت تأثیر نیروی $eE = F$ قرار داده و تقارن موجود در توزیع سرعت الکترونها را بر هم می‌زند، زیرا سرعت الکترونها که برخلاف جهت این نیرو حرکت می‌کنند کم شده و سرعت آنهایی که هم جهت با نیرو هست بیشتر می‌شود. این گونه کند یا تند شدن حرکت موجب تغییر انرژی الکtron شده و باعث می‌گردد که الکترونها به حالات دیگری با انرژی کمتر یا بیشتر درآیند. این امر وقتی محقق می‌شود که نوار کاملاً پر نباشد. در چنین وضعیتی یک میدان الکتریکی ضعیف هم قادر است به الکترونها ممتنم اضافه لازم را بدهد تا الکtron به تراز آزاد نزدیکش برود. حرکت عمومی الکترونها در خلاف جهت میدان الکتریکی جریان الکتریکی را نتیجه می‌دهد، و چنین جامداتی می‌توانند رساناهای خوبی را تشکیل دهند.

اگر نوار ظرفیت بلوار کاملاً پر بوده و از نوار خالی مجاورش با گاف انرژی عریض E_g جدا شده باشد، (شکل ۱-۱-ج) در چنین بلواری میدان خارجی توانایی آن را ندارد که نوع حرکت را در نوار ظرفیت تغییر دهد. زیرا این میدان اعمالی توانایی آرا ندارد که الکترونها را نوار ظرفیت را به نوار خالی بالاتر بفرستد. همچنین این میدان قادر نخواهد بود که در خود نوار ظرفیت که تراز خالی در آنها وجود ندارد، تغییری در نحوه توزیع الکترونها بدهد، و از این طریق توزیع الکترونها را به هم بزند. بنابراین در چنین اجسامی، میدان خارجی قادر به ایجاد حرکت جهت دار الکترونها نبوده و نتیجتاً هدایت الکتریکی چنین اجسامی عملاً صفر خواهد بود.

پس برای اینکه جسمی دارای رسانایی الکتریکی زیاد باشد باید در طیف انرژی خود، نوارهای نسبتاً خالی داشته باشد، چنانچه در مورد فلزات مشاهده می شود.

(شکل ۱۰-۱-الف و ب) عدم وجود چنین نوارهایی در جامدات متعلق به گروه دوم، باعث می شود که نارساناهای الکتریکی باشند، علی رغم اینکه این اجسام داری الکترونهایی هستند که با اتمهای خودشان بطور ضعیف پیوند دارند.

جامدات گروه دوم را معمولاً به دو دسته نارسانا و نیمرسانا تقسیم می کنند، این تقسیم بندی بر حسب عرض گاف انرژی آنها می باشد، نارسانا جامداتی را شامل می شوند که اندازه گاف انرژی آنها نسبتاً زیاد است، معمولاً برای آنها $E_g < 4\text{eV}$ است و نیمرساناها شامل

جامداتی اند که اندازه گاف انرژی آنها بسیار کم است، (شکل ۱۰-۱-د). برای نیمرساناها E_g کمتر از ۴ الکترون ولت است، بطور مثال برای ژرمانیوم $E_g \geq 0.66\text{eV}$ و در سیلیسیوم $E_g \geq 1.18\text{eV}$ است.

۸-۱- رابطه میان انرژی و بردار موج

در اینجا لازم است درباره رابطه بین E و k در نزدیکی قله، مثلاً نوار اول با تفصیل بیشتری بحث شود. در مکانیک کوانتومی سرعت یک ذره با سرعت گروه^(۱) $\frac{d\omega}{dk}$ مشخص می شود که سرعت انتقال انرژی نیز هست، ($E \equiv \hbar\omega$).

سرعت الکترون با شب منحنی $E - k$ متناسب است. بنابراین ملاحظه می شود که با شروع از نقطه $o = k$ ، سرعت ابتدا با زیاد شدن E ، زیاد می شود که ناشی از افزایش انرژی

جنبیشی الکترون است ، اما در نزدیکی قله شیب منحنی کم می شود ، لذا با وجود اینکه انرژی هنوز در حال افزایش است ، سرعت کاهش می یابد این بدان علت است که شدت بر هم کنش الکترون با پتانسیل دوره ای شبکه قابل ملاحظه است . در لبه نوار $\frac{d\omega}{dk}$ و در نتیجه سرعت الکترون صفر است . اما این امر ایجاد نمی کند که الکترون ساکن باشد بلکه بدین معنی است که حرکت الکترون در جهتهای + و - به یک اندازه محتمل است ، در نتیجه مقدار چشمداشتی سرعت صفر است .

۱- نظریه نواری در سه بعد ، مناطق بریلوئن

چون k کمیتی برداری است ، لبه نوارها باید با مرزهای یک شکل سه بعدی در فضای k توصیف شوند ، چنین شکلی را منطقه بریلوئن^(۱) گویند . شکل این منطقه با ساختار هندسی شبکه انتقال تعیین می شود و ابعاد آن به ثابت شبکه a بستگی دارد .

برای ترسیم مناطق بریلوئن می توان هر نقطه در شبکه وارون را به عنوان یک مرکز اختیار کرده و سپس عمود منصف خطوطی که آن نقطه را به همه نقاط موجود در اطراف شبکه وارون وصل می کنند ، ترسیم نمود . شبکهایی که بدین ترتیب ایجاد می شوند ، مناطق بریلوئن نامیده می شوند .

منطقه بریلوئن شبکه مکعبی ساده ، به صورت مکعب ساده ای به ضلع $\frac{2\pi}{a}$ است . خارج از

منطقه اول منطقه دومی وجود دارد که با آن دسته از مقادیر k محصور می شود که در دومین گاف انرژی اند و به همین ترتیب الی آخر برای دیگر مناطق بالاتر .

سطوح با انرژی ثابت را باید در داخل این منطقه ها ترسیم کنیم . به ازای مقادیر کوچک k این سطوح درست مانند حالت الکترون آزاد کروی اند و الکترونها حالت هایی را که داخل این کره قرار دارند پر می کنند . مرکز این کره در وسط منطقه ^(۱) واقع است . نزدیک لبه منطقه ، سطوح با انرژی ثابت واپیچیده می شوند ، یعنی E علاوه بر بزرگی به جهت k نیز بستگی پیدا می کنند .

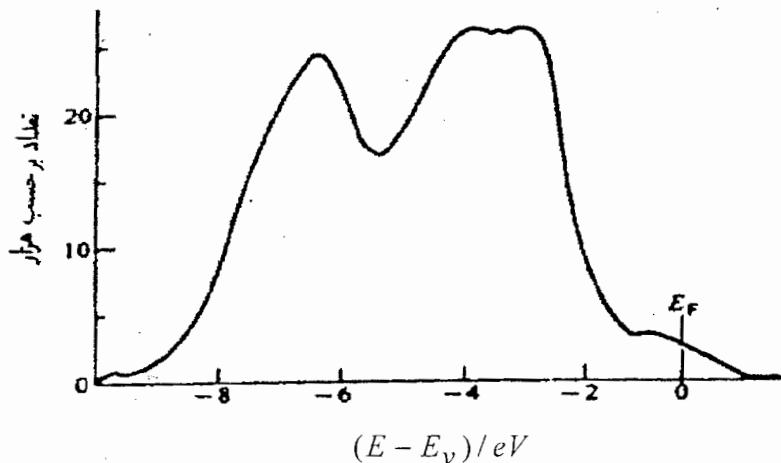
۱-۱- مشاهده تجربی نوارهای انرژی

شكل نوارهای انرژی در فلزات نخستین بار از طیفهای پرتو X استنتاج شد و با تصحیحاتی که در این روش انجام گرفت ، قدرت تفکیک بسیار خوبی بدست آمد . امروزه روش بسیار پر قدرتی برای تعیین انرژی ها و شکل تمام حالتها در اتم یا یون با دقیقی فوق العاده بالا پیدا شده است . این روش گسیل فوتون فتوالقائیده (یا پرتو X) است .

در این آزمایشها ، نمونه تحت تابش پرتو X و یا فرابنفش با انرژی معین و دقیق E قرار می گیرد که برای کندن الکترون از بلور به اندازه کافی بزرگ است . انرژی جنبشی E_k این

الکترونها گسیل شده در طیف سنج بسیار دقیق پرتو β اندازه گیری می شود .

بنابراین انرژی لازم برای کندن الکترون از اتم یا یون برابر $E_i = E - E_k$ است . از این روش می توان برای اندازه گیری بسیار دقیق ترازهای تیز داخل اتم و نیز شکل نوارها استفاده کرد . (شکل ۱-۱۱) با این روش تنها الکترونها که تا عمق $2nm$ هستند ، قابل شناسایی اند . لذا اطلاعات بدست آمده تنها به لایه های سطحی اتمها محدود می شود .



شکل ۱۱-۱- نوار خارجی که با اندازه گیری های گسیل فوتون فتوالقائیده تعیین شده است . این نوار از

همپوشانی نوارهای ۵d و ۶s تشکیل شده است . [۴]

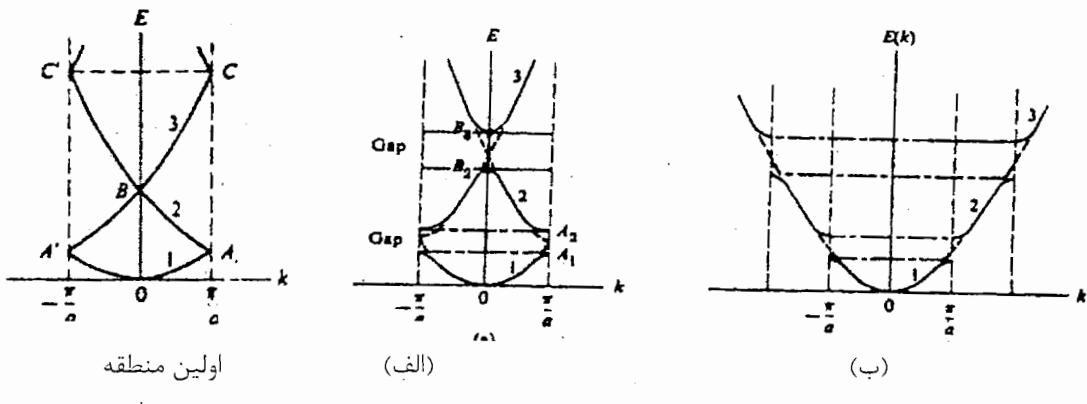
۱-۱- روش های محاسبه نوارهای انرژی

روشهای متفاوتی برای محاسبه نوارهای انرژی در جامدات بلورین وجود دارد که در زیر

معروف ترین این روشها را بررسی می کنیم :

الف- مدل الکترون تقریباً آزاد^(۱)

ساختار نواری بلورها را اغلب می توان با مدل الکترون تقریباً آزاد توصیف کرد . در این مدل الکترون های نوار رسانش به گونه ای بررسی می شوند که گویی تنها به طور ضعیفی توسط پتانسیل دوره ای مغزهای یونی مختل می شوند . بر اساس این مدل اغلب می توان ساختار نوار رسانش را توجیه کرد . البته وضعیت هایی وجود دارد که این مدل در مورد آنها صادق نیست . بخصوص هنگامی که پتانسیل واقعی بلور منظور شود طیف انرژی تغییر خواهد کرد . (شکل ۱۱-۲-ب)



شکل ۱۲ - ۱ - الف - منحنی های پاشندگی در مدل الکترون آزاد در منطقه تحول یافته

ب - همان منحنی ها در منطقه گسترش یافته [۴]

اولین و دومین نوار که قبلاً در نقطه A و A' در شکل ۱۲ - ۱ الف تماس داشتند ، حال شکافته می شوند بطوری که یک گاف انرژی در مرز منطقه بریلوئن ایجاد می شود . یک گاف مشابه در مرکز منطقه ، جایی که قبلاً نوارهای ۲ و ۳ همدیگر را قطع کرده بودند (نقطه B در شکل ۱۲ - ۱ - الف) ر همچنین در نقطه C که محل تلاقی نوارهای ۳ و ۴ بود ، ایجاد می شود . پس در حالت کلی گاف های انرژی در فضای k جایی ایجاد می شوند ، که نوارها یکدیگر را قطع می کنند . در این نقاط شکل طیف شدیداً با پتانسیل بلور ^(۱) تغییر می کند .

در باقی مانده منطقه ، شکل طیف چندان از پتانسیل بلور تأثیر نمی پذیرد ، زیرا فرض این است که این پتانسیل ضعیف است . در این ناحیه از فضای k نوارهایی که اساساً شکل هذلولی دارند حفظ می شوند و الکترون در آنجا اساساً مثل یک الکترون آزاد عمل می کند .

حتی یک پتانسیل ضعیف منجر به ایجاد گاف های انرژی می شود . البته باید توجه کرد که به جز در مرزهای منطقه که گاف ها ایجاد می شوند ، منحنی های پاشندگی اساساً همان منحنی های الکترون آزاد هستند . این مطلب را می توان با کمک اصل اغتشاش^(۱) در نظریه

$$E_g = 2 \left| V_{-\frac{2\pi}{a}} \right| \text{ که در آن}$$

$$E_g = \left| V_{-\frac{2\pi}{a}} \right| \text{ مولفه فوریه پتانسیل است تعیین می شود ، یعنی گاف های انرژی دو برابر}$$

$$E_g = \left| V_{-\frac{2\pi}{a}} \right| \text{ پایین می آید و}$$

نوار دوم ، به همان اندازه افزایش پیدا می کند و این منجر به یک گاف انرژی می شود که در رابطه بالا بیان دیده می شود .

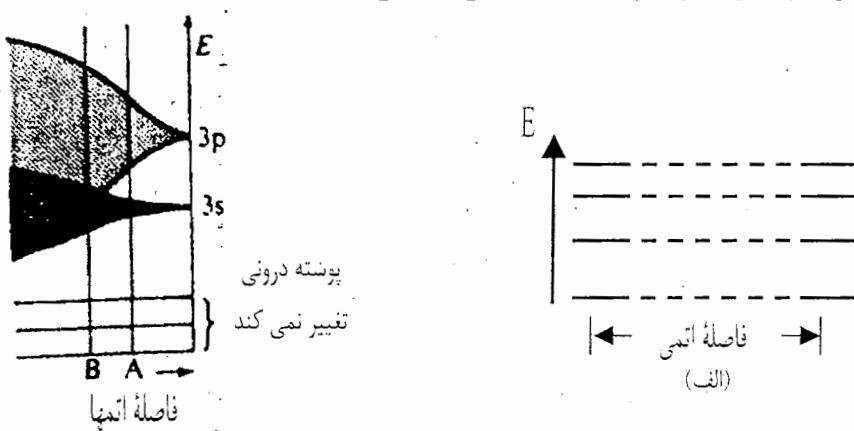
ب-تقریب بستگی قوی^(۱)

برای بررسی ساختار نواری جامدات بلورین روش های کاملاً متفاوتی با آنچه قبل ذکر شد وجود دارد ، که با کمک آنها در خصوص تشکیل نوارها به بینش عمیقتری می توان دست یافت .

در روش بستگی قوی فرض می شود که بلور با نزدیک کردن اتمهای منفرد به یکدیگر تشکیل می شود . در این مدل ، پتانسیل بلور بسیار قوی فرض می شود . از این فرض نتیجه می شود که وقتی یک الکترون در طول حرکتش درون شبکه توسط یک یون به دام می افتاد ، قبل از آنکه به یون دیگری تونل بزند ، مدت زیادی در اطراف آن یون منفرد دور می زند . یعنی تابع حالت آن اساساً مربوط به یک اوربیتال اتمی است و از اتم های دیگر تأثیرپذیر نخواهد بود .

1-Perturbation Principle
2-Tight Binding approximation

وقتی اتمها کاملاً جدا از هم باشند هر کدام یک سیستم منزوی تشکیل می‌دهند و در نتیجه، ترازهای انرژی هم ارز آنها دقیقاً یکسان خواهند بود. اما موقعی که اتمها را آنقدر به هم نزدیک کنیم که بین هر اتم و اتم مجاورش بر هم کنش ایجاد شود، آنها را باید به صورت یک تک سیستم در نظر گرفت. در این شرایط حالت‌های انرژی هم ارز اولیه، باید طوری نسبت به یکدیگر انتقال یابند که اصل طرد پائولی نقض نشود. هر چه اتمها به یکدیگر نزدیکتر شوند، این انتقال بزرگتر خواهد بود و بدیهی است که مقدار آن برای اوربیتالهای الکترونی مدارات خارجی چشمگیرتر است. اگر N اتم در اختیار داشته باشیم، هر حالت الکترونی در یک اتم به N تراز گسترش می‌یابد. این موضوع در شکل ۱۳-۱- ب نشان داده شده است. به این ترتیب تراز بیرونی $3S$ سدیم که می‌تواند دو الکترون را در خود جای دهد، به نوار حاوی N تراز گسترش می‌یابد. در بالای این تراز حالت‌های $3P$ (که در سدیم اشغال نشده‌اند) نیز پهن می‌شوند و نوار دیگری را تشکیل می‌دهد. پهنای نوارها و گاف‌های انرژی بین آنها به حالت‌های الکترونی خاص اتم‌ها و همچنین به فاصله اتمی بستگی دارد.



شکل ۱۳-۱ - رویهم افتادگی ترازهای انرژی به فواصل اتمی وابس است

الف- هنگامی که اتمها کاملاً از هم دورند و ترازهایشان تیز است.

ب- نحوه تشکیل نوارهای انرژی گاف‌های انرژی و نوارهای هم پوشان^(۱) را بیان می‌کند. [۴]

این روش تقریب بستگی قوی نامیده می شود ، زیرا فرض شده است که الکترونها خارجی در ابتدا ، بسیار وابسته به اتمهای خود هستند . با کمک این روش می توان نشان می دهد که :

الف- گافهای نواری و نیز همپوشانی نوارها تا حد زیادی به بلور مورد مطالعه بستگی دارد .

ب- چون نوارها از گسترش ترازهای الکترونی مختلف حاصل می شوند ، نه شکل نوار بالایی لزوماً با نوار پایینی یکسان است و نه لازم است که تعداد حالتها مجاز در آنها یکسان باشد .

چنین نتایجی بخصوص در محاسبات نوارهای انرژی مواد نیمرسانا اهمیت خاص دارد . هیچ کدام از نتایج ۱ یا ۲ را نمی توان از نظریه نواری الکترونها تقریباً آزاد استنتاج کرد .

ج- روش شبیه پتانسیل ^(۱)

در قسمتهای قبلی روشهایی برای محاسبه نوارهای انرژی بیان شد . این روشها یعنی روش الکترون تقریباً آزاد و روش بستگی قوی ، ساده تر از آن هستند که برای نوارهای واقعی مفید باشند و بتوان آنها را با نتایج تجربی مقایسه کرد .

در اینجا یک روش کلی را که برای محاسبه نوارهای انرژی بکار می رود مورد بحث قرار می دهیم . در این روش (شبیه پتانسیل) به دنبال تابعی هستیم که در داخل مغز یونی نوساناتی سریع داشته باشد و در باقیمانده فضای ویگنر سایتز^(۲) مانند یک موج تخت حرکت کند . تابع موج برای بردار موج k را بصورت زیر در نظر می گیریم .

$$\omega_k = Q_k - \sum_i a_i U_i \quad 1-7$$

که در آن Q_k یک موج تخت و U_i یک تابع اتمی است . جمع روی i یعنی بر روی همه حالتها اتمی اشغال شده گسترش می یابد .

تابع ω_k همان ترکیبی را دارد که به دنبال آن بودیم . توابع اتمی U_i در خارج از مغز یونی قابل چشم پوشی است و بنابراین $Q_k \equiv \omega_k$ یک موج تخت است . در مغز یونی ، پتانسیل اتمی قابل ملاحظه و به گونه ای عمل می کنند که مانند آنچه در شکل ۱۴ - ۱ نشان داده شده ، نوسانات آرامی داشته باشد . حال اگر ω_k را در معادله شرودینگر جایگزین نمائیم ، خواهیم داشت :

$$\left(\frac{-\hbar^2 \nabla^2}{2m} + V \right) \omega_k = E(k) \omega_k \quad 1-8$$

با مرتب کردن جملات در می یابیم که معادله را می توان به شکل زیر نوشت :

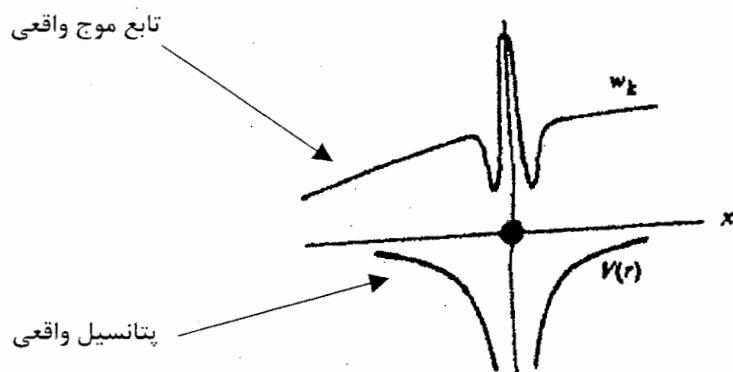
$$\left(\frac{-\hbar^2 \nabla^2}{2m} + V' \right) Q_k = E(k) Q_k \quad 1-9$$

که در آن

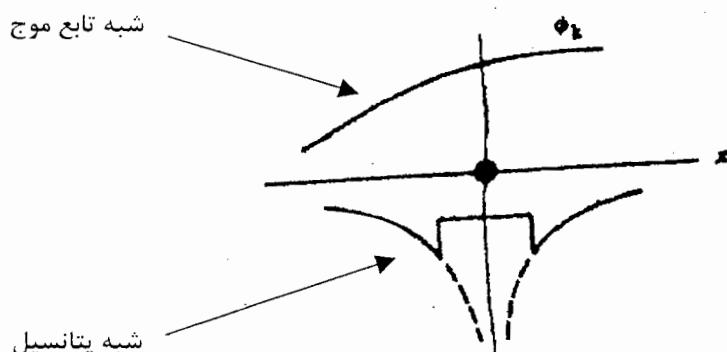
$$V' = V - \sum b_i \langle U_i | V | U_i \rangle \quad 1-10$$

معادله ۹ - ۱ نشان می دهد که پتانسیل موثر با V' بیان می شود ، در حالیکه رابطه ۱ - ۱ جمله دوم تمایل به حذف جمله اول دارد . این حذف پتانسیل بلور توسط تابع اتمی معمولاً قابل ملاحظه و اغلب منجر به پتانسیل خیلی ضعیف ' V' می شود . این پتانسیل ، شبه پتانسیل نامیده می شود . از آنجا که ' V' بسیار ضعیف است تابع موج تقریباً موج تخت است که شبه تابع نامیده می شود . تابع موج و پتانسیل واقعی در شکل ۱۴ - ۱ و شبه تابع و شبه پتانسیل در شکل ۱۵ - ۱ نشان داده شده است . چنانکه ملاحظه می شود پتانسیل در نواحی مغز های یونی کاملاً ضعیف است بطوریکه تابع موج در این ناحیه شبیه یک تابع موج تخت هموار رفتار می

کند. روش‌های دیگری نیز برای محاسبه نوارهای انرژی وجود دارد که از جمله آنها روش سلولی و روش موج تخت گسترش یافته است.



شکل ۱-۱۴ - یک نمودار شماتیک از پتانسیل واقعی و تابع موج واقعی که در نزدیک یون به سرعت نوسان می کند. (در حالی که پتانسیل واقعی قوی می باشد) [۳]



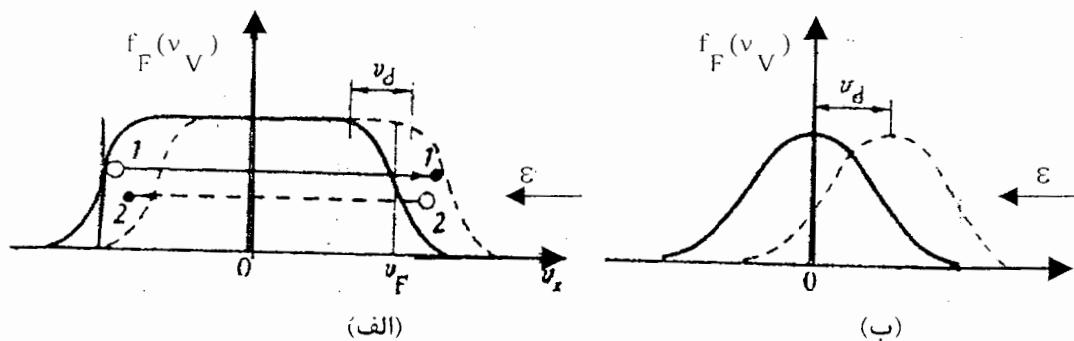
شکل ۱-۱۵ - نمودار شماتیک از تابع شبیه موج در حالی که تابع شبیه موج تغییر سریعی ندارد و نمودار شبیه پتانسیل در حالی که شبیه پتانسیل در همه جا ضعیف باقی می ماند. (در فاصله دور از یون پتانسیل های واقعی و شبیه پتانسیل و تابع موج واقعی و تابع شبیه موج یکسان می باشند) [۴]

فصل دوم

حرکت الکترون درون نیمرسانا
و مکانیسم های پراکنده کی الکترون

۲-۱ - نظریه مقدماتی رسانندگی

در غیاب میدان الکتریکی ، گاز الکترونی در یک رسانا در حال تعادل بوده و توسط توابع توزیع قابل بررسی است . در مورد یک گاز الکترونی تبیه‌گن تابع مربوطه ، تابع توزیع فرمی - دیراک^(۱) است (شکل ۲-۱ - الف) ، در صورتی که گاز غیر تبیه‌گن از تابع توزیع ماکسول - بولتزمن^(۲) پیروی می کند (شکل ۲-۱ - ب) . وقتی ماده رسانا خارج از میدان الکتریکی قرار دارد ، الکترونهای آن در بین تمام حالت‌های انرژی تا تراز بالاترین حالت توزیع می شوند و در نتیجه به همان تعداد حالت اشغال شده دارای بردار موج مثبت ، حالت‌های با بردار موج منفی نیز وجود دارد . یعنی الکترونهای بـ همان تعداد که در یک جهت حرکت می کنند ، در جهت مخالف نیز حرکت می نمایند . اگر سرعت تمام الکترونها را با هم جمع کنیم ، میانگین سرعت آنها صفر شده و در نتیجه جریان خالص الکتریکی وجود ندارد .

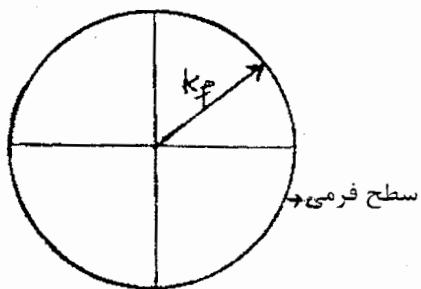


شکل ۱-۲ - الف - منحنی تابع توزیع فرمی-دیراک ب - منحنی تابع توزیع ماکسول - بولتزمن [۵]

این موضوع در شکل ۲-۲ نشان داده شده است . در این شکل توزیع همسانگرد از بردارهای موج تا مقادیر ماکزیمم نشان داده شده است . این مقادیر بر روی سطح کره ای به نام کره فرمی

۱-Fermi – Dirac distribution function
2-Maxwell – Boltzmann distribution function

قرار می‌گیرند. این سطح، معرف سطحی با انرژی ثابت، مربوط به انرژی فرمی^(۱) E_f در فضای k است.



شکل ۲ - کره فرمی

هنگامی که میدان الکتریکی E به رسانا اعمال می‌شود، به هر الکترون نیروی $-eE$ وارد می‌آید. الکترون در جهت نیروی وارده شتاب می‌گیرد. (این جهت در مورد الکترونها خلاف جهت قراردادی است) و در نتیجه جریان الکتریکی ایجاد می‌شود، که شدت آن طبق قانون اهمیت σE است که در این رابطه ضریب تناسب σ را رسانایی جسم رسانا می‌نامند.

تحت چنین شرایطی موازنۀ توزیع حالت‌های اشغال شده بثربم می‌خورد و تعداد الکترونها بیکه به سمت راست حرکت می‌کنند بیش از آنهایی است که به چپ می‌روند. یعنی یک شارش خالص بار برقرار خواهد بود. در حقیقت تابع توزیع الکترونها دستاخوش تغییر شده است. اینگونه حرکت الکترونها را حرکت سوق و سرعت آنها را سرعت سوق^(۲) می‌نامند. لیکن حرکت الکترونها همیشه نمی‌تواند به این صورت باشد، زیرا اگر میدان برقرار بماند، شتاب گرفتن الکترونها ادامه می‌یابد و در نتیجه جریان بطور نامحدودی افزایش خواهد یافت. اما تجربه نشان داده است که پس از مدت بسیار کوتاهی، جریان ثابتی برقرار می‌شود، که مقدار آن به میزان شدت میدان اعمالی بستگی دارد. علت پایداری جریان این است که الکترونها واقع در حالت‌های

نزدیک سطح فرمی با ساز و کارهای مختلفی (که بعداً به آن خواهیم پرداخت) پراکنده می شوند.

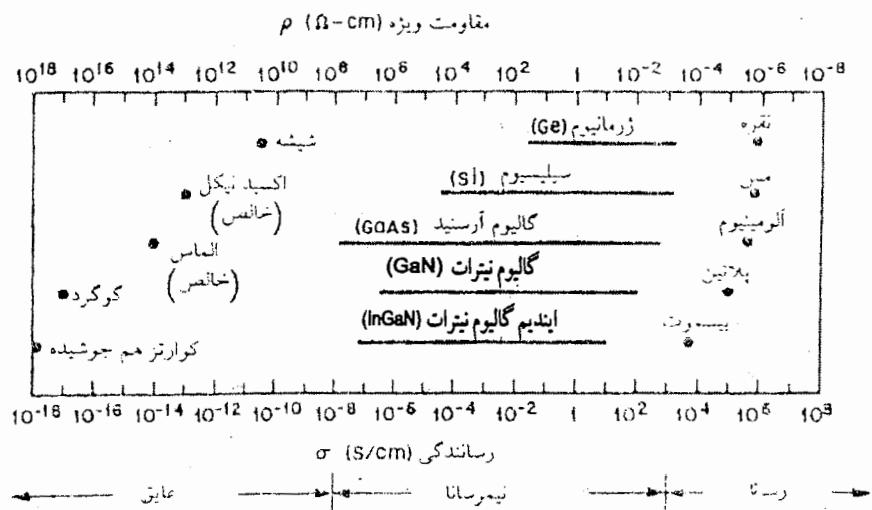
در واقع وجود نوافع شبکه موجب تغییراتی در پتانسیل دوره ای شبکه گشته و همچون راکر پراکنده‌گی برای امواج الکترونی درآمده و باعث میرایی شارجهت دار الکترونها می گردد.

همانگونه که اعمال میدان الکتریکی خارجی به یک رسانا باعث اعمال نیرو به الکtron شده و آنرا شتاب می دهد ، در نیمرسانا نیز مکانیزم مشابهی رخ می دهد که در اینحالت معادله حرکت الکترون تحت اعمال میدان الکتریکی خارجی بنام معادله بولتزمن^(۱) مشهور بوده که در فصل بعدی به شرح آن می پردازیم . در این قسمت ابتدا خواص عمومی نیمرساناها را مرور خواهیم کرد .

به طور کلی جامدات به سه دسته نارساناها (عایق) ، نیمرسانا (نیمه هادی) و رساناها (هادی) گروه بندی می شوند . شکل ۳ - ۲ رسانندگی الکتریکی ۵ و مقاومت ویژه مربوطه کوارتز همچو شیده دارای رسانندگی خیلی پائین در حدود 10^{-18} تا 10^{-8} s/cm مربوط به مهمترین مواد در هر سه گروه را نشان می دهد . نارساناها مانند شیشه و $\rho = \frac{1}{\sigma}$ (زیمنس) می باشند ، در صورتیکه رساناها نظیر آلومینیوم و نقره دارای رسانندگی بالا ، بطور نمونه از 10^6 تا 10^4 s/cm هستند . نیمرساناها جامدات بلورینی هستند که دارای آرایش دوره ای و منظم از اتمها هستند . این دسته مواد خواص ویژه و منحصر به فردی دارند ، بطوریکه امروزه جایگاه ویژه ای در صنعت به خود اختصاص داده اند و با پیشرفت فن آوری ، هر روز بزرگاربردهای آنها افزوده می شود .

دیودهای نوری ، لیزرهای نیمرسانها ، ترانزیستورها و انواع وسایل الکترونیکی و ... نمونه هایی از کاربردهای فراوان نیمرسانها در زندگی امروزه ماست . نیمرسانها دارای رسانندگی بین نارسانها و رساناهای هستند .

رسانندگی نیمرسانا بطور کلی نسبت به دما، روشایی، میدان مغناطیسی و مقدار دقیق ناخالصی اتمها حساسیت دارد. همین حساسیت در رسانندگی است که نیمرساناهای را به یکی از مهمترین مواد برای کاربردهای الکترونیکی تبدیل کرده است.



شکل ۳-۲ - برد نوعی رسانندگی برای عایقها - نیمرسانانها - رسانانها [۶]

مطالعه مواد نیمرسانا در اوایل قرن ۱۹ شروع شد. در طول سالها نیمرساناهای فراوانی مورد بررسی قرار گرفته اند. جدول ۲-۱ قسمتی از جدول تناوبی مربوط به مواد نیمرساناهای نشان می دهد.

VI- گروه	V- گروه	IV- گروه	III- گروه	II- گروه
	N	C	B	
S	P	Si	Al	Mg
Se	As	Ge	Ga	Zn
Te	Sb	Sn	In	Cd
		Pb		Hg

جدول ۲-۱- قسمتی از جدول تناوبی مربوط به نیمرساناهای

نیمرساناهای عنصری یعنی آنهای که از نمونه های منفرد اتمها تشکیل می شوند ، نظیر سیلیکن Si و ژرمانیوم Ge را می توان در ستون IV پیدا نمود . مع ذالک ، نیمرساناهای مرکب را می توان از دو یا چند عنصر تشکیل داد . بطور مثال GaN یک ترکیب نیمرسانا از عناصر گروه V جدول تناوبی عناصر است و یا ترکیب نیمرسانای InGaN و یا AlGaN . جدول III ۲-۲ بعضی از نیمرساناهای عنصری و مرکب دو یا سه تایی را نشان می دهد .

IV - VI	II - VI	III - V	IV - IV	عنصر
PbS	CdS	AlAs	SiC	Si
PbTe	CdSe	GaAs		Ga
	ZnTe	GaN		N
	ZnS	InN		In
		AlGaN		Ge
		InGaN		

جدول ۲-۲- نیمرساناهای عنصری و مرکب

قبل از اختراع ترانزیستور دو قطبی در ۱۹۴۷ نیمرساناهای فقط به عنوان قطعات دو پایانه نظیر صافیها و دیودهای نوری مورد استفاده قرار می گرفتند . در اوایل دهه ۱۹۵۰ ژرمانیوم

مهمترین ماده نیمرسانا بود . مع ذالک ، ثابت شد که ژرمانیوم برای بسیاری از کاربردها مناسب نمی باشد ، زیرا قطعات ژرمانیوم حتی در دماهای پایین روند نشست جریان بالایی را نشان می دهد . از اوایل دهه ۱۹۶۰ به بعد سیلیکون به یک جانشین عملی تبدیل شده است و واقعاً ژرمانیوم را برای ساخت قطعات نیمرسانا از میدان خارج کرد . در حال حاضر مهمترین نیمرسانا تک عنصری سیلیکون است . دلایل عمدۀ استفاده از سیلیکون ، ارزانی تولید ، فراوانی آن در طبیعت و نشت جریان عبوری کمتر از این لایه به لایه های زیر است . همچنین اکسید سیلیکون SiO_2 به عنوان عایق گرمایی و الکتریکی استفاده می شود . همچنین نیمرساناهای برای کاربردهای موج ریز و خواص نوری نیز مورد استفاده قرار می گیرند .

در مقایسه با نیمرساناهای ترکیبی گروه V - III که مطالعات بسیار فراوانی روی آنها صورت گرفته است نیمرساناهای گروه II - IV کمتر مورد توجه قرار گرفته اند . اخیراً به سبب پیشرفت تکنولوژی ساخت دیودهای گسیل کننده نور با طول موج کوتاه تحقیقات بر روی مواد گروه III - V نظیر AlN ، GaN ، InN و یا $\text{In}_{x}\text{Ga}_{1-x}\text{N}$ بطور وسیعی شروع شده است .

یکی از راههای تغییر در ساختار نواری یک نیمرسانا روش آلیاز کردن^(۱) می باشد . با روش آلیاز کردن ساختار نواری قابل تغییر می باشد . در این روش از نیمرساناهای با ساختار بلوری یکسان استفاده می شود . بطور مثال از ترکیب درصد وزنی مشخصی از عنصر In در ترکیب نیمرسانای دوتایی GaN می توان ترکیب سه تایی $\text{In}_{x}\text{Ga}_{1-x}\text{N}$ را بوجود آورده که در آن درصد وزنی عنصر In است که می تواند بطور مثال $0/2$ ، $0/4$ و ... انتخاب گردد .

ویژگی نیمرساناهای جدید $In_x Ga_{1-x} N$ بستگی به درصد وزنی In در ترکیب داشته و وابسته به پارامترهای فیزیکی مواد سازنده آن نظیر GaN , InN دارد که از آنها طبق قانون ویگارد^(۱) ویژگی های ساختاری ترکیبات دوتایی و سه تایی مواد نیمرسانا را می توان بر حسب درصد وزنی عناصر تشکیل دهنده آنها بدست آورد.

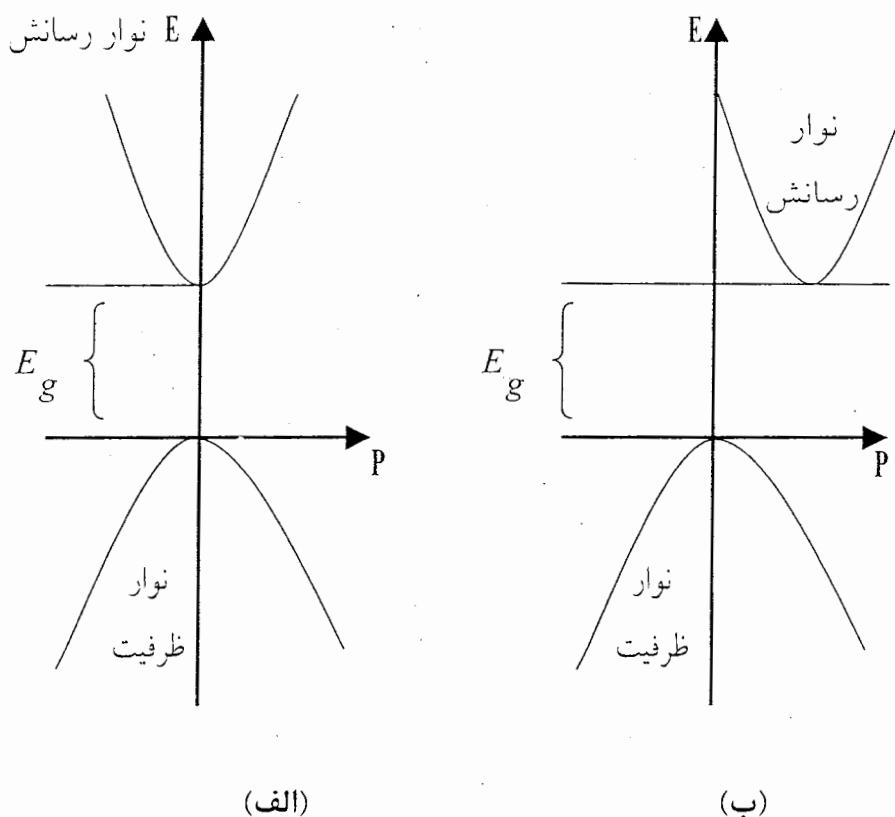
کلیه ویژگی های ساختاری و الکتریکی نیمرساناهای آلیاژی نسبت به ترکیبات سازنده شان تغییر می کند که می توان این ویژگی ها را به کمک قانون ویگارد محاسبه نمود. بطور مثال ثابت شبکه ماده نیمرسانای مرکب $In_x Ga_{1-x} N$ را با استفاده از رابطه زیر می توان بدست آورد.

$$a = x a_A + (1-x) a_B \quad 2-1$$

که در آن x درصد وزنی در ترکیب نیمرسانا بوده و a_A , a_B در اینحالت به ترتیب معرف ثابت شبکه های ترکیبات نیمرسانای GaN و InN است. به طور مشابه می توان گاف انرژی ترکیب موردنظر را با استفاده از رابطه مشابه زیر محاسبه کرد:

$$E_g = x E_g^A + (1-x) E_g^B \quad 2-2$$

ضمناً A, B عناصر تشکیل دهنده نیمرسانای مرکب و همانطور که گفته شد x درصدمولی از عناصر ترکیبی است. قابل ذکر است که هر گاه پایین ترین نقطه نوار رسانش منطبق بر بالاترین نقطه نوار ظرفیت باشد، نیمرسانا مستقیم نامیده می شود دز غیر اینصورت نیمرسانا غیرمستقیم است (شکل ۲-۴).



شکل ۴-۲ - نمودار نوار انرژی

الف نیمرسانای مستقیم ، ب نیمرسانای غیرمستقیم

معمولًاً بالای نوار ظرفیت را تراز مرجع می گیریم و چنان چه پایین ترین کمینه نوار رسانش مستقیماً در تکانه صفر در بالای بیشینه نوار ظرفیت قرار گرفته باشد نیمرسانا گاف نواری مستقیم نامیده می شود و چنانچه پایین ترین کمینه نوار رسانش در تکانه صفر نباشد نیمرسانا گاف نواری غیرمستقیم نامیده می شود.

شکل ۴-۲ نوار انرژی بر حسب تکانه را نشان می دهد شکل ۴-۲-الف نمودار نوار انرژی

یک نیمرسانای مستقیم و شکل ۴-۲ ب نمودار نوار انرژی یک نیمرسانای غیرمستقیم می باشد.

۲-۲- مکانیسم های پراکندگی الکtron^(۱)

برای محاسبه خواص ترابری الکترونی نیمرساناها باید ابتدا مکانیسم های مسهم پراکندگی الکترون را شناسایی کنیم. بنابراین، در این بخش به صورت خلاصه فرآیندهای پراکندگی الکترون به عنوان مثال در ماده GaN را بررسی کرده و فرمول هایی برای محاسبه میزان پراکندگی به عنوان تابعی از انرژی الکترون ارائه می کنیم. از این روابط در محاسبه خواص ترابری هر ماده نیمرسانای دیگری نظیر InGaN و ... نیز می توان استفاده کرد. بطور کلی آهنگ های پراکندگی محاسبه شده در این فصل در محاسبه تحرک پذیری الکترونی که با حل معادله بولتزمن بدست می آیند استفاده خواهد شد. چنین محاسباتی در فصل چهارم که نتایج حل و بحث معادله بولتزمن در خواص ترابری ماده نیمرسانای $N_{18}Ga_{82}$ است، متذکر خواهد شد.

تعریف کلی:

در یک نیمرسانا، فرآیندهای فیزیکی چندی وجود دارند که می توانند باعث پراکندگی الکترون گردند. این فرآیندها بستگی به قدرت میدان الکتریکی و خواص ماده مورد نظر دارد. هنگامی که یک الکترون پراکنده می شود بردار موج الکترون از حالت اولیه k به حالت نهایی k' تبدیل می شود. زمان لازم برای این تبدیل را پارامتر برخورد T_C می نامند. فرض ما بر این است که مدت زمان پراکندگی بسیار کوتاه باشد. ($\tau \approx 0$) برای وارد کردن آهنگ پراکندگی در محاسبات ترابری الکترون عموماً لازم است که فرمول سطح مقطع کلی پراکندگی و وابستگی زاویه ای آن بین حالات k, k' را داشته باشیم. سطح مقطع پراکندگی از حالت k به k' یعنی $s(k', k)$ عموماً بر اساس قاعدة طلایی فرمی محاسبه می شود، بطوریکه داریم [۷]:

$$s(k', k) = \frac{2\pi}{\hbar} \int |<k' | H | k>|^2 G(k', k) \delta[E(k') - E(k) \pm \Delta E] d^3 k' \quad 2-3$$

که در اینجا $|k' | H | k>$ عنصر ماتریسی بین توابع موج قبل و بعد از پراکندگی است، ΔE افزایش (+) یا کاهش (-) انرژی در طی تراپری الکترون بوده و انتگرال گیری روی تمام حالات نهایی انجام می شود که به وسیله تابع دلتای دیراک^(۱) انجام پذیر است.

$G(k, k')$ انتگرال همپوشانی^(۲) بین قسمت های پریودی توابع تناوبی بلوخ حالت های ابتدایی و انتهایی است. برای توابع موج حالت خالص (نوارهای رسانش)، انتگرال همپوشانی دقیقاً برابر با واحد است. وقتی غیر سهموی بودن نوارها را در نظر داشته باشیم انتگرال همپوشانی همیشه کمتر از یک است و معمولاً به صورت تابعی از ضرایب غیر صفر بیان می شود. در این حالت انتگرال همپوشانی به فرم کلی زیر تعریف می شود:

$$G(k, k') = \frac{1}{2} \sum_{\mu\mu'} \left| \int u_{\mu\mu'}^*(r) u_{\mu\mu'}(r) \right|^2 d^3 r \quad 2-4$$

که در آن u تابع موج بین دو حالت نوارهای انرژی است در این حالت طبق نظریه کین^(۳) انتگرال همپوشانی بصورت زیر ساده می شود [۷]:

$$G(k, k') = (a_k a_{k'} + c_k c_{k'} \cos\phi)^2 \quad 2-5$$

که در آن، ϕ زاویه بین بردارهای k, k' است، کمیتهای a_k, c_k توسط کین به صورت زیر محاسبه شده اند:

1-Dirac delta function
2-Overlap integral
3-Kin

$$a_k = \left[\frac{1+\alpha E(k)}{1+2\alpha E(k)} \right]^{1/2}, \quad c_k = \left[\frac{\alpha E(k)}{1+2\alpha E(k)} \right]^{1/2} \quad 2-6$$

بنابراین انتگرال همپوشانی عبارت است از :

$$G(k, k') = \frac{\left[[1+\alpha E(k)]^{1/2} [1+\alpha E'(k)]^{1/2} + \alpha (EE')^{1/2} \cos \phi \right]^2}{(1+2\alpha E)(1+2\alpha E')} \quad 2-7$$

که در اینجا $E' = E(k')$ انرژی الکترون در حالت k' است. وقتی انتگرال همپوشانی معلوم شد می توان آهنگ کلی پراکندگی $R(k)$ را با انتگرال گیری از سطح مقطع پراکندگی $s(k, k')$ در معادله ۲-۳ روی تمام حالات نهایی مجاز به دست آورد، بطوریکه داریم:

$$R(k) = \frac{V}{8\pi^3} \int_0^\infty \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} s(k', k) k'^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi \, dk' \quad 2-8$$

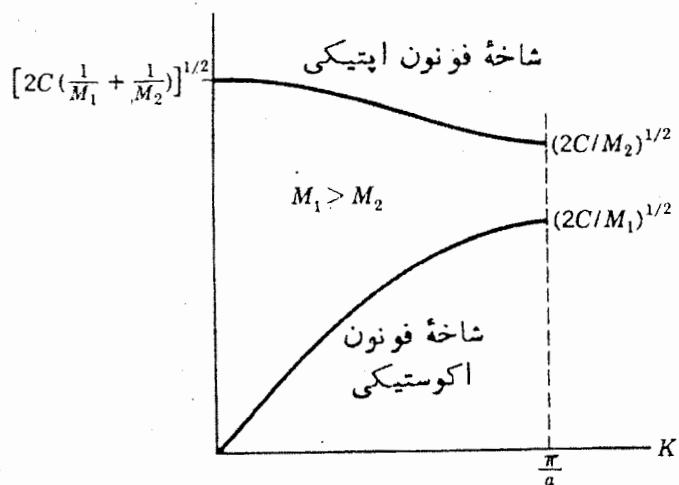
که در اینجا V حجم بلور است.

مکانیسم های پراکندگی را می توان به دو نوع اصلی طبقه بندی کرد. آنهایی که ناشی از ارتعاشات شبکه هستند و پراکندگی از شبکه یا از فونون^(۱) نامیده می شوند، و پراکندگی از نوافع بلوری مانند حضور ناخالصی ها. در زیر رفتار آهنگ پراکندگی را به عنوان تابعی از انرژی بررسی خواهیم نمود.

۲-۳- پراکندگی الکترونی ناشی از ارتعاشات شبکه

پراکندگی از شبکه بر اثر ارتعاش اتم های تشکیل دهنده بلور در اطراف محل های تعادلی آنها رخ می دهد. این ارتعاشات پتانسیل تناوبی وابسته به زمان در نیمرسانا را تغییر می دهد که

نتیجه آن پراکندگی الکترون است. ارتعاشات شبکه را می‌توان کوانتیزه در نظر گرفت و فرآیندهای پراکندگی شبکه را می‌توان به عنوان برهمکنش الکترون‌ها با کوانتوم ارتعاشات شبکه که فونون نامیده می‌شود در نظر گرفت. انرژی فونون‌ها $(q\omega)$ است، که در آن (q) فرکانس ارتعاش بوده و ω بردار موج ارتعاشات شبکه است. پراکندگی الکترون‌ها توسط فونون‌ها بستگی به ماهیت فونون‌ها دارد. بطور کلی فونون‌ها به دو گروه تقسیم می‌شوند و هر گروه شامل دو شاخه است (شکل ۲-۵). برای فونون‌های آکوستیکی، فرکانس ارتعاشات شبکه ω تقریباً به صورت خطی نسبت به a در حوالی مرکزی منطقه بریلوئن افزایش می‌یابد و در مرزهای منطقه به حداقل می‌رسد.



شکل ۲-۵ - شاخه‌های اپتیکی و آکوستیکی رابطه پاشندگی برای یک شبکه خطی دو اتمی.

فرکانس‌های حدی در مرزهای اولین منطقه بریلوئن نشان داده شده‌اند، (ثابت شبکه برابر با a) است) . [۵]

دو شاخه این گروه متناظر با ارتعاشات طولی (LA) و عرضی (TA) هستند. در مورد فونون‌های اپتیکی، چنانچه از شکل مشاهده می‌شود، فرکانس ارتعاشات شبکه در مرکز مناطق

بریلوئن تقریباً ثابت است ولی در مرز منطقه به مقدار کمتری می‌رسد. دو شاخه این گروه نیز متناظر با ارتعاشات طولی (L_0) و عرضی (T_0) هستند.

۱-۳-۲- پراکندگی الکترون در اثر فونون های آکوستیکی^(۱)

ارتعاشات آکوستیک شبکه باعث می‌شوند که اتم‌های مجاور در ساختار تنابی بلور به صورت هم‌فاز ارتعاش کنند. پراکندگی الکترون‌ها توسط فونون‌های آکوستیکی به دو طریق زیر اتفاق می‌افتد.

الف- پراکندگی الکترونها در اثر تغییر شکل شبکه

مدهای مختلف فونون‌های آکوستیکی فضای بین اتم‌ها را تغییر می‌دهند. تغییر در فضای بین اتم‌ها در شبکه بلوری باعث جابجایی لبه‌های نوارهای رسانش در ساختار نواری بلور می‌شود. نتیجه چنین جابجایی‌هایی در لبه‌های نوارهای انرژی باعث بوجود آمدن پتانسیل اغتشاش گری بنام پتانسیل تغییر شکل شبکه^(۲) است که بر حرکت الکترون اثر می‌گذارد و منجر به پراکندگی الکترون‌ها می‌شود. محدوده انرژی در پراکندگی به وسیله فونون‌های آکوستیکی از 0 تا $2\hbar v_k$ است. که در آن v سرعت صوت (چون بقای اندازه حرکت بلوری، تغییر بردار موج فونون را به محدوده 0 تا $2k$ محدود می‌کند) و k بردار موج الکترون است. به طور معمول، مقدار متوسط k در محدوده 10V/cm و سرعت صوت در محیط حدود 10^5 cm/s است. بنابراین $2\hbar v_k$ تقریباً برابر با 1 میلی الکترون ولت است که نسبت به انرژی حرارتی در دمای اندک است. بنابراین، پراکندگی تغییر شکل را می‌توان یک فرآیند الاستیک دانست.

1-Acoustic Phonon

2-Deformation Potential

آهنگ پراکندگی پتانسیل تغییر شکل برای الکترونی با انرژی E در نوار غیر سهموی از قاعده

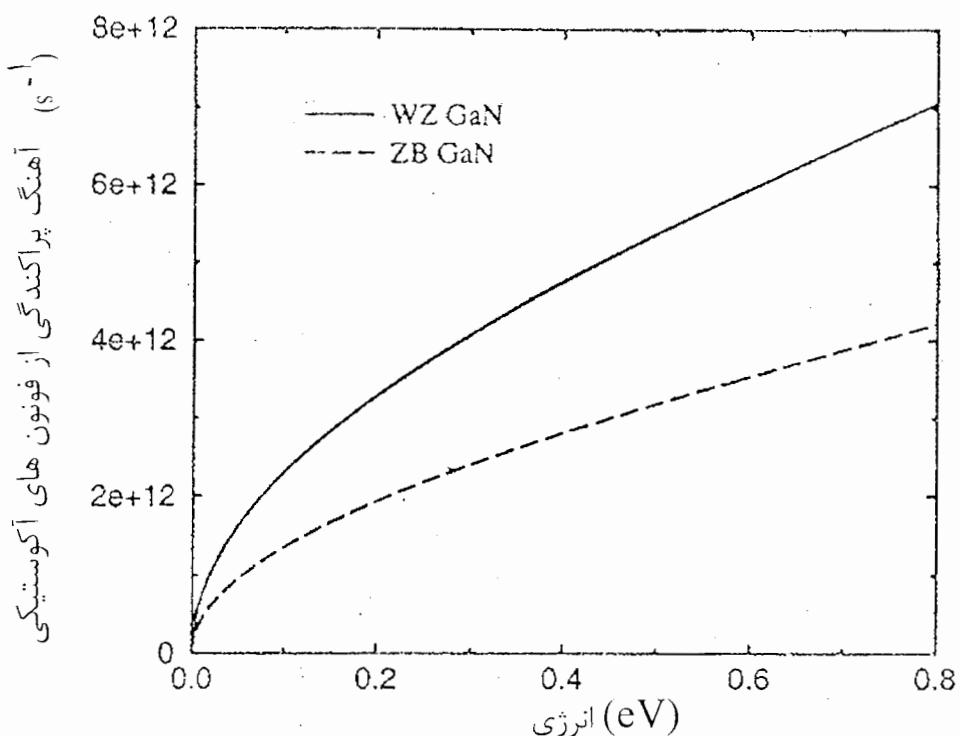
طلایی فرمی بدست می آید ، بطوریکه داریم [۸] :

$$R_{de}(k) = \frac{\sqrt{2}D_{ac}^2 (m_t^* m_I^*)^{1/2} k_B T}{\pi p u^2 \hbar^4} \frac{\sqrt{E(1+\alpha E)}}{(1+2\alpha E)} \left[(1+2\alpha E)^2 + 1/3(\alpha E)^2 \right] \quad ۲-۹$$

که در اینجا D_{ac} پتانسیل تغییر شکل آکوستیکی ، ρ چگالی ماده و α ضریب انحراف

نوارهای انرژی از سهموی بودن ^(۱) است . رابطه فوق نشان می دهد که این پراکندگی با دما

افزایش می یابد .



شکل ۲-۶ - آهنگ پراکندگی فونون های آکوستیکی بر حسب انرژی در دره Γ برای

الکترونهای GaN در ساختارهای زینک بلند و وورتسایت در دمای اتاق [۸]

آهنگ پراکندگی از پتانسیل تغییر شکل شبکه در هر دو نوع ساختار زینک بلند و وورتسایت GaN در شکل ۲-۶ نشان داده شده است.

چنانکه از رابطه ۲-۹ ملاحظه می شود ، وابستگی آهنگ پراکندگی به انرژی به صورت $E^{\frac{3}{4}}$ است . روشن است که در وورتسایت ، آهنگ پراکندگی بالاتر از ساختار زینک بلند است که ناشی از پایین بودن سرعت صوت و بالاتر بودن جرم موثر الکترون در درجه Γ است . همانند سایر مواد III – V این پراکندگی در دماهای بالا مهم ترین مکانیسم پراکندگی است .

ب-پراکندگی الکترونها در اثر پیزوالکتریک^(۱)

نوع دوم پراکندگی الکترون زمانی روی می دهد که جابجایی اتم ها از طریق اثر پیزوالکتریک یک میدان الکتریکی ایجاد نماید . این مسئله در نیمرساناهای مرکب $\text{V}-\text{II}-\text{VI}$ و $\text{III}-\text{V}$ که دارای عدم تقارن بالایی در ساختار بلوری می باشند ، ملاحظه می شود . پراکندگی ناشی از فرآیند پیزو الکتریک ابتدا توسط ریدلی^(۲) بررسی شد . وی پراکندگی الکترون تحت اثر خواص پیزوالکتریسیته بلور را با خاطر انرژی پایین الکترونها الاستیک در نظر گرفته و آهنگ پراکندگی کل الکترونها را می توان با رابطه کلی زیر محاسبه نمود [۴] :

$$R_{\text{PZ}}(k) = \int (1 - \cos \theta) S_{\text{el}}(k, k') d^3 k' \quad 2-10$$

که در آن $S_{\text{el}}(k, k')$ سطح مقطع پراکندگی الکترونها تحت تأثیر پتانسیل موثر اغتشاش

است که بصورت زیر در نظر گرفته می شود :

$$S_{el}(k, k') = \frac{e^2 k_B T P^2}{4\pi \hbar^2 \epsilon_0} \frac{G(k, k')}{|k - k'|^2} \delta[E(k) - E(k')] \quad 2-11$$

در این رابطه P ضریب پیزوالکتریک ماده موردنظر است. با جایگذاری رابطه ۲-۱۱ در ۲-۱۰ آهنگ پراکندگی الکترونها در اثر خواص پیزوالکتریک ماده قابل محاسبه است بطوریکه

داریم :

$$R_{PZ}(k) = \frac{e^2 k_B T P^2}{4\pi \hbar^2 t} \int (1 - \cos \theta) \frac{G(k, k')}{|k, k'|^2} [E(k) - E(k')] d^3 k' \quad 2-12$$

که در آن $d^3 k'$ المان حجم در سیستم مختصات کروی است بطوریکه می توان نوشت :

$$d^3 k' = k'^2 dk' d(\cos \theta') d\phi \quad 2-13$$

برای محاسبه انتگرال ۲-۱۲ بر حسب بردار موج k' کافی است از خواص تابع دلتای دیراک

استفاده کنیم. چنانچه می دانیم می توان نوشت :

$$\delta[E(k) - E(k')] = \frac{\delta(k - k')}{\left| \frac{\partial E(k')}{\partial k'} \right|} \quad 2-14$$

که در آن برای نوارهای انرژی همواره داریم :

$$\frac{\partial E(k')}{\partial k'} = \frac{\hbar^2 k'}{m^* (1 + 2\alpha E')} \quad 2-15$$

بنابراین با در نظر گرفتن انتگرال همپوشانی $G(k, k')$ از معادله ۲-۷ و جایگذاری روابط ۲-۱۳ و ۲-۱۴ و ۲-۱۵ در رابطه ۲-۱۲ و نهایتاً انتگرالگیری از آن، آهنگ پراکندگی الکترونها در

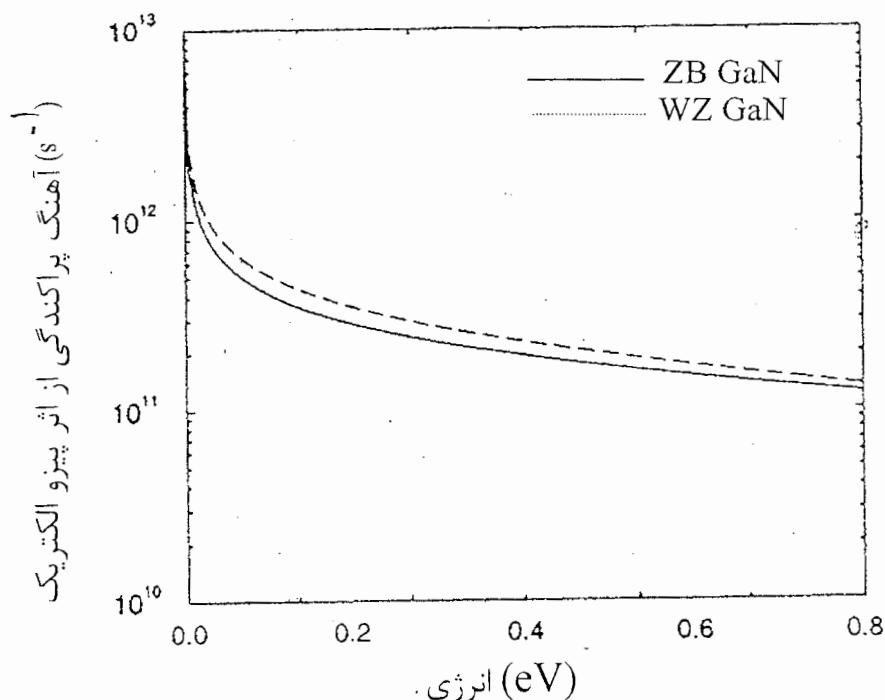
پراکندگی پیزوالکتریک برابر می شود با [۸] :

$$R_{pz}(k) = \frac{\sqrt{m^*} e^2 (k_{av}^2 k_B T)}{4\sqrt{2\pi}\hbar^2 \epsilon_0 \epsilon_s} \gamma^{-\frac{1}{2}} (E)(1+2\alpha E)^{\frac{1}{2}} \times \\ \left\{ \ln\left(1 + \frac{\lambda m^* \gamma(E)}{\hbar^2 q_0^2}\right) - \frac{1}{1 + \hbar^2 q_0^2 / \lambda m^* \gamma(E)} + \left(\frac{\sqrt{2}\alpha E}{1+2\alpha E}\right)^2 \right\} \quad 2-16$$

که در اینجا k_{av} یک ثابت بدون بعد است.

آهنگ پراکندگی ناشی از فرآیند پیزو الکتریک در دو نوع ساختار زینک بلند وورتسایت

در شکل ۲-۷ نشان داده شده است.



شکل ۲-۷ - آهنگ پراکندگی پیزو الکتریک بر حسب انرژی در درجه Γ برای الکترونهای GaN در دو

ساختار زینک بلند و وورتسایت در دمای اتاق [۸]

اگر ثابت پیزو الکتریک هر دو نوع ساختار بلوری را $Cm^{-2}/375$ در نظر بگیریم ، بالاتر بودن آهنگ پراکندگی در ساختار بلوری وورتسایت به علت بالاتر بودن حرم موثر الکترون در این ساختار است .

۲-۳-۲-پراکندگی الکترونها در اثر فونون های اپتیکی ^(۱)

ارتعاشات اپتیکی شبکه باعث می شود اتمهای مجاور در شبکه در فاز مخالف هم به ارتعاش در آیند . بنابراین جابجایی اتمها شبکه در فاز مخالف هم باعث جدایی یون های مثبت و منفی شبکه در دو سوی بلور می گردد . نتیجه چنین جایه جایی بار در شبکه باعث بوجود آمدن اثرات دو قطبی در ساختار بلورین است . لذا عموماً پراکندگی ناشی از فونون اپتیکی را ، پراکندگی الکترونها در اثر اندرکنش آنها با پتانسیل دوقطبی ایجاد شده در بلور نیز می نامند که در زیر به شرح آن می پردازیم .

الف-پراکندگی فونون های اپتیکی قطبی ^(۲)

میدان الکتریکی دو قطبی حاصل از فونون های اپتیکی باعث اندرکنش بین شبکه و الکترون ها می گردد که نتیجه آن پراکندگی الکtron هاست . این نوع پراکندگی مهم ترین مکانیسم پراکندگی د، دمای اتاق در نیمرساناهای گروه V – III مانند GaN و یا ترکیبات دیگر نظیر InGaN است . زیرا در این گروه ترکیبات نیمرسانا انرژی فونون ها بالاست . بطور مثال انرژی فونون های اپتیکی در نیمرسانای GaN که در ساختار وورتسایت متبلور شده باشد در حدود 99meV است که در مقایسه با دیگر ترکیبات نیمرسانا از گروه های V – III و VI – II بسیار بیشتر است . همچنین در اینگونه ترکیبات فونون های اپتیکی تا قبل از رسیدن به چنین

1-Optical Phonons

2-Polar Optical Phonon interaction

انرژی ای، هیچگونه گسیلی از خود نشان نمی دهد و تمامی انرژی کسب شده را صرفاً بصورت ارتعاش فونون اپتیکی در شبکه بلور آزاد می کند. با محاسبه ای مشابه آنچه که در پراکندگی فونون های آکوستیکی انجام شد می توان نشان داد که آهنگ پراکندگی از فونون های اپتیکی برای الکترون هایی با انرژی E که در دره مرکزی Γ قرار دارند از رابطه زیر بدست می آید [۸] :

$$R_{po}(k) = \frac{\sqrt{2m^*} e^2 \omega_{op}}{8\pi\epsilon_0 \hbar} \left(\frac{1}{\epsilon_\infty} - \frac{1}{\epsilon_s} \right) \frac{1+2\alpha E'}{\gamma^\chi(E)} F_o(E, E') \begin{Bmatrix} N_{op} \\ N_{op} + 1 \end{Bmatrix} \quad 2-17$$

که در آن داریم :

$$F_o(E, E') = C^{-1} \left\{ A \ln \left| \frac{\gamma^\chi(E) + \gamma^\chi(E')}{\gamma^\chi(E) - \gamma^\chi(E')} \right| + B \right\}$$

$$A = [2(1+\alpha E)(1+\alpha E') + \alpha(\gamma + \gamma')] \quad 2-18$$

$$B = -2\alpha \gamma^\chi \gamma'^\chi [4(1+\alpha E)(1+\alpha E') + \alpha(\gamma + \gamma')]$$

$$C = 4(1+\alpha E)(1+\alpha E')(1+2\alpha E)(1+2\alpha E')$$

که در آن ϵ_∞ بترتیب ضرایب گذردهی الکتریکی ماده در حد فرکانس های پایین و

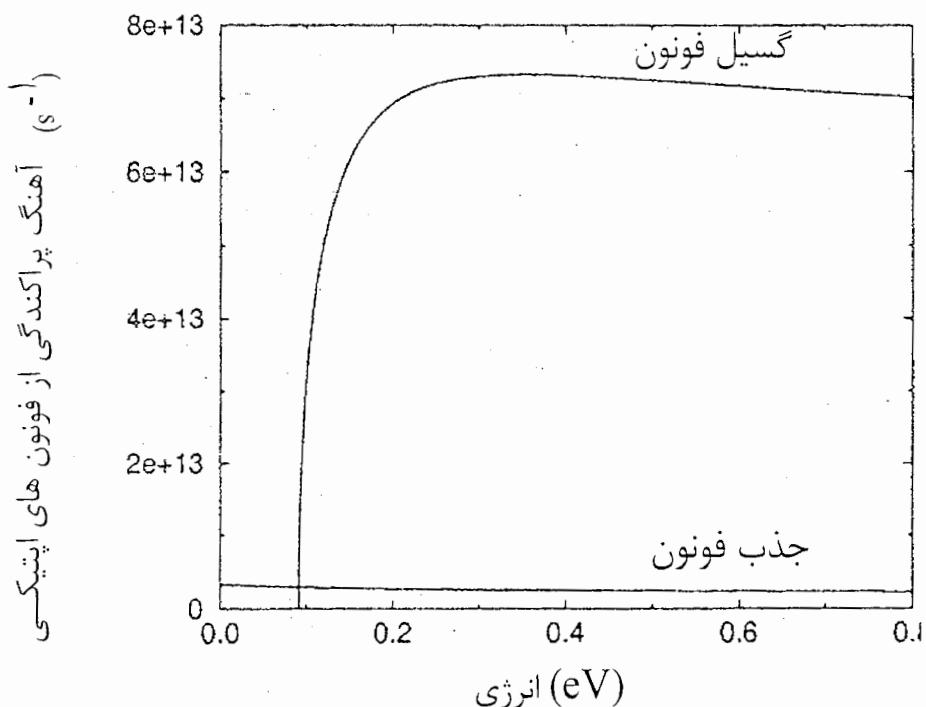
بالاست. N_{op} عدد اشغال فونون است و مقادیر (+) و (-) به ترتیب معرف حالتها جذب و گسیل

فونون است. برای میدان های الکتریکی ضعیف چگالی فونون ها در حد تعادل خواهد بود و تابع

توزیع فونون ها با استفاده از تابع توزیع بوز - اینشتین^(۱) محاسبه می شود بطوریکه داریم :

$$N_{op} = \frac{1}{\exp\left(\frac{\hbar\omega_{op}}{K_B T}\right) - 1} \quad 2-19$$

که در اینجا، ω_{op} انرژی فونون های اپتیکی قطبی است. آهنگ پراکندگی از فونون های اپتیکی برای ساختار وورتسایت GaN بعنوان مثال در دو حالت جذب و گسیل الکترون در شکل ۲-۸ نشان داده شده است.



شکل ۲-۸ - آهنگ پراکندگی فونون های اپتیکی بر حسب انرژی در ذره Γ برای الکترونهای GaN در دو ساختار زینک بلند و وورتسایت در دمای اتاق [۸]

چنانچه ملاحظه می شود، جذب فونون های اپتیکی در هر سطح انرژی صورت می پذیرد ولی گسیل فقط زمانی صورت می پذیرد که انرژی اولیه الکترون از انرژی فونون های اپتیکی (0.0995eV) بالاتر باشد. در انرژی آستانه، آهنگ پراکندگی به حد $7 \times 10^{13} \text{s}^{-1}$ می رسد و بعد به کندی کاهش می یابد. آهنگ جذب فونون های اپتیکی در $2 \times 10^{12} \text{s}^{-1}$ است.

شکل ۲-۸ اهمیت گسیل فونون های اپتیکی در دمای بالا را در خواص ترابری الکترون ها در ساختارهای نیترات دار نظیر GaN ، AlN و InN و یا حتی ترکیبات سه و یا چهارتایی از آنها را نشان می دهد .

۳-۲-۳- پراکندگی از حضور اتم های ناخالصی^(۱)

این نوع پراکندگی در اثر وجود اتم های ناخالصی در نیمرسانا بوجود می آید . جایگزینی یک اتم ناخالصی در یک محل شبکه باعث به هم خوردن نظم پتانسیل تناوبی بلور می گردد . بی نظمی در پتانسیل تناوبی شبکه طبق نظریه اغتشاش در کوانتوم مکانیک ایجاد پتانسیل اغتشاشگر کرده که با محاسبه توابع موج الکترونی در حضور چنین پتانسیلی می توان ویژه حالات انرژی را در این حالت محاسبه کرد .

در هر حال اندرکنش الکترون با چنین پتانسیل اغتشاشگری باعث پراکندگی الکترون خواهد شد . در هر صورت چون عموماً جرم اتم ناخالصی بسیار بیشتر از جرم الکترون است ، لذا پراکندگی از حضور اتم های ناخالصی در بلور ، از نوع الاستیک می باشد .

آنگ پراکندگی الکترونها از اتم های ناخالصی در دماهای پایین بیشتر از دماهای بالاست .

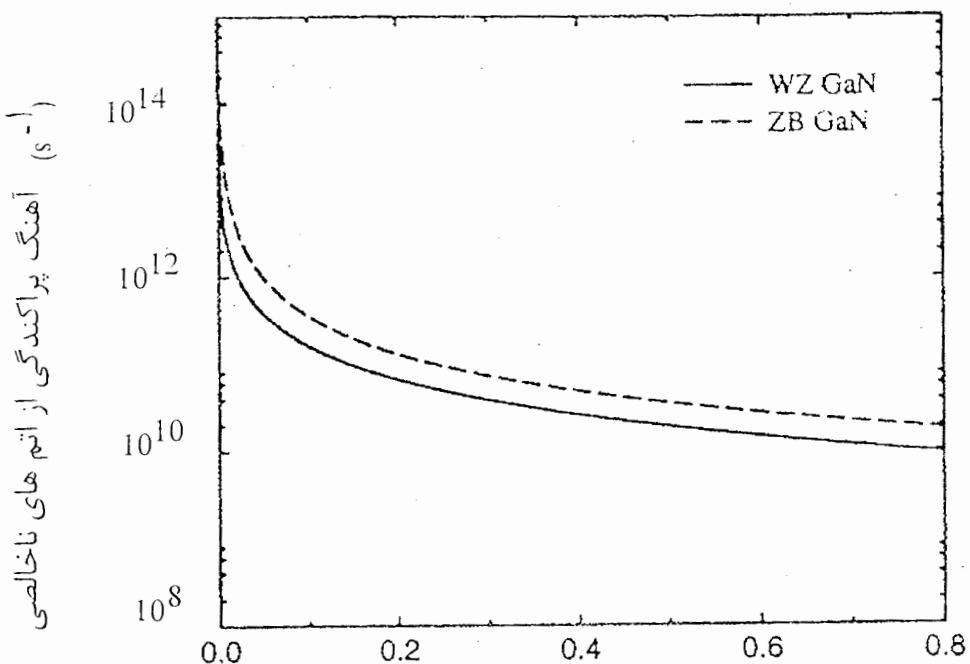
زیرا در دماهای پایین انرژی جنبشی الکترون کم بوده ($T_B^{\frac{3}{2}}$) و لذا الکترون زمان بیشتری در حضور اتم ناخالصی خواهد بود و بنابراین اثر پتانسیل کولنی ناشی از آن را بیشتر احساس خواهد کرد . در فصل نتایج به وضوح اثر حضور اتم های ناخالصی را در پراکندگی الکترونها در دو حد دماهای بالا و پایین در محاسبه تحرک پذیری در ماده $\text{In}_{0.18}\text{Ga}_{0.82}\text{N}$ ملاحظه خواهیم کرد . بسا

محاسبات مشابهی مطابق آنچه در قسمت های قبلی انجام شد می توان ثابت کرد که آهنگ پراکندگی الکترونها در درجه مرکزی Γ ناشی از اتم های ناخالصی از رابطه زیر بدست می آید [۸] :

$$R_{im}(k) = \frac{\lambda \pi n_i e^4}{k_s^2 \hbar q_0} (m_t^* m_l^*) \gamma(E) \frac{1 + 2\alpha F}{1 + 4\sqrt{2}\gamma(E)(m_t^* m_l^*) / \hbar q_0} \quad ۲-۲۰$$

که در آن n_i چگالی اتم های ناخالصی ، q_0 ثابت استثار و k_s ثابت دی الکتریک ماده

است . آهنگ پراکندگی از اتم های ناخالصی برای چگالی اتم های ناخالصی از مرتبه 10^{22} m^{-3} در شکل ۲-۹ برای دو ساختار زینک بلند و وورتسایت GaN بعنوان مثال نشان داده شده است .



شکل ۲-۹ - آهنگ پراکندگی در اثر حضور اتم های ناخالصی بر حسب انرژی در درجه Γ برای الکترون های GaN در دو ساختار زینک بلند و وورتسایت در دمای اتاق [۸]

چنانچه ملاحظه می شود ، آهنگ پراکندگی الکترونها با افزایش انرژی الکترون کاهش می یابد . بنابراین در حد میدان های الکتریکی شدید و برای الکترون های پرانرژی پراکندگی از اتم های ناخالصی اهمیت چندانی در ترابری حامل ها در جامدات بلورین ندارد .

فصل سوم

معادله تراپری بولتزمن

معادله تراابری بولتزمن

خواص تراابری الکترون‌ها در نیمرساناهای با گاف انرژی مستقیم را می‌توان به راحتی با حل مستقیم معادله بولتزمن بدست آورد. از حل معادله بولتزمن می‌توان خواص تراابری حامل‌های بار را در هر جامد بلورین که تحت تأثیر میدان الکتریکی خارجی قرار دارد مشخص کرد. از جمله این خواص تراابری حامل‌ها می‌توان به محاسبه جریان الکتریکی، تحرک پذیری حامل‌های نیمرسانا، ضریب هال و مقاومت الکتریکی اشاره نمود.

معادله بولتزمن در حالت کلی بصورت زیر مطرح می‌شود:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \vec{V} \cdot \vec{\nabla}_r f + \frac{e \vec{E}}{\hbar} \cdot \vec{\nabla}_k f = \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{coll}} \quad 3-1$$

که در آن $f = f(r, k, t)$ تابع توزیع حامل‌های بار مانند الکترون‌ها درون ماده نیمرساناست. با توجه به آنکه الکترون‌ها فرمیون‌اند^(۱) (یعنی ذراتی با عدد اسپینی غیر صحیح) لذا تابع توزیع الکترونها در درون ماده نیمرسانا از آمار فرمی - دیراک^(۲) پیروی کرده که می‌توان آن را بصورت کلی زیر در نظر گرفت:

$$f = f(r, k, t) = \frac{1}{1 + e^{\frac{E - E_f}{k_B T}}} \quad 3-2$$

همچنین در معادله تراابری حامل بولتزمن، \vec{E} شدت میدان الکتریکی اعمال شده بر بلور، \vec{V} سرعت حامل‌های بار در بلور و $\vec{\nabla}_r$ و $\vec{\nabla}_k$ به ترتیب مشتقات تابع توزیع الکترونها نسبت به مختصات فضای حقیقی (\vec{r}) و فضای وارونه بلور (\vec{k}) می‌باشند. در این معادله $\left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{coll}}$ معرف تغییر در تابع توزیع الکترونها تحت تأثیر عوامل مختلف پراکندگی است که در فصل قبل به

1-Fermion

2-Fermi – Dirac distribution function

آنها بطور اجمال اشاره گردید . به منظور سادگی حل و بحث معادله بولتزمن انتخاب شرایط اولیه اعمال شده بر بلور ضروری است . بدین منظور در این پژوهش شرایط را طوری در نظر می گیریم که اولاً ، میدان الکتریکی خارجی اعمال شده بر بلور نیمرسانا یکنواخت بوده و مستقل از زمان باشد و همچنین تراپری الکترونها را در ماده نیمرسانا در حالت پایا بررسی می کنیم . این بدان معناست که تابع توزیع الکترونها در بلور به مختصه مکانی بلور وابسته نیست . تحت چنین شرایطی می توان معادله بولتزمن را به ساده ترین شکل ممکنه در نظر گرفت ، بطوریکه خواهیم

داشت :

$$\frac{e\bar{E}}{\hbar} \cdot \vec{\nabla}_k f = \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{coll}} \quad 3-3$$

در محاسبه تغییر در تابع توزیع الکترونها تحت تأثیر عوامل مختلف پراکندگی باید هر دو حالت گسیل و جذب الکترونها را بین حالات انرژی بالا و پایین در نظر گرفت . زیرا چنانکه می دانیم تحت تأثیر عوامل مختلف پراکندگی ، الکترون ممکن است انرژی جذب نموده و از حالت اولیه k به حالت نهایی k' برانگیخته شود . تحت چنین شرایطی قطعاً تابع توزیع الکترونها پس از جذب انرژی تغییر خواهد کرد . البته باید درنظر داشت که در گذار الکترون از یک حالت انرژی به حالت انرژی بلافاصله یا پایین تر ، اصل طرد پائولی باید برقرار بماند . این بدان معنی است که در برانگیختگی الکترون از حالت اولیه k با تابع توزیع $f(k)$ به حالت برانگیخته k' که در آن تابع توزیع الکترونها $f(k')$ فرض می شود ، وجود یک تراز انرژی خالی برای راه یافتن الکترون به آن تراز ضروری است . بنابراین در اینحالت احتمال پراکندگی الکترونها از یک تراز k به k' با ضریب $[1 - f(k')]_0 f(k)$ قابل بررسی است که در آن $(1 - f(k'))_0$ احتمال خالی بودن یک تراز

انرژی در سطح انرژی بالاتر k' است. چنین ضریبی را نیز در پراکندگی الکترونها از سطح تراز انرژی بالاتر k' به تراز انرژی پایین تر k باید در نظر گرفت، $f(k') [1 - f_0(k)]$. در محاسبه خواص تراپری الکترونها در مواد نیمرسانا عموماً مهمترین عوامل پراکندگی شامل پراکندگی غیرالاستیکی از فونون های اپتیکی است که پراکندگی از آنها را با رابطه $S_{inel}(k, k')$ نمایش می دهیم و پراکندگی الاستیکی نظیر پراکندگی از فونون های آکوستیکی، پراکندگی پیزوالکتریک و پراکندگی ناشی از حضور اتم ها ناخالصی است. پراکندگی از چنین فرآیندهای الاستیکی را با نماد $S_{el}(k, k')$ نمایش می دهیم. لذا در حالت کلی آهنگ پراکندگی کل الکترون ها در ماده نیمرسانا مجموع ایندو پراکندگی بوده بطوریکه می توان نوشت [۹] :

$$S(k, k') = S_{el}(k, k') + S_{inel}(k, k') \quad 3-4$$

به منظور حل و بحث معادله بولتزمن تحت شرایط حالت پایا (معادله ۳-۳)، فرض می کنیم الکترونها در غیاب هر گونه میدان الکتریکی خارجی در پایین ترین درجه نوار رسانش (درجه Γ) با تابع توزیع $f_0(k)$ حضور داشته باشند. با اعمال میدان الکتریکی خارجی تابع توزیع الکترونها از حالت تعادل خارج شده و می توان آن را طبق نظریه اغتشاش در مکانیک کوانتومی بررسی نمود. بدین منظور اگر میدان الکتریکی خارجی اعمالی به بلور نیمرسانا به حد کافی ضعیف باشد. (۱۰ N/m^5)، تغییر در تابع توزیع الکترونها را تا تقریب مرتبه اول می توان بصورت زیر در نظر گرفت :

$$f(k) = f_0(k) + g(k) \cos\theta \quad 3-5$$

که در آن θ زاویه بین بردارهای میدان الکتریکی اعمالی \bar{E} و بردار موج الکtron \bar{k} است. $g(k)$ تغییر جزیی در تابع توزیع الکترونهاست که خود وابسته به اندازه شدت میدان

الکتریکی اعمالی است . با جایگذاری تابع توزیع الکترونها در اینحالت در معادله بولتزمن (معادله ۳-۳) و با در نظر گرفتن آهنگ پراکندگی کل (معادله ۴-۳) پس از ساده سازی خواهیم داشت [۴] :

$$\frac{eE \cos \theta}{\hbar} \frac{\partial f_i}{\partial k} = \left\{ \int \cos \phi g' \left[S'_i (1 - f_i) + S_i f_i \right] d^3 k' \right. \\ \left. - g \cos \phi \int \left[S'_i (1 - f'_i) + S'_i f'_i \right] d^3 k' \right\} \quad 3-6$$

که در آن جمع بر روی تمامی فرآیندهای پراکندگی موجود در شبکه بلور است . همچنین در رابطه فوق به منظور خلاصه نویسی آهنگ پراکندگی در حالت گسیل و جذب را با روابط متقارن ، آهنگ پراکندگی به بردارهای موج حالت اولیه و نهایی (و در نتیجه سطح تراز انرژی حالت های اولیه و نهایی) و زاویه بین ایندو بستگی دارد ، بطوریکه می توان در محاسبه انتگرال رابطه ۳-۶ از اتحاد ریاضی زیر استفاده نمود یعنی [۴] :

$$\int \cos \theta' A(\cos \phi) d^3 k' = \cos \theta \int \cos \phi A(\cos \phi) d^3 k' \quad 3-7$$

که در آن $A(\cos \phi)$ تابعی از $\cos \phi$ بوده و بستگی به زوایای θ', ϕ' ندارد .

بنابراین با استفاده از اتحاد فوق می توان معادله ۳-۶ را بصورت زیر نیز نوشت [۴] :

$$\frac{eE}{\hbar} \frac{\partial f_i}{\partial k} = \left\{ \int \cos \phi g' \left[S'_i (1 - f_i) + S_i f_i \right] d^3 k' \right. \\ \left. - g \int \left[S'_i (1 - f'_i) + S'_i f'_i \right] d^3 k' \right\} \quad 3-8$$

حال همانطور که اشاره کردیم ، چون آهنگهای پراکندگی کل الکترونها هنگام گسیل و جذب الکtron S'_i, S_i شامل هر دو نوع پراکندگی الاستیکی و غیرالاستیکی است ، چنانچه در

رابطه فوق اثر هر دو نوع پراکندگی را از رابطه ۳-۴ در نظر بگیریم ، $g(k)$ که همان تغییر جزئی درتابع توزیع الکترونها در پی برخوردهای متوالی است از رابطه زیر محاسبه خواهد شد [۹].

$$g(k) = \frac{\frac{-eE}{\hbar} \frac{\partial f_0}{\partial k} + \int \cos \phi g'(k) \left[S'_{inel}(1-f_0) + S_{inel} f_0 \right] d^3 k'}{\int (1-\cos \phi) S_{el} d^3 k' + \left[S_{inel}(1-f'_0) + S'_{inel} f'_0 \right] d^3 k'} \quad 3-9$$

در رابطه فوق اولین جمله در مخرج ، مجموع آهنگ های پراکندگی الکtron در اثر کلیه پراکندگی های الاستیکی است .

معادله پیچیده فوق را می توان به روش های عددی مختلف حل نمود . بطور مثال چنانچه آن را به روش عددی برگشت پذیر^(۱) حل و بحث کنیم ، معادله بازگشته اندازه تغییر جزئی تابع توزیع الکترونها در مرتبه n بر حسب مرتبه $1-n$ از رابطه زیر بدست خواهد آمد :

$$g(k)[n] = \frac{\frac{-eE}{\hbar} \frac{\partial f_0}{\partial k} \int \cos \phi g'(k) [n-1] \left[S'_{inel}(1-f_0) + S_{inel} f_0 \right] d^3 k'}{\int (1-\cos \phi) S_{el} d^3 k' + \left[S_{inel}(1-f'_0) + S'_{inel} f'_0 \right] d^3 k'} \quad 3-10$$

برای محاسبه معادله بازگشته فوق کافی است یک برنامه کامپیوتری^(۲) نوشته شود بطوریکه این برنامه مشتمل بر محاسبه کلیه آهنگ های پراکندگی موجود در نمونه بلورین تحت تأثیر میدان های الکتریکی اعمالی باشد . پس با محاسبه رابطه ۳-۱۰ اندازه $g(k)$ یعنی تغییر جزئی در تابع توزیع الکترونها تحت تأثیر میدان الکتریکی خارجی بدست می آید . اگر بتوان $g(k)$ را با دقت بالایی از حل معادله بازگشته ۳-۱۰ محاسبه نمود ، با کمک آن خواهیم توانست

1-Iteration method

2-Computer Program

پارامترهای الکتریکی ماده نیمرسانا نظری تحرک پذیری^(۱) را با کمک رابطه زیر محاسبه کنیم

بطوریکه خواهیم داشت [۱۰] :

$$\mu_e = \frac{\int \vec{V} \cdot \vec{E} f(k) d^3 k}{E^2 \int f(k) d^3 k} \quad ۳-۱۱$$

با جایگذاری مقدار تابع توزیع الکترونها $f(k)$ از رابطه ۳-۵ در رابطه فوق و انتگرالگیری از

آن در سیستم مختصات کروی خواهیم داشت :

$$\mu_e = \frac{\int V E \cos \theta (f + g \cos \theta) k^2 dk \sin \theta d\theta d\varphi}{E^2 \int (f + g \cos \theta) k^2 dk \sin \theta d\varphi} \quad ۳-۱۲$$

مقادیر مشابه را در صورت و مخرج اگر حذف کنیم ، خواهیم داشت :

$$\mu_e = \frac{\int V E f k dk \int \cos \theta \sin \theta d\theta + \int V E g k^2 dk \int \sin \theta \cos^2 \theta d\theta}{E^2 \int f k^2 dk \int \sin \theta d\theta + E^2 \int f k^2 dk \int \cos \theta \sin \theta d\theta} \quad ۳-۱۳$$

در محاسبه انتگرال های فوق از نتایج زیر استفاده می کنیم :

$$\int V E f k^2 dk = ۰ \quad \int \sin \theta \cos^2 \theta d\theta = \frac{2}{3}$$

$$\int \cos \theta \sin \theta d\theta = ۰ \quad \int \sin \theta d\theta = \pi$$

در اینصورت خواهیم داشت :

$$\mu_e = \frac{\int V k^2 \left(\frac{g}{E} \right) dk}{3 \int k^2 f_0 dk} \quad 3-14$$

برای نوار غیر سهموی سرعت گروه به جرم موثر نسبی وابسته بوده و با رابطه زیر بدست

می آید [۱۵] :

$$v(k) = \frac{\hbar k}{m^*} \left(\frac{1}{1+2\alpha E} \right) \quad 3-15$$

با جایگذاری این نتیجه در معادله ۳-۱۴ خواهیم داشت :

$$\mu_e = \frac{\hbar}{3m^* E} \cdot \frac{\int (\frac{1}{1+2\alpha E}) g(k) dk}{\int k^2 f_0(k) dk} \quad 3-16$$

با استفاده از رابطه فوق می توان تحرک پذیری را بر حسب جرم موثر الکترون و اندازه

میدان الکتریکی اعمالی در گستره انرژی الکترونی متفاوت بدست آورد. چنانکه ملاحظه می شود

اگر بتوان $g(k)$ ، تغییر جزئی در تابع توزیع الکترون ها را در اثر پراکندگی با دقت بالایی از معادله

۳-۱۰ محاسبه نمود ، آنگاه تحرک پذیری الکترونی قابل محاسبه است . در فصل آینده نتایج حل

معادله ۳-۱۶ را در محاسبه تحرک پذیری الکترونی بر مواد نیمرسانای GaN ، InN و

$In_{1/2}Ga_{1/2}N$ در حد میدان های الکتریکی ضعیف بررسی خواهیم نکرد و بستگی آن را به دما و

چگالی الکترونی تحقیق خواهیم نمود .

فصل چهارم

بررسی ساختار بلوری و نواری InGaN
و نتایج و کارهای انجام شده

۱-۴- مقدمه

چنانچه در فصول قبلی اشاره شد ، مطالعه خواص ترابری الکترونها در جامدات بلوری نظری نیمرساناها که تحت تأثیر میدان الکتریکی خارجی قرار گرفته اند به مشخصه های ساختار بلوری نیمرسانا نظری نوع شبکه بلوری و ثابت های ساختاری آن نظری ثابت شبکه بستگی دارد . همچنین خواص ترابری الکترونها بستگی مستقیم به خواص ساختار نواری و مکانیزم های مختلف پراکندگی الکترون در این مواد دارد . از مطالعه ساختار نوار رسانش ترکیبات نیمرسانا می توان اطلاعات بسیار مهمی مانند جرم موثر الکترون در دره های مختلف انرژی بدست آورد و چنانکه در فصل های پیش نشان داده شد ، مهمترین پارامتری که ذر تحرک پذیری الکترون و حرکت آن در ساختار بلوری ماده نیمرسانا اهمیت دارد اندازه جرم موثر الکترون است . همچنین از اینگونه مطالعات می توان فاصله بین دره ها و شبکه نوارهای رسانش که امکان ترابری الکترونها را بین دره ها و نوارهای مختلف رسانش فراهم می سازند ، بدست آورد .

هدف از این پژوهش مطالعه تحرک پذیری الکترونها در نیمرساناهای مرکب نیترات دار نظری GaN و InN از ترکیبات مواد نیمرسانای گروه III و V جدول تناوبی و همچنین مقایسه پارامترهای الکتریکی این ترکیبات دوتایی با ترکیب سه تایی (آلیاژ) InGaN با درصد مولی ۰/۲

از ماده نیمرسانای $In_{0.8}Ga_{0.2}N$ درصد از ماده نیمرسانای Ga است .

در محاسبه پارامتر الکتریکی تحرک پذیری این مواد ، وابستگی تحرک پذیری به دما و چگالی اتم های ناخالصی مقایسه خواهد شد تا بتوان تفاوت های رسانایی ترکیبات دو تایی InN و GaN را با ترکیب سه تایی $In_{0.8}Ga_{0.2}N$ بهتر مقایسه نمود و نشان داد که وجود اتم های ناخالصی و آلیاژ نمودن ترکیبات نیمرسانا چه اثری بر خواص الکتریکی و رسانندگی آنها دارد .

برای محاسبه تحرک پذیری الکترونها در این ترکیبات نیمرسانا چنانچه در فصل قبل متذکر شدیم از حل معادله بولتزمن استفاده شده است . بدین منظور با تعریف یک برنامه ساده کامپیوترا سعی در حل معادله ترابری بولتزمن به روش برگشت پذیر شده است ، بطوریکه این برنامه قادر است پس از حل معادله بولتزمن ، تحرک پذیری الکترونها را در ماده موردنظر در حد میدان های الکتریکی ضعیف محاسبه کند . بدین منظور اثر پراکندگی از فونون های اپتیکی و آکوستیکی ، پراکندگی از خاصیت پیزوالکتریک و پراکندگی از اتم های ناخالصی در نظر گرفته شده است که نتایج حاصله از آن برای ترکیب سه تایی $In_{0.18}Ga_{0.82}N$ در ادامه این فصل ارائه خواهد شد . همچنین به منظور آشنایی با برنامه طراحی شده در آخر این پژوهه خلاصه ای از آن آورده شده است .

به منظور ارائه نتایج و کارهای انجام پذیرفته در این پژوهش ، این فصل به قسمت های زیر تقسیم شده است . در بخش اول ابتدا با توجه به آنکه ترکیبات دو و سه تایی نیترات دار نظری عوموماً در ساختار بلوری زینک بلند^(۱) و وورتسایت^(۲) متلبلور می شوند ، مروری خلاصه بر مشخصات فیزیکی ساختارهای بلوری این ترکیبات انجام خواهد شد .

در بخش دوم با توجه به اهمیت ساختار نواری ترکیبات نیمرسانا در اندازه گیری پارامترهای الکتریکی درباره ساختار نواری این ترکیبات و پارامترهای مربوطه به آن برای هر ترکیب صحبت خواهیم کرد . سپس در بخش سوم ، آهنگ های پراکندگی از عوامل مختلفی چون فونون های آکوستیکی ، فونون های اپتیکی ، اثر پیزوالکتریک و اتم های ناخالصی را برای ترکیب نیمرسانانی

$\text{In}_{0.2} \text{Ga}_{0.8} \text{N}$ بدست آورده و آنرا با آهنگ پراکندگی برای ترکیب نیمرسانای GaN که در فصل

دوم انجام شده است مقایسه خواهیم نمود.

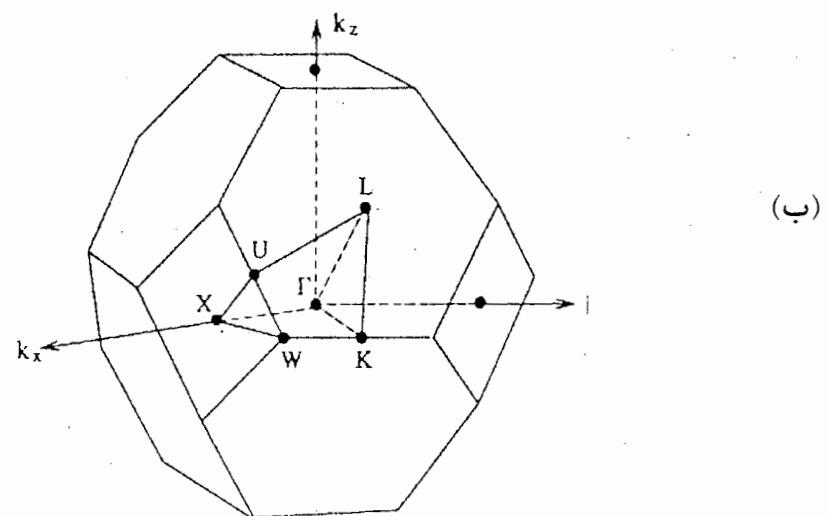
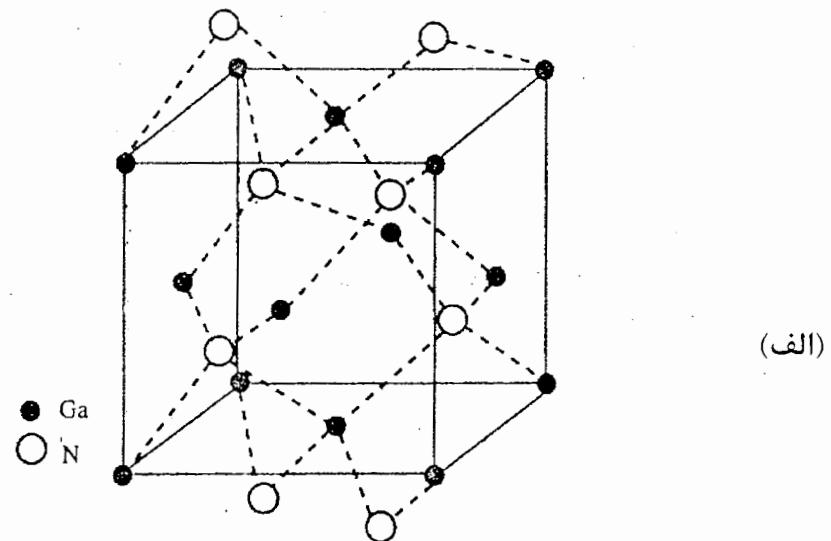
نهایتاً در بخش چهارم با حل معادله بولتزمن به روش برگشت پذیر، تحرک پذیری ترکیب نیمرسانای $\text{In}_{0.2} \text{Ga}_{0.8} \text{N}$ را بصورت توابعی از دما و چگالی اتم های ناخالصی محاسبه نموده و آن را با ترکیبات نیمرسانای InN و GaN مقایسه خواهیم نمود.

۴-۲- ساختار بلوری ترکیبات نیمرسانای InN ، GaN و $\text{In}_{0.2} \text{Ga}_{0.8} \text{N}$

ترکیبات نیمرسانای InN ، GaN عموماً در ساختار بلوری وورتسایت و زینک بلند متبلور می شوند. هر چند که رشد در ساختار بلوری وورتسایت شایع ترین روش رشد این ترکیبات است ولی می توان تحت شرایط خاص و روش های رشد بلور ویژه این ترکیبات را در ساختار مکعبی زینک بلند رشد داد. به هر حال چنانکه می دانیم ویژگی های ساختاری اینگونه شبکه های بلوری نظیر ثابت های شبکه، نوع شبکه بلوری، تقارن های شبکه ای، تعداد همسایه های اول و ... کاملاً با یکدیگر متفاوت است.

به عنوان معرفی ساختار بلوری ترکیب نیمرسانای GaN در ساختار زینک بلند در شکل

(۱-۴ - الف) نشان داده شده است.



شکل ۱-۴-الف - ساختار بلوری زینک بلند نیمرسانای GaN

۱-۴-ب - اولین منطقه بریلوئن بلوری زینک بلند همراه با نقاط و راستاهای اصلی تقارن

همچنانکه از شکل ملاحظه می شود ، ساختار بلوری زینک بلند از دو شبکه مکعبی fcc^(۱) که در طول قطر اصلی مکعب به اندازه $\frac{1}{4}$ قطر اصلی در یکدیگر فرو رفته اند تشکیل شده است . در این ساختار اتم های Ga بر روی یکی از شبکه های مکعبی fcc و اتم های N بر روی شبکه مکعبی fcc دیگر قرار گرفته اند . بنابراین هر اتم گالیم یا ازت توسط چهار اتم از نوع مخالف (همسايۀ اول) احاطه شده است . سلول واحد اينگونه ساختار نواری یک چهار وجهی است بطور يکه بردارهای اولیۀ اين سلول واحد بر حسب ثابت شبکه a در سیستم مختصات دکارتی عبارتند از :

$$\vec{a} = \left(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right) a$$

$$\vec{b} = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2} \right) a$$

۴ - ۱

$$\vec{c} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0 \right) a$$

همچنین شکل ۴-۱ ب اولین منطقه بریلوئن برای ساختار زینک بلند GaN نشان داده شده است . چنانکه ملاحظه می شود ، اولین منطقه بریلوئن یک چهارده وجهی به حجم $\frac{2\pi}{a^3}$ است . این چهارده وجهی از شش مربع که بر جهت بلوری <100> عمود است و هشت شش گوشه که بر جهت بلوری <111> عمود است ، تشکیل شده است . در این شکل همچنین نقاط با تقارن بالای Γ , X, L, نشان داده شده است . که در آن Γ مرکز منطقه بریلوئن است ، یعنی جایی که تمامی الکترونها در غیاب هر گونه میدان الکتریکی اعمالی و حتی در حضور میدان های الکتریکی ضعیف قرار دارند .

X, L در واقع مراکز مربع ها و شش گوشه ها هستند. همانگونه که در بخش بعد نشان خواهیم داد این نقاط معرف دره های بالاتر در نوار رسانش این بلور می باشند و الکترونها فقط هنگامی می توانند در این دره ها وجود داشته باشند که انرژی کافی را برای گسیل از دره مرکزی Γ به دره های بالاتر X, L کسب کرده باشند که این امر فقط در حد میدان های الکتریکی قوی رخ خواهد داد.

بطور مشابه چنانچه بجای تمامی اتم های گالیم در شکل ۴-۱-الف اتم های ایندیم قرار گیرد این شکل معرف ساختار بلوری ترکیب نیمرسانای InN خواهد بود و اگر بجای برخی اتم های گالیم در شکل ۴-۱-الف اتم های ایندیم قرار گیرد، ساختار بلوری InGaN نتیجه خواهد شد.

ساختار بلوری وورتسایت در مورد ترکیب نیمرسانای GaN در شکل ۴-۲ - الف نشان داده شده است. شبکه بلوری وورتسایت در واقع از دو شبکه شش گوشی به هم پکیده^(۱) (HCP) که در امتداد ثابت شبکه C به اندازه ثابت $\frac{3}{8}a$ جایجا شده اند تشکیل شده است. فاصله بین اتم های واقع در صفحات افقی با ثابت شبکه a نشان داده می شود، بطوريکه در هر ساختار بلوری وورتسایت نسبت $\frac{c}{a}$ همواره مقدار ثابت ۱/۶۳ را دارد.

سلول واحد اينگونه ساختار نواری به شکل منشور است بطوريکه بردارهای اولیه اين سلول واحد بر حسب ثابت های شبکه ای a, c در سیستم مختصات کارتزین عبارتند از :

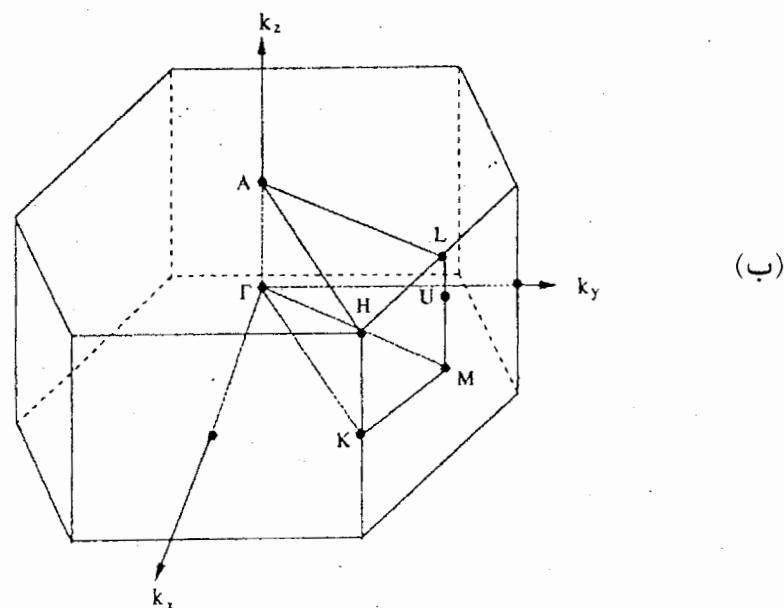
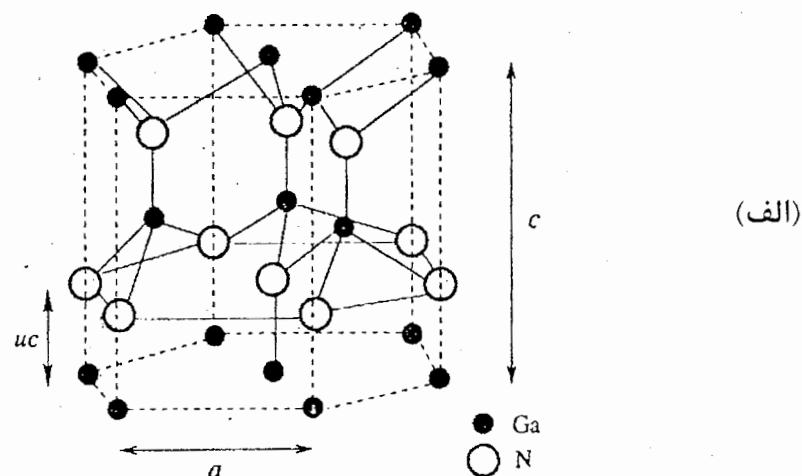
$$\vec{a} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0 \right) a$$

$$\vec{b} = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, 0, \frac{1}{2} \right) a \quad 4-2$$

$$\vec{c} = (0, 0, \frac{c}{a}) a$$

همچنین در شکل ۲-۴-ب اولین منطقه بریلوئن ساختار بلوری و ورتسایت نشان داده شده

است.



شکل ۲-۴-الف - ساختار بلوری و ورتسایت نیمرسانای GaN

ب - اولین منطقه بریلوئن بلوری و ورتسایت همراه با نقاط و راستاهای اصلی تقارن

چنانکه ملاحظه می شود . اولین منطقه بریلوئن یک منشور شش وجهی است که دارای

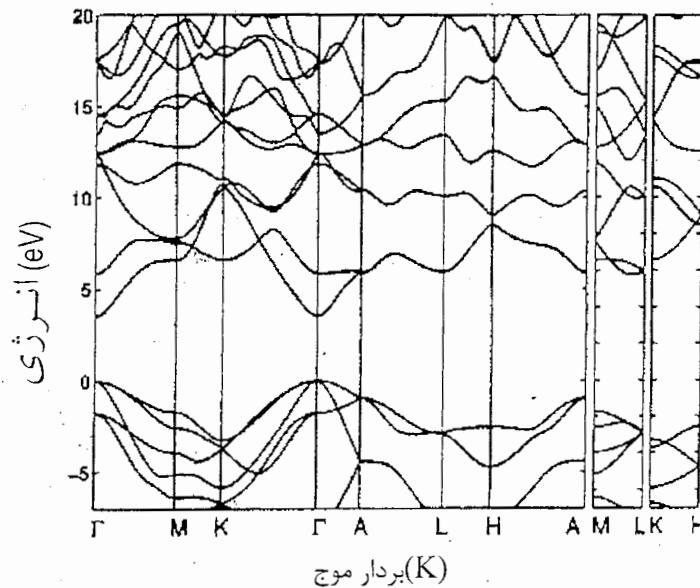
$$\text{حجمی برابر } \frac{2}{\sqrt{3}} \frac{(\pi)^3}{a^2 c} \text{ است . در این شکل همچنین } \Gamma \text{ مرکز منطقه بریلوئن (پایین ترین دره }$$

نوار رسانش) و دیگر نقاط با تقارن بالا نظیر M , K , L نشان داده شده است که معرف دیگر دره های نوار رسانش است .

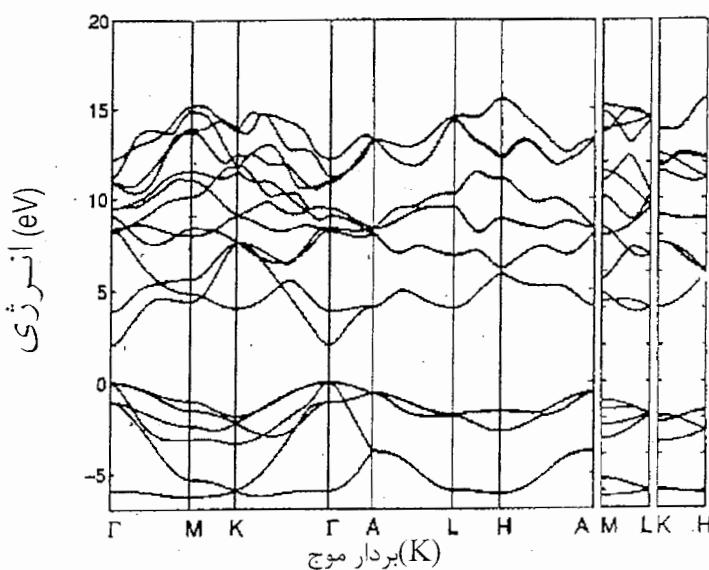
مانند ساختار بلوری زینک بلند ، اگر بجای تمامی اتمهای گالیم در شکل ۴-۲-الف اتم های ایندیم قرار گیرد ، این شکل معرف ساختار بلوری InN خواهد بود و اگر بجای برخی اتم های گالیم اتم های ایندیم قرار گیرد ، ساختار بلوری InGaN نتیجه خواهد شد .

۴-۳-ساختار نواری ترکیبات نیمرسانای In_{0.12}Ga_{0.88} , InN , GaN و N_{0.18}

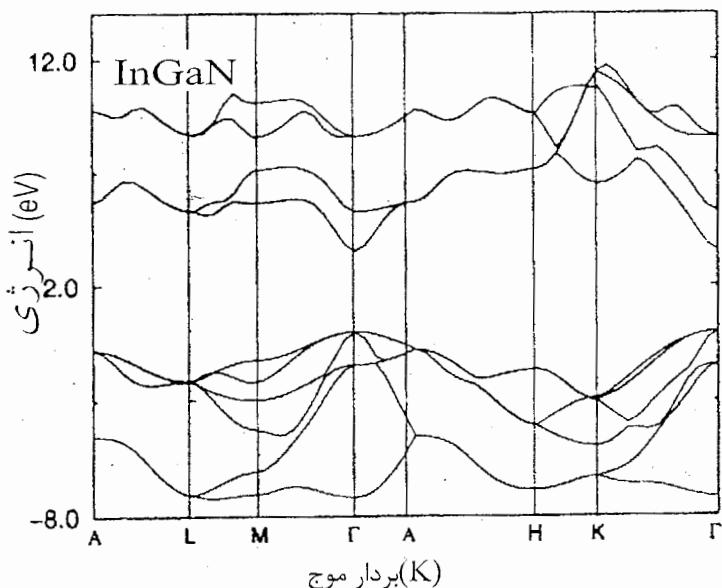
خواص الکتریکی و رسانندگی الکترونها در هر ماده نیمرسانایی به ساختار نواری و پارامترهای وابسته به آن بستگی دارد . چنانچه در فصل اول اشاره شد روش های متعددی برای محاسبه ساختار نواری و تغییرات نوارهای انرژی بر حسب بردار موج شبکه وارون در هر ساختار بلورین وجود دارد . یکی از این روش ها ، روش شبه پتانسیل بود که با جایگزینی پتانسیل واقعی بلور با یک پتانسیلی که در ناحیه مغزهای یونی رفتار نسبتاً آرامتری را نشان می دهد می توان تغییرات نوارهای انرژی را محاسبه نمود . اگر از محاسبات ساختار نواری ترکیبات نیمرسانای In_{0.12}Ga_{0.88} , InN , GaN و N_{0.18} که به روش شبه پتانسیل انجام شده استفاده کنیم [1] ، می توان نمودار ساختار نواری این ترکیبات را در ساختار بلوری وورتسایت در امتداد محورهای با تقارن بالا در طول مناطق بریلوئن در اشکال ۴-۳ ، ۴-۴ و ۴-۵ ملاحظه نمود .



شکل ۴-۳- ساختار نواری نیمرسانای GaN در ساختار بلوری وورتسایت در امتداد محورهای با تقارن بالا در طول مناطق بریلوئن بر اساس مدل شبیه پتانسیل [11]



شکل ۴-۴- ساختار نواری نیمرسانای InN در ساختار بلوری وورتسایت در امتداد محورهای با تقارن بالا در طول مناطق بریلوئن بر اساس مدل شبیه پتانسیل [11]



شکل ۴-۵- ساختار نواری نیمرسانای $In_{1/8}Ga_{7/8}N$ ر ساختار بلوری وورتسایت در امتداد محورهای

با تقارن بالا در طول مناطق بریلوئن بر اساس مدل شبیه پتانسیل [۲۰]

مقایسه ای از ساختار نواری این ترکیبات نشان می دهد که هر سه ترکیب ، نیمرساناهایی با گاف انرژی مستقیم می باشند ، (زیرا پایین ترین لبه دره مرکزی Γ از نوار رسانش بر بالاترین لبه گله نوار ظرفیت منطبق است) هر چند که اندازه گاف انرژی این سه ترکیب با یکدیگر متفاوت است .

همچنین مقایسه ای از ساختار نواری این ترکیبات نشان می دهد که اولاً فاصله دره های انرژی این ترکیبات با یکدیگر یکسان نبوده و ثانیاً انحنای نوارهای انرژی که منجر به تغییر جرم موثر الکترون در هر دره و نوار می شود با یکدیگر فرق می کند این تفاوت باعث تغییرات خواص

$$m^* = \frac{\hbar^2}{\partial^2 E / \partial k^2}$$

تراپری الکترونها در این ترکیبات می شود (

هدف از این پژوهش محاسبه خواص رسانندگی الکتریکی این ترکیبات در حد میدان های الکتریکی ضعیف ($E < 10^5 \text{ N/m}$) است. لذا فرض می شود که الکترونها در طی فرآیندهای ترابری صرفاً در درجه مرکزی نوار رسانش (Γ) قرار داشته باشند. بنابراین در مطالعه حاضر فقط انحنای درجه مرکزی و جرم مؤثر الکترون در آن دارای اهمیت است. اما اگر هدف بررسی ترابری الکترونها در حد میدان های الکتریکی قوی ($E > 10^5 \text{ N/m}$) باشد، جرم مؤثر الکترون در دیگر درهای نوار رسانش نظیر دره K , M , ... انحنای این نوارها و همچنین فواصل آنها از یکدیگر در محاسبه خواص رسانندگی الکتریکی حائز اهمیت خواهد بود.

به هر حال همانگونه که اشاره شد در این بررسی ترابری الکترونها در درجه مرکزی Γ منظور شده است. بطوریکه رابطه بین انرژی و بردار موج K با دز نظر گرفتن اثرات انحراف از سهموی بودن نوار Γ بصورت زیر فرض شده است [۸]:

$$E(1 + \alpha E) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \quad 4-3$$

که در آن m^* جرم مؤثر الکترون در درجه Γ و α ضریب انحراف از سهموی بودن درجه Γ است که مقدار آن به گاف انرژی و جرم مؤثر الکترون بستگی دارد بطوریکه داریم [۸]:

$$\alpha = \frac{1}{E_g} \left(1 - \frac{m^*}{m_0} \right)^2 \quad 4-4$$

که در آن m جرم الکترون آزاد است.

در جدول ۴-۱ پارامترهای ساختار نواری ترکیبات نیمرسانی InN , GaN و $\text{In}_{x/2}\text{Ga}_{1-x/2}\text{N}$ که در محاسبه خواص ترابری الکترونها در این پژوهش از آنها استفاده شده است با یکدیگر مقایسه شده است.

ترکیب	گاف انرژی E_g (eV)	جرم موثر الکترون m^*/m	ضریب انحراف درجه Γ α (eV) ⁻¹
GaN	۳/۳۸	۰/۲	۰/۱۸۹
InN	۱/۸۹	۰/۱۱	۰/۱۳۵
$\text{In}_{\frac{1}{2}} \text{Ga}_{\frac{1}{8}} \text{N}$	۲/۸۸	۰/۱۷	۰/۱۸۸

جدول ۴-۱- مشخصات پارامترهای نواری برای درجه مرکزی Γ در ترکیبات نیمرسانای GaN، InN و $\text{In}_{\frac{1}{2}} \text{Ga}_{\frac{1}{8}} \text{N}$ [۱۲ و ۱۳]

۴-۴- محاسبه آهنگ پراکندگی در ترکیب نیمرسانای $\text{In}_{\frac{1}{2}} \text{Ga}_{\frac{1}{8}} \text{N}$

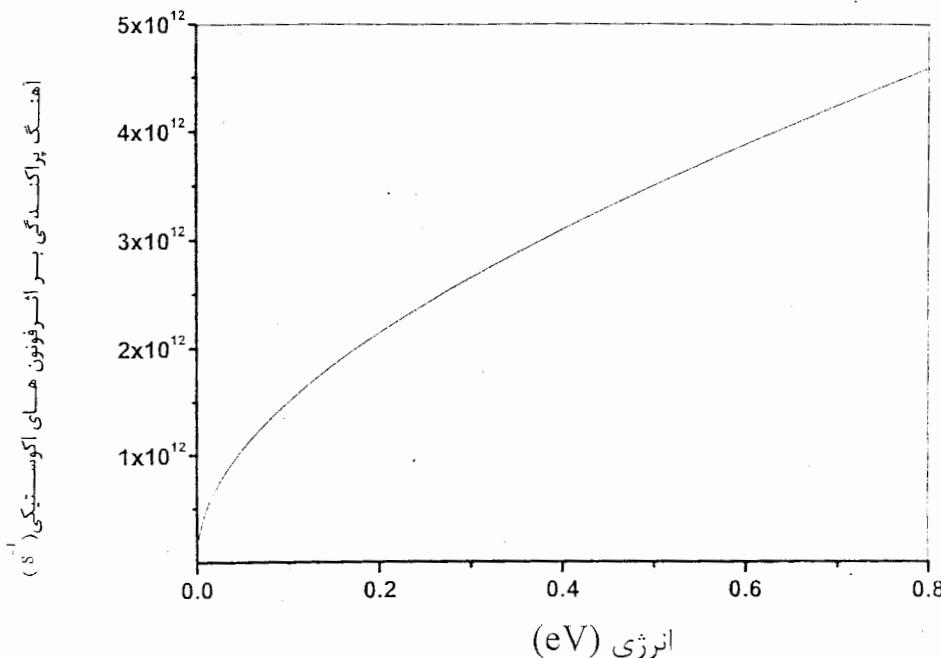
یکی از مهمترین عوامل محدود کننده رسانندگی الکتریکی ترکیبات نیمرسانا اندازه آهنگ پراکندگی الکترونها هنگام اعمال میدان الکتریکی خارجی است. چنانکه در فصل دوم بطور اجمال بحث شد، از مهمترین عوامل پراکندگی الکترونها می‌توان به پراکندگی ناشی از فونون ها (فونون های اپتیکی و آکوستیکی) و پراکندگی ناشی از عیوب شبکه بلوری مانند حضور اتم های ناخالصی اشاره نمود. همانطور که در فصل دوم بررسی شد، آهنگ پراکندگی به سطح مقطع پراکندگی الکترونها بین حالات انرژی متفاوت (s, s') و زاویه بین برخورد الکترونها با عوامل گوناگون بستگی دارد، و چنانکه ملاحظه گردید آهنگ پراکندگی از این عوامل با استفاده از قاعده طلابی فرمی قابل محاسبه بود. در هر مورد رابطه کلی آهنگ پراکندگی بر حسب تابعی از انرژی الکترون، جرم موثر آن و دیگر پارامترهای الکتریکی و ساختاری ماده نیمرسانا بیان شده است. در این قسمت آهنگ های پراکندگی ناشی از فونون های آکوستیکی، فونون های اپتیکی، اتم های ناخالصی و اثر پیزوالکتریک در ترکیب نیمرسانای $\text{In}_{\frac{1}{2}} \text{Ga}_{\frac{1}{8}} \text{N}$ بر حسب تابعی از انرژی

الکترونها نشان داده شده است . پارامترهای ساختاری و الکتریکی استفاده شده در محاسبه آهنگ های پراکندگی برای ترکیب نیمرسانای $In_{0.18}Ga_{0.82}N$ در مقایسه با دیگر ترکیبات InN و GaN در جدول ۴-۲ نشان داده شده است .

پارامتر	GaN	InN	$In_{0.18}Ga_{0.82}N$
چگالی (m/s ²)	۶۱۰۰	۶۸۱۰	۶۲۴۲
ثابت دی الکتریک در فرکانس کم	۱۰/۴	۱۵/۳	۱۱/۳۸
ثابت دی الکتریک در فرکانس بالا	۵/۴۷	۸/۴	۶/۵۶
انرژی فونون های اپتیکی (meV) _{op}	۹۱	۸۹	۹۰
ثابت پیزوالکتریک (cm ^{-۲})	۰/۵	۰/۳	۰/۴۶
ثابت پتانسیل آکوستیکی (eV)	۹/۲	۸/۵	۹/۰۶
ثابت شبکه (A°)	۴/۵	۴/۹۸	۴/۵۹
سرعت صوت (m/s)	5×10^3	5×10^3	5×10^3

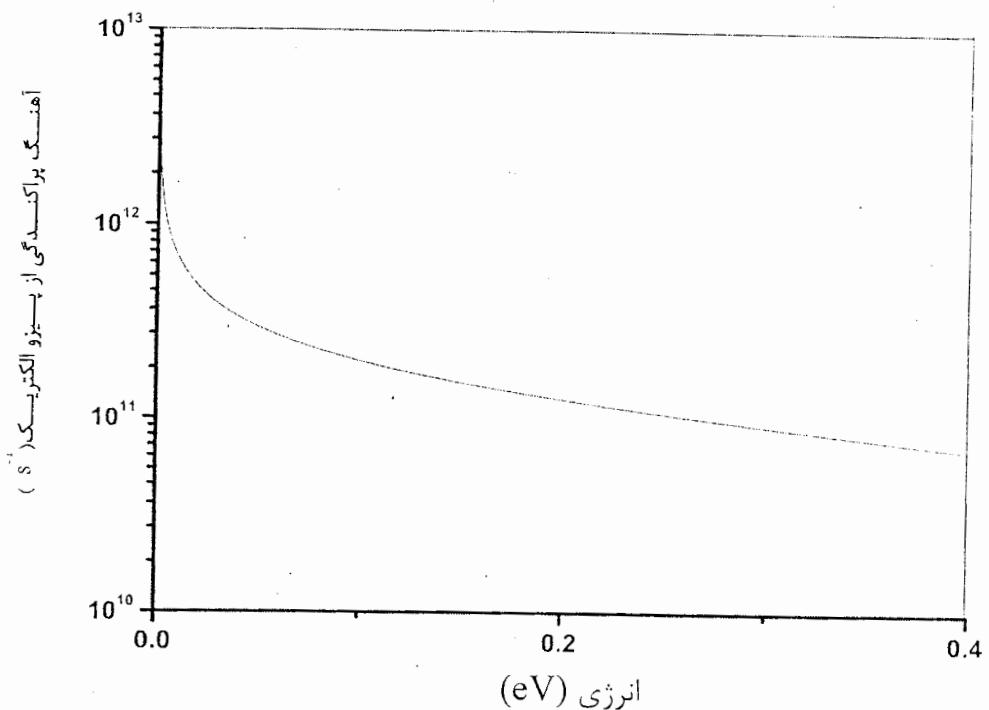
جدول ۴-۲ - پارامترهای فیزیکی مربوط به سه ترکیب نیمرسانای GaN و InN و $In_{0.18}Ga_{0.82}N$

در ساختار بلوری وورتسایت در دمای اتفاق [۱۳ و ۱۴]

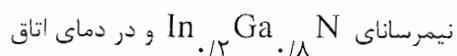


شکل ۴-۶- آهنگ پراکندگی الکترونها در درجه مرکزی Γ از فونون های آکوستیکی را بر حسب تابعی از انرژی برای نیمرسانای مرکب $In_{1/8}Ga_{7/8}N$ در دمای اتاق

شکل ۴-۶ آهنگ پراکندگی الکترونها در درجه مرکزی Γ از فونون های آکوستیکی را بر حسب تابعی از انرژی برای نیمرسانای مرکب $In_{1/8}Ga_{7/8}N$ نشان می دهد. چنانکه ملاحظه می شود با افزایش انرژی الکترون ها تحت تأثیر میدان الکتریکی خارجی آهنگ پراکندگی الکترونها افزایش می یابد. بطوریکه در دمای اتاق و در انرژی الکترونی $eV = 0.8$ آهنگ پراکندگی الکترونها حدوداً به $10^{12} \times 4$ برحورد در هر ثانیه افزایش می یابد، تغییر آهنگ پراکندگی الکترونها از فونون های آکوستیکی در دماهای متفاوت نشان می دهد که در دماهای بالا اثر پراکندگی الکترونها از فونون های آکوستیکی از اهمیت بیشتری برخوردار است. همچنانکه آنرا در محاسبه حرکت پذیری الکترونها بر حسب تابعی از دما برای رسانندگی الکتریکی نیمرسانای $In_{1/8}Ga_{7/8}N$ مشاهده خواهیم نمود.



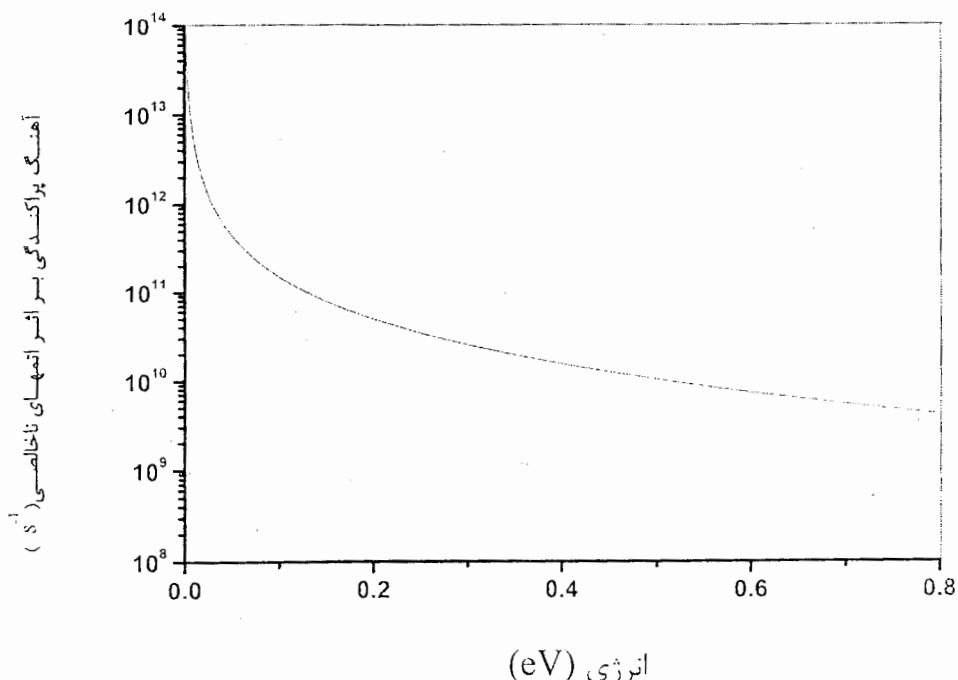
شکل ۴-۷ - آهنگ پراکندگی الکترونها مموج در دره مرکزی Γ - ناشی از اثر پیزوالکتریک در



شکل ۴-۷ آهنگ پراکندگی الکترونها مموج در دره مرکزی Γ را ناشی از اثر پیزوالکتریک در نیمرسانی $\text{In}_{0.8} \text{Ga}_{0.2} \text{N}$ و در دمای اتاق نشان می دهد . با توجه به آنکه

آهنگ پراکندگی الکترونها در اثر خاصیت پیزوالکتریک با انرژی بصورت تابع $E^{-1/2}$ کاهش می یابد ، ملاحظه می شود که با افزایش انرژی الکترونها از صفر به 0.4 eV ، آهنگ پراکندگی الکترونها بطور خیلی سریع از مقدار ماکریمم 2×10^{12} برخورد در هر ثانیه به کمتر از ۱۱ بروخورد در هر ثانیه کاهش می یابد . لذا می توان نتیجه گرفت که پراکندگی از اثر پیزوالکتریک فقط در حد انرژی های الکترونی ضعیف دارای اهمیت است و در حد میدان های الکتریکی قوی که در آن انرژی الکترونها بالاست اثر قابل توجهی در پراکندگی الکترونها ندارد .

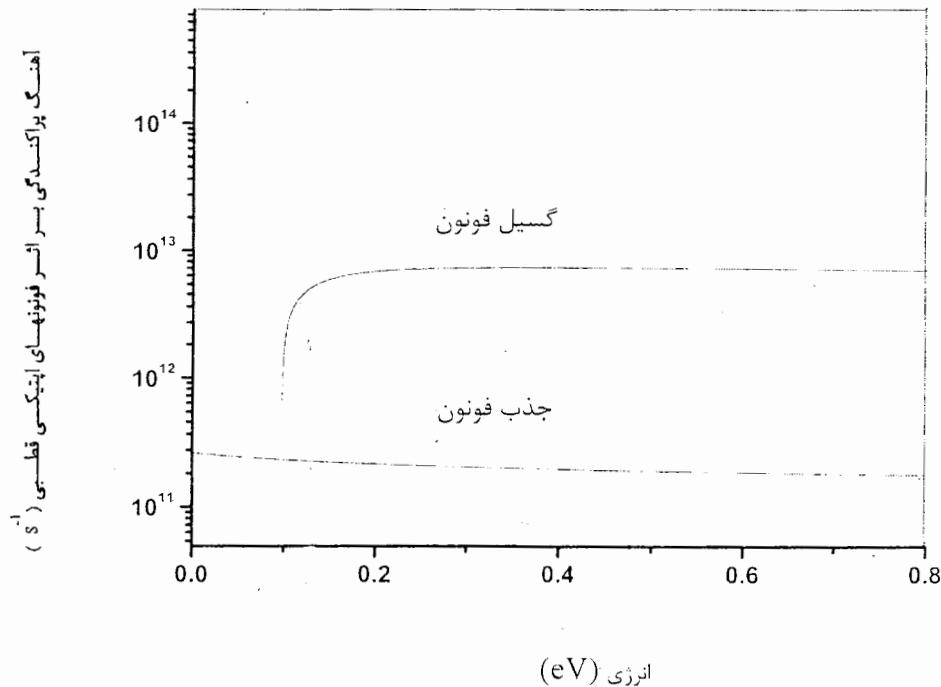
پیزوالکتریک فقط در حد انرژی های الکترونی ضعیف دارای اهمیت است و در حد میدان های الکتریکی قوی که در آن انرژی الکترونها بالاست اثر قابل توجهی در پراکندگی الکترونها ندارد . از مقایسه آهنگ پراکندگی پیزوالکتریک در دو ترکیب نیمرسانای GaN نشان داده شده در فصل دوم و آهنگ پراکندگی آن در ترکیب نیمرسانای $In_{0.8}Ga_{0.2}N$ (شکل ۴-۷) ملاحظه می گردد که آهنگ پراکندگی الکترونها از اثر پیزوالکتریسیته در دمای اتاق و در حد انرژی های پایین در ماده GaN بیشتر از $In_{0.8}Ga_{0.2}N$ است . بالاتر بودن آهنگ پراکندگی پیزوالکتریسیته در $In_{0.8}Ga_{0.2}N$ به علت جرم موثر بیشتر الکترونها در این ماده در مقایسه با نیمرسانای $In_{0.8}Ga_{0.2}N$ است (m_e در GaN و m_e در $In_{0.8}Ga_{0.2}N$ زیرا آهنگ پراکندگی الکترونها در اثر پیزوالکتریک نسبت مستقیم با جرم موثر الکترونها دارد .



شکل ۴-۸ - آهنگ پراکندگی از حضور اتم های ناخالصی با چگالی $10^{22} m^{-3}$ در دمای اتاق بر حسب تابعی از انرژی الکترونها موجود در درجه مرکزی Γ برای نیمرسانای $In_{0.8}Ga_{0.2}N$ در دمای اتاق

شکل ۴-۸ آهنگ پراکندگی از حضور اتم های ناخالصی با چگالی 10^{22} m^{-3} را در دمای اتاق بر حسب تابعی از انرژی الکترون‌های موجود در دره مرکزی Γ برای نیمرسانای $\text{In}_{0.18} \text{Ga}_{0.82} \text{N}$ نشان می دهد.

چنانکه ملاحظه می شود ، آهنگ پراکندگی از مقدار ماکزیمم 8×10^{13} برخورد در هر ثانیه در انرژی بسیار پایین به مقدار $2/5 \times 10^{10} \text{ eV}$ برخورد در هر ثانیه در انرژی های الکترونی پایین است . کاهش می یابد . لذا اثر غالب این پراکندگی در حد انرژی های الکترونی پایین است . مقایسه ای از آهنگ پراکندگی از اتم های ناخالصی برای ترکیب نیمرسانای GaN نشان داده شده در فصل دوم ، با $\text{In}_{0.18} \text{Ga}_{0.82} \text{N}$ نشان می دهد که در حد انرژی های الکترونی پایین آهنگ پراکندگی الکترونها از حضور اتم های ناخالصی در GaN به حدود 2×10^{14} برخورد در هر ثانیه می رسد که در مقایسه با ترکیب $\text{In}_{0.18} \text{Ga}_{0.82} \text{N}$ بیشتر است . این افزایش به دلیل جرم موثر بیشتر الکترونها در ترکیب نیمرسانای GaN در مقایسه با $\text{In}_{0.18} \text{Ga}_{0.82} \text{N}$ است ، زیرا آهنگ پراکندگی از اتم های ناخالصی نسبت مستقیم با جرم موثر الکترونها دارد .



شکل ۴-۹- آهنگ پراکندگی الکترونها در درجه مرکزی Γ از فونون های اپتیکی برای هردو حالت جذب

و گسیل بین ترازهای انرژی متفاوت بر حسب تابعی از انرژی در نیمرسانی $In_{0.8}Ga_{0.2}N$ در دمای اتاق

شکل ۴-۹ آهنگ پراکندگی الکترونها در درجه مرکزی Γ را از فونون های اپتیکی برای هردو
حالت جذب و گسیل بین ترازهای انرژی متفاوت بر حسب تابعی از انرژی در نیمرسانی
 $In_{0.8}Ga_{0.2}N$ نشان می دهد . چنانکه ملاحظه می شود در حالت جذب (absorbtion) آهنگ
پراکندگی الکترونها از فونون های اپتیکی در هر سطح انرژی رخ می دهد بطوریکه آهنگ آن بطور
متوسط به ازای انرژی های الکترونی متفاوت در حدود 2×10^{11} برخورد در هر ثانیه ثابت
می ماند . حال آنکه در حالت گسیل (emission) پراکندگی الکترونها از فونون های اپتیکی
صرفاً زمانی رخ می هد که انرژی الکترونها در ماده نیمرسانی $In_{0.8}Ga_{0.2}N$ از انرژی

فونون های اپتیکی در این ترکیب نیمرسانا ($eV / ۰.۰۹$) بیشتر باشد . در اینحالت چنانچه ملاحظه می شود آهنگ پراکندگی الکترونها از صفر به ماکزیمم $۱۰^{۱۳}$ برخورد در هر ثانیه افزایش می یابد.

۴-۵ - محاسبه حرک پذیری در حد میدان الکتریکی ضعیف

با محاسبه آهنگ پراکندگی الکترون ها در درجه مرکزی Γ در ترکیبات نیمرسانای GaN ، InN و $In_{\frac{1}{2}}Ga_{\frac{1}{2}N}$ می توان با حل معادله بولتزمن ، حرک پذیری الکترونها را محاسبه نمود . جزئیات حل و بحث معادله بولتزمن به روش برگشت پذیری و چگونگی محاسبه پارامتر حرک پذیری الکترونها بطور کامل در فصل سوم شرح داده شد . در این بخش نتایج بدست آمده از حل این معادله برای میدان الکتریکی اعمالی $E = ۱۰^4 N/m$ بررسی خواهیم کرد .

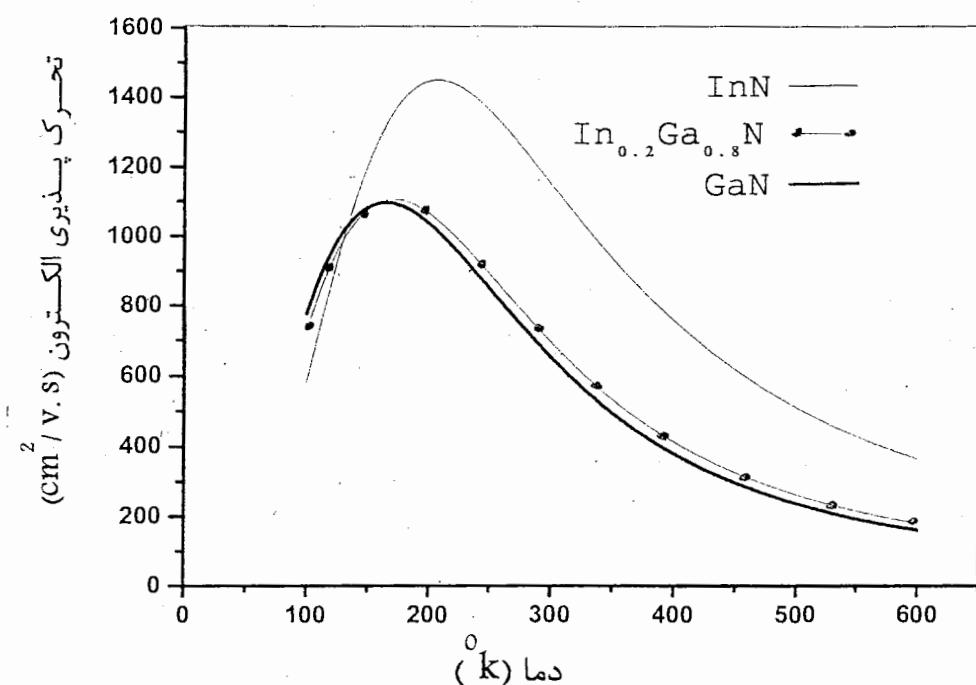
کلیه پارامترهای ساختاری و الکتریکی استفاده شده برای محاسبه حرک پذیری در جدول ۴-۱ و ۴-۲ ذکر شده است . با استفاده از این پارامترها سعی شده است نمودار تغییرات حرک پذیری این سه ترکیب در مقایسه با یکدیگر و بر حسب تابعی از دما و چگالی الکترونی متفاوت رسم شود تا بهتر بتوان ویژگی های رسانایی الکتریکی این ترکیبات نیمرسانا را با یکدیگر مقایسه نمود .

عنوان مثال شکل ۴-۱ نمودار تغییرات حرک پذیری بر حسب دما را برای سه ترکیب نیمرسانای InN ، $In_{\frac{1}{2}}Ga_{\frac{1}{2}N}$ و GaN نشان می دهد . در این محاسبه چگالی الکترونها در هر سه مورد m^{-3} $۱۰^{۲۳}$ در نظر گرفته شده است . چنانکه ملاحظه می شود حرک پذیری الکترونی در نیمرسانای InN در تمامی دمایا بیشتر از GaN و $In_{\frac{1}{2}}Ga_{\frac{1}{2}N}$ است . بطوریکه

ماکریم مقدار آن در دمای $T = 200^{\circ}\text{K}$ در حدود $\frac{\text{cm}^2}{\text{V.S}}$ ۱۴۰۰ است و سپس در اثر آهنگ

پراکندگی از فونون های اپتیکی به شدت افت نموده بطوریکه در دمای اتاق به حدود

$$1100 \frac{\text{cm}^2}{\text{V.S}} \text{ کاهش می یابد.}$$



شکل ۴-۱۰- نمودار تغییرات تحرک پذیری بر حسب دما برای سه ترکیب نیمرسانی InN . GaN و

$$1.023 \text{ m}^{-3} \text{ در چگالی } \text{In}_{0.2}\text{Ga}_{0.8}\text{N}$$

همچنین این شکل نشان می دهد که تحرک پذیری ترکیب نیمرسانی $\text{In}_{0.2}\text{Ga}_{0.8}\text{N}$ بیز

از نیمرسانی GaN اندکی بیشتر است . بطوریکه در دمای اتاق تحرک پذیری بدست آمده برای

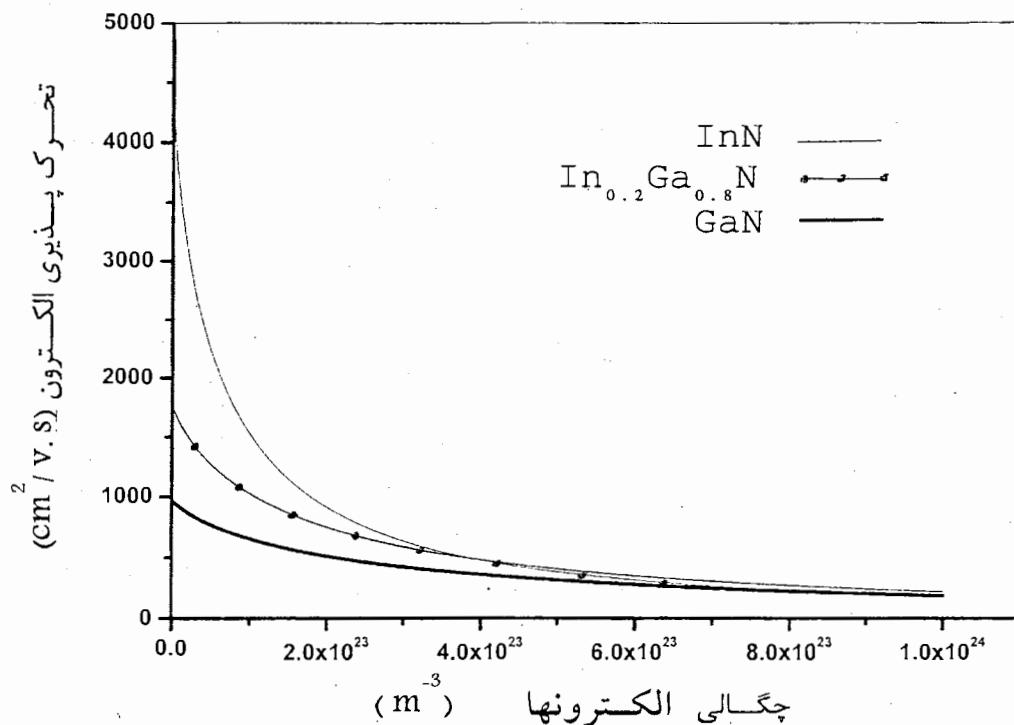
$$\frac{\text{cm}^2}{\text{V.S}} \text{ در حدود } \text{In}_{0.2}\text{Ga}_{0.8}\text{N} \text{ ۷۵۰ است در صورتیکه برای نیمرسانی GaN در حدود}$$

$\frac{\text{cm}^2}{\text{V.S}}$

GaN ۶۵۰ است . تحرک پذیری بیشتر ترکیب نیمرسانای $\text{In}_{0.2}\text{Ga}_{0.8}\text{N}$ در مقایسه با GaN

به علت جرم موثر کمتر الکترون در این ماده در مقایسه با GaN است ، $(0.02m_0)$ در مقایسه با

$(0.117m_0)$



شکل ۴-۱۱ - نمودار تغییرات تحرک پذیری در سه نیمرسانای InN ، $\text{In}_{0.2}\text{Ga}_{0.8}\text{N}$ ، GaN

در دمای اتاق بر حسب چگالی الکترونی

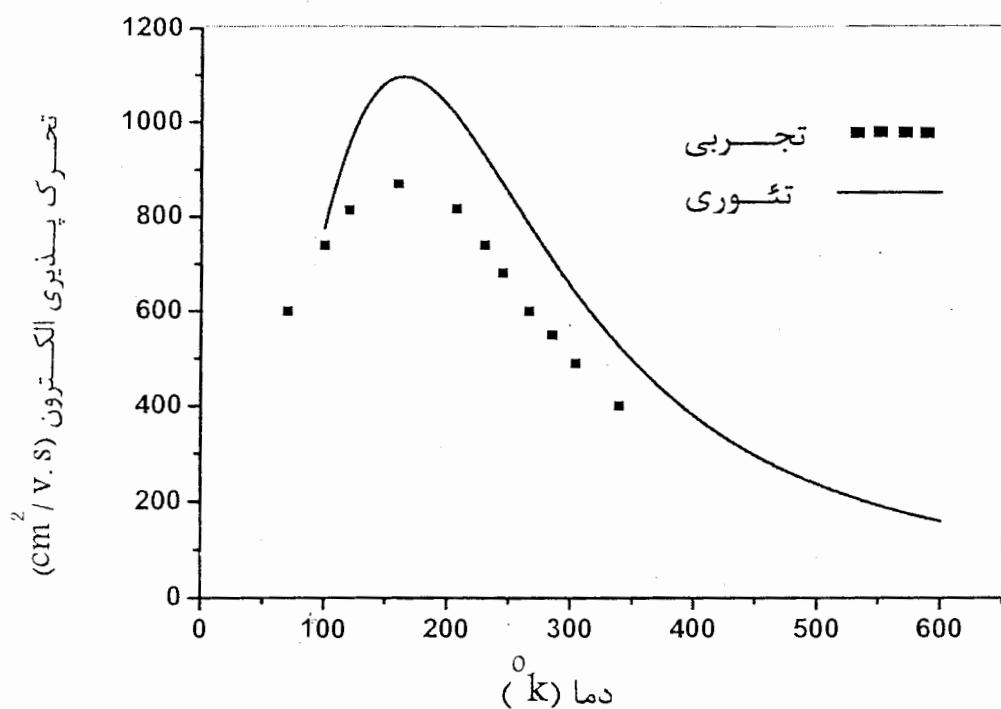
شکل ۴-۱۱ نمودار تغییرات تحرک پذیری در سه نیمرسانای GaN ، InGaN ، InN در دمای

اتاق بر حسب تابعی از چگالی الکترونها آزاد نشان می دهد . چنانکه ملاحظه می شود با افزایش

چگالی الکترونها از 10^{22} الکtron بر هر مترمکعب به 10^{24} بر هر مترمکعب در هر ماده ، تحرک

پذیری الکترونها به دلیل افزایش آهنگ پراکندگی کاهش می یابد ، اما به هر حال تفاوتی در اندازه

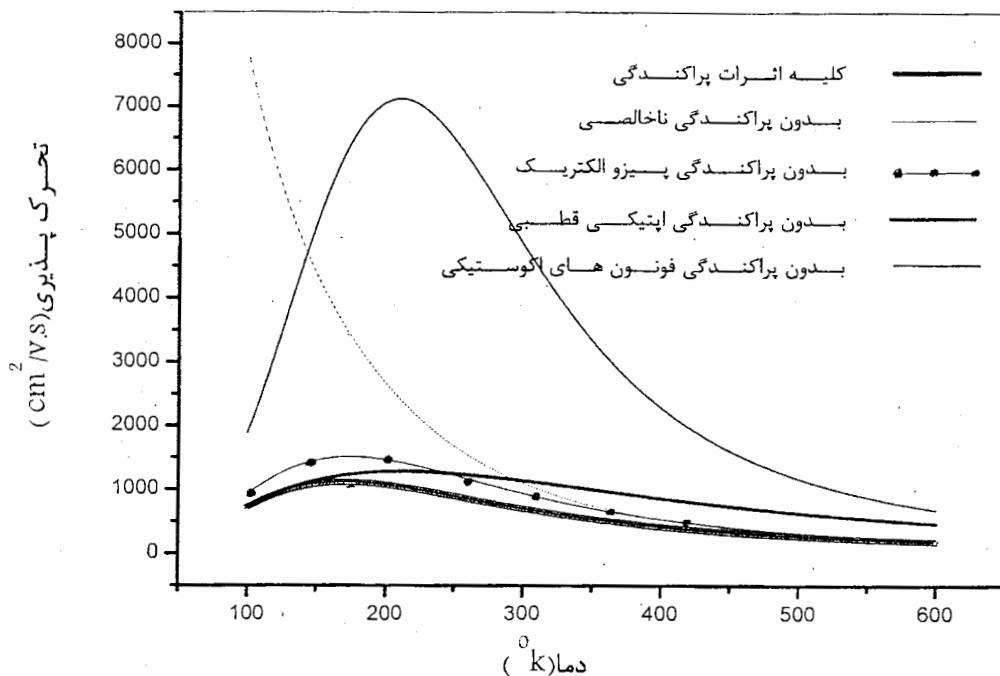
تحرک پذیری ، ناشی از تفاوت در پارامترهای الکتریکی و بخصوص جرم موثر الکترون در درء Γ است ، ملاحظه می گردد .
 به منظور مقایسه ای با دیگر کارهای تئوری و یا تجربی انجام پذیرفته در محاسبه تحرک پذیری الکترونی در ترکیبات نیمرسانای نیترات دار به شکل ۴-۱۲ توجه می کنیم . این شکل نمودار تغییرات تحرک پذیری بر حسب دما را در ترکیب نیمرسانای GaN به ازای چگالی الکترونی 1.0^{23} cm^{-3} الکترون بر هر مترمکعب (1.0^{17} cm^{-3} الکترون بر هر سانتی مترمکعب) نشان می دهد .



شکل ۴-۱۲ - مقایسه نمودارهای تجربی و تئوری تغییرات تحرک پذیری بر حسب دما در ترکیب نیمرسانای GaN در چگالی الکترونی 1.0^{23} m^{-3}

چنانکه ملاحظه می شود ، نمودار تغییرات تحرک پذیری GaN در این تحقیق شباهت کلی با نمودار تحرک پذیری محاسبه شده دارد . نمودار تجربی نشان می دهد که در دمای اتاق برای چگالی الکترونی 10^{23} اتم بر هر متر مکعب (10^{17} cm^{-3}) تحرک پذیری الکترونها در نیمرسانای GaN در حدود $\frac{\text{cm}}{\text{V.S}} \cdot 550$ است که اگر آنرا با مقدار محاسبه شده در این پژوهش مقایسه کنیم ملاحظه می شود که مقدار محاسبه شده در این پژوهش در دمای اتاق برای چگالی الکترونی 10^{23} بر هر مترمکعب در حدود $\frac{\text{cm}}{\text{V.S}} \cdot 600$ است که در توافق نسبتاً خوبی با نتایج ارائه شده در این مقاله است .

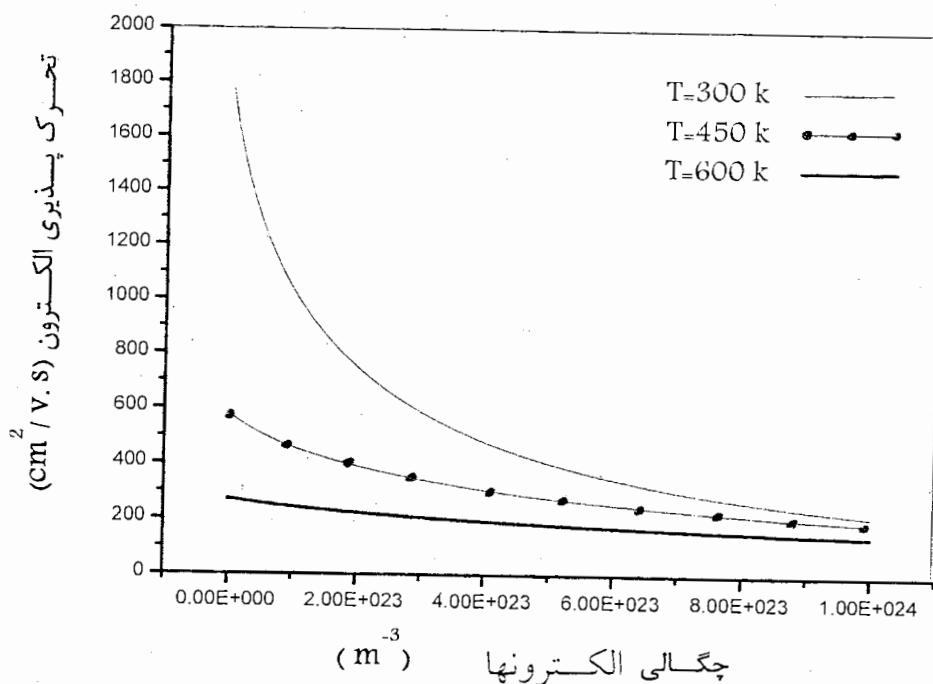
به منظور بررسی اثر پراکندگی الکترونها تحت تأثیر عوامل مختلف پراکندگی ، بررسانش الکتریکی ترکیبات نیمرسانای متفاوت ، در شکل ۱۳ - ۴ تحرک پذیری الکترونها در ترکیب نیمرسانای $\text{In}_{1/2}\text{Ga}_{1/2}\text{N}$ بر حسب تابعی از دما در غیاب برخی از عوامل پراکندگی مهم در مقایسه با نمودار کلی نشان داده شده است .



شکل ۴-۱۳ - تحرک پذیری الکترونها در ترکیب نیمرسانای $\text{In}_{\frac{1}{2}}\text{Ga}_{\frac{1}{2}}\text{N}$ بر حسب تابعی از دما

در غیاب برقی از عوامل پراکنندگی مهم در مقایسه با نمودار کلی

بطور مثال چنانکه در این شکل دیده می شود تحرک پذیری الکترونها در غیاب پراکنندگی از اتم های ناخالصی در دماهای پایین به شدت افزایش می یابد . این شکل بوضوح نشان می دهد که اثر پراکنندگی از اتم های ناخالصی بر تحرک پذیری الکترونها در دماهای پایین بسیار شدیدتر است . علت این امر هم آنستکه در دماهای پایین انرژی جنبشی الکترونها به شدت کاهش می یابد و این امر باعث می شود که الکترونها به آهستگی از کنار اتم های ناخالصی حرکت کنند و لذا اثر پتانسیل دافعه کولنی بین اتم ناخالصی و الکترون بیشتر بوده و بنابراین آهنگ پراکنندگی از اتم های ناخالصی به شدت افزایش می یابد .



شکل ۴-۱۵ - تغییرات تحرک پذیری الکترونها در درجه Γ برای ترکیب نیمرسانی $\text{In}_{0.18}\text{Ga}_{0.82}\text{N}$ بر حسب تابعی از چگالی اتم‌های ناچالصی در دمای $T=600$ ، $T=450$ ، $T=300$ K

شکل ۴-۱۴ نشان می‌دهد که با افزایش چگالی الکترونها در ترکیب نیمرسانی

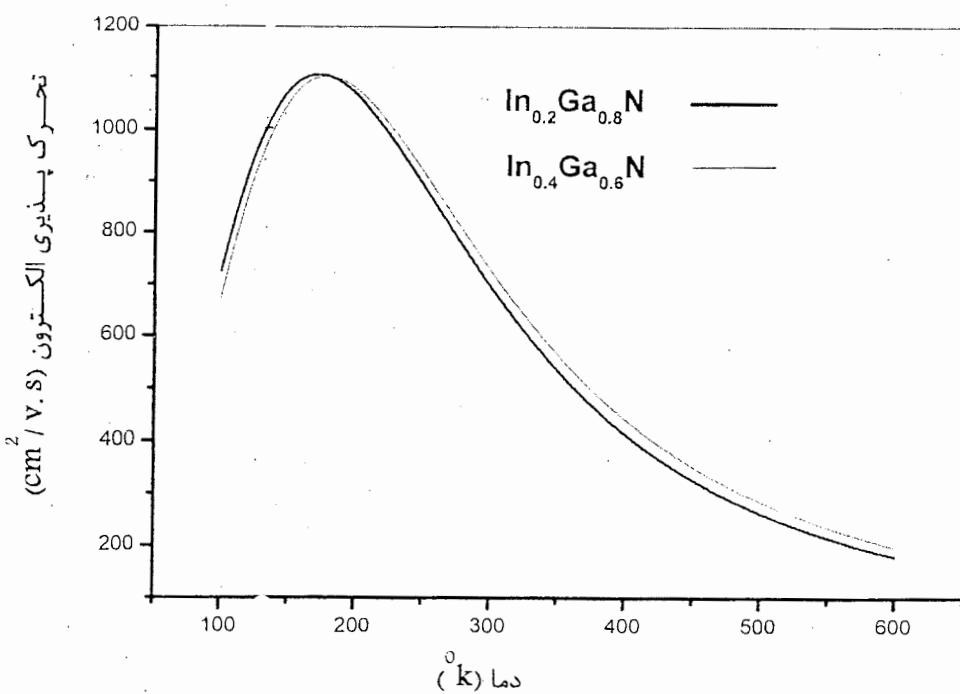
از $\text{In}_{0.18}\text{Ga}_{0.82}\text{N}$ از $1.0 \times 10^{21} \text{ m}^{-3}$ به $1.0 \times 10^{23} \text{ m}^{-3}$ تحرک پذیری الکترونها به دلیل افزایش آهنگ پراکندگی کاهش می‌یابد.

شکل ۱۵-۴ ، تغییرات تحرک پذیری الکترونها را بر حسب چگالی الکترونها در دمای

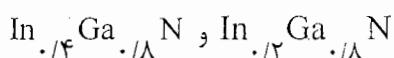
متفاوت نشان می‌دهد . چنانکه ملاحظه می‌شود با افزایش دما از $K^{\circ} 300$ به $K^{\circ} 600$ ، تحرک پذیر الکترونها به سرعت به ازای کلیه چگالی الکترونی متباخت کاهش می‌یابد . دلیل کاهش تحرک پذیری الکترونی در دمای بالاتر این است که با افزایش دما ، آهنگ پراکندگی از

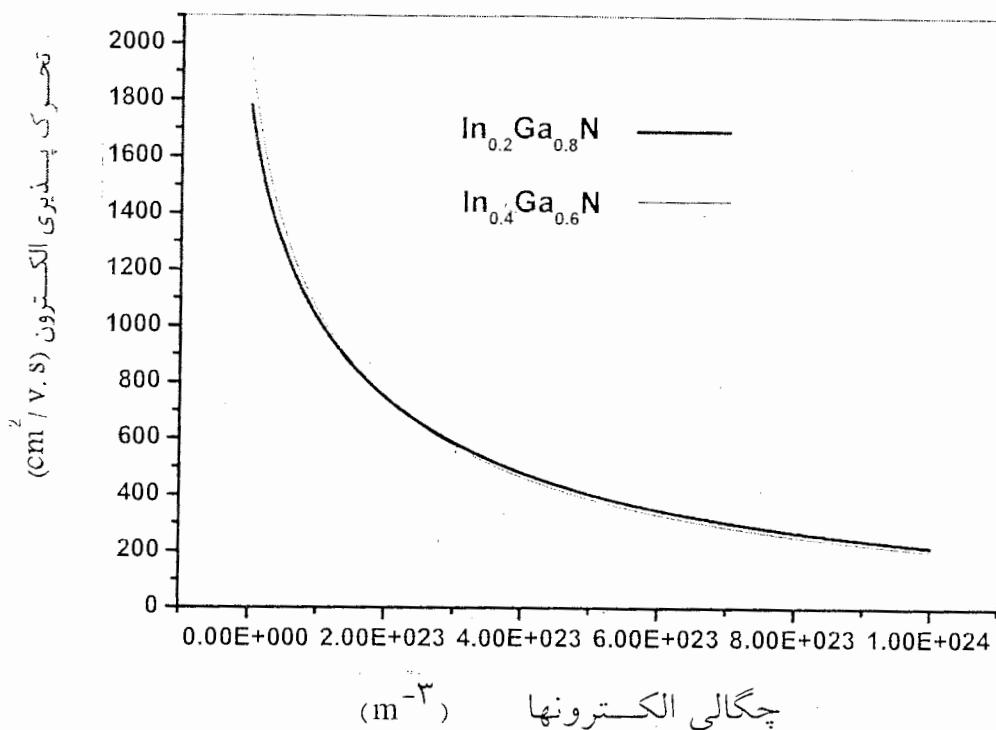
فونون های آکوستیکی ، اپتیکی افزایش می یابد . زیرا افزایش دما باعث افزایش ارتعاشات شبکه شده و بنابراین انرژی فونون های اپتیکی و صوتی افزایش می یابد . چنین افزایشی در انرژی فونون ها باعث برهمکنش قوی بین الکترون و این فونون ها شده که نتیجه آن افزایش آهنگ پراکندگی الکترونها و نهایتاً کاهش تحرک پذیری است . این شکل به وضوح چنین اثراتی در تحرک پذیری الکترونها در نیمرسانای $In_{0.2}Ga_{0.8}N$ را نشان می دهد .

به منظور مقایسه ای از اثرات ترکیب درصد وزنی عنصر In در ترکیب نیمرسانای InGaN بر رسانش الکتریکی این ماده نیمرسانا محاسبات تحرک پذیری الکترونها را بر حسب دما و چگالی الکترونها برای دو ترکیب نیمرسانا $In_{0.4}Ga_{0.6}N$ و $In_{0.6}Ga_{0.4}N$ انجام داده ایم . شکل های ۱۶-۴ و ۱۷-۴ نتایج بدست آمده را نشان می دهند .



شکل ۱۶-۴ - نمودار تحرک پذیری الکترون بر حسب دما برای دو ترکیب





شکل ۴-۱۶ - نمودار تحرک پذیری الکترون بر حسب چگالی برای ترکیب

$\text{In}_{0.2}\text{Ga}_{0.8}\text{N}$ و $\text{In}_{0.4}\text{Ga}_{0.6}\text{N}$ در دمای اتاق

چنانکه از این نمودارها ملاحظه می شود ، با تغییر درصد مولی ماده ایندیم از ۰/۲ درصد وزنی به ۰/۴ درصد وزنی ، تفاوتی جزئی در تحرک پذیری الکترونها بر حسب تابعی از دما و چگالی الکترونی بدست می آید . دلیل این تفاوت کم آنستکه با تغییر درصد وزنی ایندیم از ۰/۲ تا ۰/۴ تغییرات چندان زیادی در پارامترهای الکتریکی و ساختاری این مواد بوجود نمی آید . بطور مثال با تغییر درصد وزنی ، جرم موثر الکترون از $m_0/173$ به $m_0/170$ [۳] افزایش می یابد که این افزایش جزئی باعث چندان تغییر بزرگی در خواص رسانش الکتریکی این ماده نمی گردد .

۶-۴-کارهای آینده

با تهیه نرم افزاری که قادر به حل معادله تراپری الکترونها در ترکیبات نیمرسانا است ، می توان خواص الکتریکی در ماده نیمرسانایی را که دارای گاف انرژی مستقیم است محاسبه نموده و تغییرات این پارامترهای الکتریک را با دما و چگالی الکترونها آزاد آنها مقایسه نمود . با استفاده از این نرم افزارها می توان اینگونه بررسی را در دیگر ترکیبات نیمرسانا از گروه II ، IV جدول تنابوی مانند CdSe ، CdTe یا آلیاژهای ترکیبات نیمرسانایی نظیر AlGaN ، AlGaAs و ... انجام داد . همچنین با استفاده از این نرم افزار می توان خواص تراپری الکترونها را نه تنها در درجه مرکزی Γ ، بلکه در هر درجه بالاتر دیگری نیز بررسی نمود . بطور مثال می توان خواص تراپری الکترونها را هنگامی که در دومین و یا سومین درجه نوار رسانش ترکیبات نیمرسانا قرار می گیرند با یکدیگر مقایسه نمود . بررسی چنین مواردی خود نیاز به اطلاعات وسیعی از مشخصات نوارهای انرژی بالاتر ، و خواص الکترونها در درجه های بالاتر انرژی دارد که می تواند اساس پژوهش جدید دیگری را تشکیل دهد .

منابع و مراجع:

- ۱- مبانی پراش پرتو X ، تالیف بی . دی . کالیتی، ترجمه دکتر بیژن اعتمادی، دکتر جمشید عمیقیان، انتشارات دانشگاه شیراز، ۱۳۷۵
- ۲- شناسایی مواد به کمک اشعه ایکس ، تالیف هارالد کریشنر، ترجمه دکتر عباس طائب، چاپ تهران دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۷۰
- ۳- فیزیک حالت جامد ، تالیف علی عمر، ترجمه غلامرضا نبیونی، حسن عزیزی - دانشگاه اراک ۱۳۸۰
- ۴- فیزیک حالت جامد، تالیف روزنبرگ، ترجمه دکتر حسین عشقی، حسن عزیزی - دانشگاه مرکز دانشگاهی تهران، ۱۳۷۶
- ۵- آشنایی با فیزیک حالت جامد، تالیف چارلز کیتل، ترجمه اعظم پور قاضی، مهدی سفا، جمشید عمیقیان، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۶
- ۶- فیزیک و تکنولوژی قطعات نیمرسان، تالیف اس . ام . زی، ۱۹۸۵ ، ترجمه غلامحسین سدیر عابدی، دانشگاه امام رضا(ع) مشهد، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی ، ۱۳۷۵،
- 7-Rode ,D.L, Electron Transport in InSb , InAs and InP *physical Review B*, PP.3287 –3299,(1971)
- 8-Molestue.c, *Monte Carlo simulation of semiconductor Devices* chapman and Hall, 1993
- 9-Rode,D.L, *SemiConductors and Semimetals*, Academic Press,Vol .50,(1970)
- 10-Ohar . S and Ghosh. S,Electron mobility in GaN *J.Appl. Phys.* Vol .86,Pp.2668 –2675,(1999).
- 11-Goano,M and Bellott, E Band structure nonlocal Pseudopotential... GaN , ALN and InN, *J.APPL. Phys*, Vol.83,No.11,PP.6468-6474,(2000)
- 12-Morkoc, H Nitride Semiconductor and Devics,Springer – Verlag (1999)

13-Farahmand, M,*Monte Carlo simulation of Electron Transport in*

III-nitride wurtzite Phaase, IEEE Transactions on Electron Devices, Vol.4, No.3.(2001)

14-Anwar, A.F.M Temperabure dependant Transport Properties in GaN, Al_xGa_{1-x}N and In_xGa_{1-x}N Semiconductors, *IEEE. Transactions on Electron Devices*, Vol. 48, No .3, PP. 576,572,(2001)

منابع دیگری که مورد استفاده قرار گرفته اند .

1-Ashcroft, w, Mermin, N.D, Solid State Physics Printed by Holt, Rinehart and winston, 1979.

2- Rode, D.L and Beer, A,C, *Phys . Rev.B3*,PP. 2534(1991)

3-Crow.G.C, Abram . R.A and Yangthaisong. *A, Semicond. Sci. Technol.*15,770,(2000).

4- Dhar and S.Ghosh.*J.APPL. Phys.* 86. 2668.(1999)

5- Basic Crgstallography,*J.J.Rousseau,John wiley sons*,1998.

۶-بلور شناسی با پرتو X ، تالیف ، لئونیدو و آذارف ترجمه دکتر ناصر تجبر، چاپ دانشگاه فردوسی مشهد ، ۱۳۷۱

۷-برنامه نویسی به زبان فرترن ۷۷، تأليف چارلیس بی، کریتسبرگ، نورمن تی. کارپنتر، ترجمه دکتر سید رضا غلامرضا پناهی ، انتشارات دانشگاه گیلان و موسسه انتشاراتی فاطمی، ۱۳۷۴

Abstract

Temperature and doping dependence of electron mobility in wurbzite $\text{In}_{0.2}\text{Ga}_{0.8}\text{N}$ structure has been calculated using an iterative technique. The following scattering mechanisms, such as impurity, polar optical phonon, acoustic phonon and piezoelectric scattering are included in the calculation. Ionized impurity scattering has been treated beyond the Born approximation using the phase – shift analysis. It is found that the electron mobility decreases monotonically as the temperature increases from 100 k to 500 k.

The low temperature Value of electron mobility in bulk $\text{In}_{0.2}\text{Ga}_{0.8}\text{N}$ increases significantly with increasing doing concentration. Our iterative results are in fair agreement with other recent calculations obtained using the experimental methods.

low - field transport properties in InGaN structurey

POSTER SESSION ABSTRACTS - MONDAY, JUNE 14

These observations suggest that increasing levels of chain unsaturation may reduce the sensitivity of bilayer order to variations in pressure.

* Supported by NSERC (MRM) and CIHR (KMWK).

MO-POS-82

Characterization Of Anisotropy In Foams: An Ultrasonic Approach*, Hussein Elmehdji, J.H. Page AND M.G. Scanlon, *University of Manitoba* — We use low frequency ultras waves (50 kHz) to investigate the mechanical properties of anisotropic freeze-dried bread foams that were prepared by applying uniaxial stress to fresh breadcrumb. Longitudinal ultrasonic velocity and amplitude measurements were taken in directions parallel and perpendicular to the compression direction. The velocity was found to decrease as the amount of compression is increased, with the decrease being greater in the parallel direction. The velocity data were interpreted using two theoretical models, one based on static compression of a simplified strut model of foams and the other including the effects of tortuosity on wave propagation through anisotropic media. Both models allowed velocity anisotropy to be directly related to the anisotropy of the foam structure, and give predictions in good overall agreement with the data. The results also allowed us to conclude that there must be a weakening of the cell walls caused by the uniaxial compression in addition to the effects resulting from the anisotropy alone.

* This work is being supported by NSERC.

MO-POS-83

Structure of a Homologue Series of Banana Mesogens Studied By C13 NMR Spectrum*, J. Xu and R.Y. Dong, *University of Manitoba* — C13 NMR spectroscopy was used to obtain the geometrical information in three members of a homologue series of banana molecules, 9CIPBBC, 8DCIPBBC and 9DCIPBBC. The orientational order parameter S and bending angles and tilt angles between the biphenyl rings were determined from the temperature dependent chemical shifts in the nematic phases. Although the temperature dependence of S was found to be different for these molecules, the S values at T_c were almost identical. It was also found that tilt angles depend linearly on temperature, an bending angle in the mono-substituted molecule is about 14 degree smaller than the di-substituted molecular. A SUPER (Separation of Undistorted Chemical-Shift Anisotropy Powder Patterns) technique was used to determine the chemical shift tensors of carbons of model compounds (e.g. 4-Chlororesorcinol). These tensorial components are required for fitting the temperature dependent chemical shifts in aligned samples.

* Research is supported by NSERC and Brandon University

MO-POS-84

On the Physical Mechanism of Vortex Stirring in MHD-Driven Two-Fluid Molten Metal Flows, David Munger and A. Vincent, *Université de Montréal* — Magnetohydrodynamics (MHD) instabilities such as those observed in aluminum reduction cells have been thoroughly studied, for instance by means of linear analysis by Sneyd (1992) and numerical simulation by Potocnik (1989) using industrial codes, as well as by Gerbeau (2001) using finite elements. Though its understanding is critical for efficient aluminium production, the physical mechanism is still unknown. We focus on the stability of vortex stirring that naturally occurs in MHD-driven systems of two fluids with a large electrical conductivity ratio, traversed by an intense vertical electric current and under a strong background magnetic field. We perform three-dimensional nonstationary numerical simulations of the conservative equations, using a levelset technique to track the position of the interface between the two fluids. Periodic transport of large eddies occurs, in which we observe oscillation of vortex energy arising from a balance between the dissipation forces and the supply from the imposed electric current. The corresponding frequencies are orders of magnitude smaller than those observed in typical metal pad roll, so that long-lasting simulations are necessary to track slowly growing instabilities. We are able to find a stable threshold in terms of the electrical conductivity of the fluids, and we are currently trying to correlate it with the cell's dimensions. We conjecture that an increase of the latter will compensate a decrease of conductivity in the triggering of instabilities. Simulations are underway and results will be presented at the conference.

MO-POS-85

Spin Wave Dispersion of the 2D Hubbard Model at Intermediate Coupling*, Walter Stephan, *Bishop's University* — The spin wave dispersion relation for the 2D square lattice Hubbard model at half-filling is calculated using an "exact" linked cluster expansion method. The approach used is most reliable at strong coupling, but still converges reasonably well when the Coulomb repulsion is of the same order of magnitude as the band width. Results are compared to those of other approximate calculations as well as neutron scattering measurements of undoped cuprates.

* This work is being supported by NSERC.

MO-POS-86

The Giant Magnetocaloric Effect (GMCE) in Ni-Mn-Ga, Wei Li, Xuezhi Zhou, H P Kunkel and Gwyn Williams, *University of Manitoba* — Several previous investigations have demonstrated that a giant magnetocaloric effect (GMCE) – a large isothermal entropy / adiabatic temperature change associated with the application of an external magnetic field to a system – is most often linked to the substantial entropy change accompanying a first-order phase change. However, it appeared plausible that in systems exhibiting sequential magnetic transitions – specifically a continuous paramagnetic to ferromagnetic transition followed by a first-order / discontinuous (order-order) transition - this effect might be enhanced if these two transitions could be brought into close proximity, or better still, merged. The veracity of this suggestion has been demonstrated in the Ni-Mn-Ga system where such a coincidence can be achieved through careful compositional tuning, thus for $\text{Ni}_{55.2} \text{ Mn}_{18.6} \text{ Ga}_{26.2}$ an entropy change of $\Delta S_M = -20.4 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ is observed at 3 T in a field of 5T, one of the larger values measured at or above room temperature.

MO-POS-87

Comparison of Electron Mobility in Zincblende and wurtzite GaN, A. Somaee², M. Sadeghi², H. Arabshahi¹, M. Ghazi², ¹Tarbiat Moallem University and ² Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran — GaN has received much attention in recent years because of its potential for a wide range of applications in high power and optoelectronic devices. The demands of device designs have encouraged numerical studies of electron transport in the material. In this research a numerical iteration method has been developed and used to model electron transport in zincblende and wurtzite GaN at low electric fields. Our results show that the electron drift mobility of wurtzite GaN is lower than that for the zincblende structure at all temperatures. This is largely due to the higher G valley effective mass and a higher electron scattering rate in the wurtzite phase.

MO-POS-88

Low-Field Electron Transport Calculations in Bulk Wurtzite GaN Using Iterative Technique, Hadi Arabshahi, *Tarbiat Moallem University* — Temperature and electric field-dependent electron transport in bulk wurtzite GaN structure have been calculated using an iterative technique. The following scattering mechanisms, i.e., impurity, polar optical phonon, acoustic phonon, piezoelectric and electron plasmon are included in the calculation. Ionized impurity scattering has been treated beyond the Born approximation using the perturbation theory. The low electron drift mobility is calculated for temperatures in the range of 300–600 K and for ionized impurity concentrations between 10^{16} and 10^{18} cm^{-3} . The temperature value of electron mobility increases significantly with increasing doping concentration. The iterative results are in fair agreement with other recent calculations obtained using the relaxation-time approximation and experimental methods. Compensation effects on the mobility are also examined. Due to the freezout of deep donor levels the role of ionized impurity scattering in bulk wurtzite GaN is suppressed and the role of phonon scattering is enhanced, compared to zincblende structure. Electron transport properties have been modelled with an electric field applied both parallel and perpendicular to the (0001)c-axis. The extracted model parameters can be used for electron transport simulations in GaN-based transistors.

MO-POS-89

Design and Modelling of Inductively Heated Substrate Holders for Advanced Plasma Materials Processing Applications*, Ajay K. Singh and Michael P. Bradley, *University of Saskatchewan* — Plasma processing of materials will be one of the key enablers for advances in electronics and photonics technology in the 21st century. Effective plasma materials processing requires careful control of process parameters, including the temperature of the target material. For example, a minimum target temperature ~ 800 Celsius is required for plasma deposition of diamond films. Unfortunately, in high pressure (~ 10 Torr) microwave plasma systems (such as the diamond film growth system at the University of Saskatchewan) the ultimate target temperature may be limited to ~ 500 Celsius because ion-neutral collisions limit the amount of heat delivered to the target, and because relatively high convective cooling rates. Thus it is necessary to directly heat the target to achieve the high temperatures required. Direct heating via heating wire may be difficult to implement because in most cases the substrate must be biased with respect to the grounded chamber walls to achieve good film growth. Inductive eddy current heating provides a solution. Heating energy is efficiently coupled into the substrate via induced eddy currents, providing rapid and potentially highly uniform heating. The purely inductive coupling means that the substrate can be biased to arbitrary voltages as required. This presentation will discuss our design efforts on heated substrate holders. We will present results of thermal modelling calculations (i.e. heating curves, mean temperature, temperature uniformity) and will discuss their implications for advanced target holder design.

* This work is being supported by NSERC.

MO-POS-90

Elastic Fields from Reconstructed Terraces of a Semi-Infinite Solid*, R. Arief Budiman, *University of Calgary* — Two-dimensional problem of a semi-infinite solid with surface reconstruction boundary condition is considered. Surface reconstruction produces sinusoidal displacement fields on a terrace and attractive interaction due to the reconstruct-

**CANADIAN ASSOCIATION
OF PHYSICISTS**



**ASSOCIATION CANADIENNE
DES PHYSICIENS ET PHYSICIENNES**

Suite.Bur. 112, Imm. McDonald Bldg., Univ. of / d'Ottawa, 150 Louis Pasteur, Ottawa, Ontario, Canada K1N 6N5
Tel. / Tél. : (613) 562-5614; Fax / Téléc. : (613) 562-5615; E-mail / Courriel : cap@physics.uottawa.ca

2004 April 29

Dear Mr. Somace:

**2004 CAP Annual Congress
June 13-17, Winnipeg, Manitoba**

I thank you for your submitted abstract entitled "Comparison of Electron Mobility in Zincblende and wurtzite GaInN". I am pleased to advise you that your abstract has been selected by the chair of the Condensed Matter and Materials Division as a poster during the plenary Beer and Poster Session on Monday evening, June 14th.

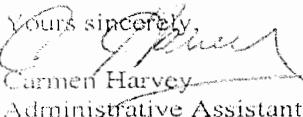
Your poster will be included in the DCMMMP poster session as poster number **MO-POS-124**. Instructions for the preparation and display of posters are attached. As noted above, this year we are holding the poster session as an evening plenary starting at 19h00 on June 14th.

You or a co-author (if applicable) of the abstract must be available at your poster between 19h00 and 21h00 on the 14th. The posters can be mounted any time after noon on June 13th and left mounted until noon on Wednesday, June 16th.

A copy of the Congress program will be mailed to all 2004 CAP Congress delegates by mid-May. Please ensure that the mailing address at the top of this letter is correct, and forward any changes to the CAP office no later than May 15th. In the meantime, please feel free to check the CAP's website (<http://www.cap.ca>) which is being updated on a regular basis to include the most recent Congress Program available.

Register before May 1st for discounted rates!

If you have any questions regarding any of the above or require Congress registration information, please feel free to contact me at (613) 562-5614. Otherwise, I will look forward to seeing you at the Congress.

Yours sincerely,

Carmen Harvey
Administrative Assistant